



دانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای رشته نانو فیزیک پایان نامه کارشناسی ارشد

سنتز و مشخصه یابی نانوساختارهای دی اکسید تیتانیوم آلایش یافته برای کاربرد در سلول های خورشیدی پروسکایتی

نگارنده:

سید مهدی موسوی

استاد راهنما:

دكتر محمدباقر رحمانى

تیرماه ۱۳۹۸

تقديم به بمسرم که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم می باشد، او که اسوه صبروتخل بوده و مشکلات مسیر رابرایم تسهیل نمود. به پاس قدر دانی از قلبی آکنده از عثق و معرفت که محیطی سرتار از سلامت و امنیت و آرامش و آسایش برای من فراہم آورده

است.

وتقديم به فرزمدان امير يلى زندكيم

محد حسين ومحدياسين.

سمع وقدرداني

بیان خدای را که سخوران، در ستودن او باندو ثمار ندگان، شمردن نعمت بای او ندانند و کوشندگان، حق او را کزاردن نتوانند. و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاک او، طاہران معصوم، ہم آنان که وجودمان وامدار وجود ثان است؛ و نفرین پوسته بر دشمنان ایثان تا روز رستاخیز... بدون شک جایگاه و منرات معلم، اجمّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی ثانیه می او، بازبان قاصر و دست ناتوان، چنری بگاریم. امااز آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که در مقام قدردانی از زحمات بی ثانیه می او، بازبان قاصر و دست ناتوان، چنری امااز آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که در مقام قدردانی از زحمات بی ثانیه می او، بازبان قاصر و دست ناتوان، چنری امااز آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که مند و خایت آ فرینش را تامین می کند و سلامت امانت بایی راکه به دست سپرده اند، تضمین؛ بر حسب و خلیفه و از باب:

از پدروماد عزیزم . . . این دو معلم بزرگوارم . . . که بمواره برکوتاین و در شتی من ، قلم عفوکشیده و کریانه از کنار غفلت مایم کدشته اندو در تام عرصه پای زندگی یارویاوری بی چشم داشت برای من بوده اند؛ از اساد با کالات و ثابیة؛ جناب آقای دکتر رحانی که در کال سعه صدر، باحس خلق و فروتنی، از پیچ کلی در این عرصه بر من دیغ ننمودند و زحمت را منایی این رساله رابر عهده کرفتند؛ از داوران کرامی که زحمت داوری و تصحیح این پایامه را به عهده داشتند کال سپاس را دارم. خالصانه از تامی اساتید و معلان ومدرسانی که در مقاطع مختلف تحصیلی به من علم آموخته و مرا از سرچشمه دانایی سیراب کرده اند مشکرم . از کلیه بهم دانشگامیان و بمرامان عزیزو دوستان خوبم ، نهایت سپاس را دارم.

تعهد نامه

اینجانب سیدمهدی موسوی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته نانوفیزیک دانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای دانشگاه صنعتی شاهرود نویسنده پایان نامه سنتز و مشخصه یابی نانوساختارهای دی اکسید تیتانیوم آلایش یافته برای کاربرد در سلول های خورشیدی پروسکایتی تحت راهنمائی آقای دکتر محمدباقر رحمانی متعهد می شوم:

- تحقیقات در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است.
 - در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است.
- مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی در هیچ
 جا ارائه نشده است.
- کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد و مقالات مستخرج با نام « دانشگاه
 صنعتی شاهرود » و یا « Shahrood University of Technology به چاپ خواهد رسید.
- حقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایح اصلی پایان نامه تأثیر گذار بوده اند در مقالات مستخرج از پایان نامه رعایت می گردد.
- در کلیه مراحل انجام این پایان نامه ، در مواردی که از موجود زنده (یا بافتهای آنها) استفاده شده است ضوابط و اصول اخلاقی رعایت شده است.
- در کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردی که به حوزه اطلاعات شخصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است اصل رازداری ، ضوابط و اصول اخلاق انسانی رعایت شده است .

تاريخ

امضای دانشجو

مالکیت نتایج و حق نشر

- کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن (مقالات مستخرج، کتاب، برنامه های رایانه ای، نرم افزار ها و تجهیزات ساخته شده است) متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد. این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود.
 - استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد.

* متن این صفحه نیز باید در ابتدای نسخه های تکثیر شده پایان نامه وجود داشته باشد .

در سالهای اخیر شاهد پیشرفت سریع شاخه جدیدی از سلول های خورشیدی بر پایه مواد پروسکایت هالید آلی-غیرآلی بوده ایم. اولین باری که در سال ۲۰۰۹ گزارش شد تاکنون بازده تبدیل انرژی سلول های خورشیدی پروسکایت (PSC) به سرعت از ۳/۸٪ تا ۲۲/۱٪ افزایش یافته است. برای این PSC ها لايه انتقال الكترون (ETL) نقش مهمي را در انتقال الكترون ها و مسدود كردن حفره ها انجام مي دهند. در اکثر سلول های پروسکایت، استفاده از TiO₂ در لایه های انتقال الکترون به خاطر خواص الکترونی عالي ، ارجح است. در اين پژوهش، TiO2 بدون آلايش و آلاييده (با يک درصد مولي Al ,Na و Fe) برای ساخت قطعات سلول خورشیدی پروسکایت، به روش هیدروترمال بهبود یافته سنتز شد. ویژگی های ساختاری، ترکیب عنصری، ریخت شناسی سطحی و نوری پودرهای سنتز شده به ترتیب با روش های آنالیز EDAX ، FESEM ، Raman ، XRD و UV-VIS مطالعه شد. بر اساس نتایج XRD ، استفاده از روش هیدروترمال بهبود یافته در سنتز نانوپودرها، باعث رشد فاز ترجیحی آناتاز با رد کمی از فاز بروکیت شد. این نانو ذرات سنتز شده به عنوان لایه انتقال دهنده الکترون در ساخت سلول های خورشیدی پروسکایتی استفاده شدند. سلول های خورشیدی ساخته شده از نوع n-i-p بودند که با TiO2متخلخل ساخته شدند، مراحل ساخت شامل أماده سازی FTO ، پوشش لایه فشرده TiO2 به عنوان سد كننده حفره و لايه متخلخل TiO₂ خالص و ألايش يافته با ألومينيوم و أهن به عنوان لايه انتقال الکترون و سپس پوشش لایه پروسکایت (CH₃NH₃Pbl₃) بود. برای پوشش این لایه از دو روش یک مرحله ای و دو مرحله ای (شامل دو روش مختلف) استفاده شد. در روش دو مرحله ای، Pbl₂ به روش لایه نشانی چرخشی پوشش داده شد و سپس (CH3NH3I (MAI) به دو روش چرخشی و غوطه وری به طور مجزا لایه نشانی شد. نتیجه های سه روش استفاده شده با هم مقایسه شدند. از میان آنها روش لایه نشانی دو مرحله ای چرخشی-چرخشی با توجه به کیفیت بهتر لایه، مناسب تشخیص داده شد و از این روش در ساخت سلول ها استفاده شد. از اسپایرو امتاد بدون افزودنی در لایه انتقال حفره استفاده شد. سرانجام، طلا به عنوان الكترود پشتی با استفاده از روش كند و پاش DC لايه نشانی شد. آنالیزهای Raman و UV-Vis برای کنترل کیفیت لایه نشانی هر یک از لایه ها در جریان ساخت سلول استفاده شدند. اندازه گیری های I-V قطعه های ساخته شده نشان می دهند که سلول دارای آلایش آهن، بهترین عملکرد را داشت.

کلمات کلیدی: سلول خورشیدی پروسکایتی؛ دی اکسید تیتانیوم؛ هیدروترمال؛ آلایش؛ اندازه گیری I-V ؛ بازده

لیست مقالات مستخرج از پایان نامه

۱- موسوی،سیدمهدی؛رحمانی،محمدباقر؛ ۱۳۹۷سنتز و مشخصه یابی ساختاری ونوری Tio2 آلایش
 یافته با AI و Fe ؛ بیست و ششمین همایش ملی کانی شناسی و بلورشناسی ایران ، ۳و۴ بهمن ۱۳۹۷
 ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره),.

صفحه	عنوان
	فصل اول:معرفی سلول خورشیدی پروسکایت
۲	۱–۱ مقدمه
۳	۲-۱ انواع سلول های خورشیدی
۴	۳-۱ پروسکایت
۷	۴-۱ تاریخچه سلول های خورشیدی پروسکایتی
۹	۵-۱ ساختار سلول
۱۰	۱-۵-۱ زیرلایه
11	۲-۵-۱ لایه انتقال دهنده الکترون درسلول های خورشیدی پروسکایتی (ETL)
١٢	۱-۵-۱ لایه سدکننده حفره
۱۳	۲-۵-۱ لایه نیمرسانای متخلخلTiO2
14	۳−۲−۵−۱ آلایش TiO ₂
۱۵	۱–۵–۳ لایه جاذب نور
۱۵	۴-۵-۱ لایه انتقال دهنده حفره (HTL)
١۶	۵-۵-۱ الكترود مقابل
١٧	۱-۶ صنعتی سازی
۱۷	۷-۱ جمع بندی

فهرست مطالب

فصل دوم:مروری بر مقالات

۲۰	۱-۲ مقدمه
۲۱	۲-۲ آلایش TiO ₂ فشرده با Fe
۲۷	۲-۳ آلایش TiO ₂ فشرده با Al
۲۸	۲-۴ آلایش TiO2 فشرده با MgواA
۳۱	۵-۲ آلایش TiO2 متخلخل باW
۳۶	۲-۶ آلایش TiO2متخلخل با ZnZnمتخلخل با
۴۳	۲-۲ جمع بندی
فصه یابی	فصل سوم:معرفی روش های سنتز و مشخ
49	۳–۱ مقدمه
۴۶	۳-۲-۳ مطالعه ویژگی های نوری با روش طیف سنجی UV-VIS
۴۶	۲-۲-۳ روش های تجربی برای بدست آوردن مقدار انرژی گاف نیمرسانا
۴۷	۳-۲-۳ وابستگی گاف انرژی به اندازه نانوذرات
۴۸	۳-۳ آنالیز SEM-EDS
۵۰	۳-۳ آنالیزXRD
۵۲	۳-۵ آنالیز رامان
۵۴	۳-۶ كوره الكتريكى
۵۵	۳-۷ گلاوباکس
۵۶	۳-۸ اندازه گیری خواص فوتوولتائی سلول خورشیدی
۵۷	۹-۳ لايه نشاني کندوپاش

۵۸	۳-۱۰ دستگاه لایه نشانی چرخشی۳
۵۹	۳–۱۱ روش های لایه نشانی پروسکایت
۵۹	۳-۱۱-۱ روش لایه نشانی دومرحله ای
۶۰	۳-۱۱-۲ روش لایه نشانی تک مرحله ای
۶۰	۳-۱۱-۳ روش تبخیری
۶۱	۳-۱۲ . روش ساخت سلول پروسکایت
۶۴	۳-۱۳ مشخصه های سلول خورشیدی۳
99	۳–۱۴ مقاومت های مزاحم
۶۷	۳–۱۵ جمع بندی
ى پروسكايتى	فصل چهارم:سنتز و آلایش TiO2وساخت سلول خورشید:
γ٠	۱–۴ مقدمه
γ٠	۲-۴ سنتز TiO2. سنتز TiO2
۷۰	۴-۲-۲ مواد مورد نیاز و روش های انجام آزمایش
٧٠	۴-۲-۲ بدست آوردن دی اکسیدتیتانیوم با فاز روتایل
۷۱	۲-۲-۴ آلایش TiO2 با سدیم
۷۲	۳-۲-۴ آنالیزUV-VIS
٧۴	۵-۲-۴ آنالیز XRD
٧۶	۴-۲-۴ آنالیز رامان
	1

ΥΥ	۴–۳–۲ مطالعه خواص نوری نانوذرات
٨٠	۴-۳-۴ طیف نگاری رامان
۸۱	۴–۳–۳ آنالیز ساختاری
٩٠	۴-۳-۴ آنالیز ریخت شناسی
۹۴	۴–۳–۵ آنالیز عنصری
٩٨	۴-۴ ساخت سلول
۱۰۹	۵-۴ مشخصه یابی سلول خورشیدی
117	۴-۶ جمع بندی
ش های آتی	فصل پنجم:جمع بندی و پیشنهادات برای پژوه
114	۵-۱ نتیجه گیری
114	۲-۵ پیشنهادات
۱۱۶	مراجع
	فهرست شکل ها
صفحه	عنوان
۳	شكل۱-۱طبقه بندى صنعت فوتو ولتايي به همراه درصد فروش
۵	شکل۱-۲ ساختار بلوری هالید پروسکایت آلی فلزی
۹	شكل۱-۳ ساختار سلول پروسكايت
۱۰	شکل۱-۴ طراحی های غالب سلول های خورشیدی پروسکایت
۲۲	شکل۲-۱٪ ساختار سلول خورشیدی پروسکایت متخلخل
و منحنی های جذب UV-VIS	شکل ۲-۲ الگوی پراشXRD از نمونه های خالص و آلایش یافته با آهن TiO ₂

شکل ۲-۳ (a) منحنی هایJ-V سلول های خورشیدی پروسکایت بر پایه TiO₂ خالص و آلایش یافته(b) نقص های TiO₂ خالص(c) جانشانی+Fe³⁺ درمکان نقص.....

شکل ۲- ۴(الف) نمودار لگاریتمی منحنی های I-V قطعه های باTiO2 خالص و آلایش یافته با آهن با FTO/TiO₂ (or TiO₂)/meso- J-V (ب) منحنى هاى FTO/TiO₂ or Fe³⁺-TiO₂/Au ساختار FTO/%1% mol//TiO₂/MAPbl₃/Spiro-OMeTAD/Au (ج) چگالی جریان حالت پایدار سلول های خالص وآلايش يافته..... شکل ۲-۵ خواص الکترونیکی سلول های خورشیدی آلایش یافته با آهن...... شکل ۲-۶ محاسبه گاف نواری بر مبنای طیف جذبی..... شکل ۲-۷ الگوی XRD نمونه های خالص و آلایش یافته با Al و Mgو عکس های SEM...............۳۰ شكل ٢-٨ الگوهاي XRD پودر TiO2 خالص و آلايش يافته با W......W الگوهاي XRD پودر XRD خالص و آلايش يافته با شکل ۲-۹ عکس های SEM سطحی از لایه TiO2 خالص و آلایش w با TiO2 و عکس های نمایش EDS عنصری شامل عناصر O، Ti و W..... شکل ۲–۱۰ منحنی هایV-I و ولتامتری دوره ای برای لایه های خالص و آلایش یافته با W با زیرلایه FTO و نمودار سطوح انرژی سلول های خورشیدی پروسکایتی۳۴ شکل ۲-۱۱ نمودارهای نایکوئست و منحنی های فیت شده آنها بر پایه TiO2 خالص و آلایش یافته............۳۶ شکل ۲–۱۲ عکس های SEM نشان دهنده ساختار میکرونی سطح (الف) TiO2 متخلخل بدون آلایش و مقادیر متفاوت آلايش Zn:TiO2

ودارهای J-V	کل۲-۱۳ الگوهایXRD و طیف جذبیUV-VIS و نمودار تاوک آلایش های مختلفTiO2 متخلخل و نم	ش
۴۰	لول های پروسکایت با آلایش های مختلف TiO2	w
۴۱	کل ۲-۱۴ طیف PL قطعه های با ساختار CH3NH3PbI3/meso-Zn:TiO2/dense TiO2/ FTO.	شک
47	کل ۲-۱۵ نمودار سطوح انرژی مقادیر مختلف آلایش TiO2 متخلخل باZn از طریق اندازه گیری UPS.	شک
۴۸	کل ۳-۱ دستگاه طیف سنج uv-vis مستقر در دانشگاه شاهرود	شک
۴٩	کار. ۳–۲ نمانی ا: دستگاه ESEM	شک

۵۲.	شکل ۳-۳ دستگاه XRD موجود در دانشگاه دامغان
۵۴	شکل ۳-۴ دستگاه رامان موجود در دانشگاه شاهرود
۵۵	شکل۳-۵ کوره الکتریکی موجود در دانشگاه شاهرود
۵۶	شکل ۳-۶ دستگاه گلاوباکس موجود در دانشگاه شاهرود
۵۷.	شکل۳-۷ الف-دستگاه شبیه ساز نور خورشید و دستگاه اندازه گیری V-I سلول خورشیدی
۵۸	شکل ۳-۸ دستگاه اسپاترینگ رومیزی موجود در دانشگاه شاهرود
۵۹	شکل ۳-۹ دستگاه لایه نشانی چرخشی
۶۲.	شکل ۳-۱۰روش های لایه نشانی تک مرحله ای و دومرحله ای
۶۳.	شکل ۳–۱۱ لایه نشانی دومرحلهای لایه پروسکایت
۶۵.	شکل ۳-۱۲ نمودار جریان-ولتاژ ومشخصه های سلول خورشیدی پروسکایت
99	شکل ۳–۱۳ مدار معادل
۶۷	شکل ۳–۱۴ اثر مقاومت های سری و موازی در نمودار جریان- ولتاژ
۷۱	شکل ۴-۱ نمودارهای جذب،عبور،تاوک وتاوک دی اکسید تیتانیوم روتایل
۷۲	شکل ۴-۲ نمودارهای جذب و تاوک دی اکسید تیتانیوم آلایش یافته با سدیم
۷۳	شکل ۴–۳ طبف XRD دی اکسید تیتانیوم وتایا
۷۵	شکل ۴-۴ محاسبه اندازه دانه و کرنش شبکه دی اکسید تیتانیوم روتایل با استفاده از چهار قله اول
٧۶	شکل ۴-۵ طيف رامان دي اکسيد تيتانيوم روتايل
۷۸	شکل۴-۶ طیف جذب و عبور نور نمونه های خالص TiO ₂ و آلایش یافته با آهن و آلومینیوم
٨٠	شکل۴-۷ نمودار تاوک برای نمونه های خالص TiO2 و آلایش یافته با آهن و آلومینیوم
۸۱	شکل ۴-۸ طیف رامان نمونه های خالص TiO ₂ و آلایش یافته با آهن و آلومینیوم
٨۴	شکل ۴-۹ طیف XRD نمونه های TiO ₂ آمورف و خالص وآلایش یافته با آهن و آلومینیوم

۸۵	شکل ۴–۱۰ محاسبه اندازه دانه و کرنش شبکه دی اکسید تیتانیوم آناتاز اولیه
٨۶	شکل ۴–۱۱ محاسبه اندازه دانه و کرنش شبکه دی اکسید تیتانیوم آناتاز
۸۷	شکل ۴–۱۲ محاسبه اندازه دانه و کرنش شبکه دی اکسید تیتانیوم آناتاز برای آلایش آلومینیوم
۸۸	شکل ۴-۱۳ محاسبه اندازه دانه و کرنش شبکه دی اکسید تیتانیوم آناتاز برای آلایش آهن
۹١	شکل ۴–۱۴ تصاویر FESEM برای دی اکسیدتیتانیوم خالص
۹۲	شكل ۴–۱۵ تصاوير FESEM مربوط به نانوذرات دى اكسيد تيتانيوم آلايش يافته با آلومينيوم
۹۳	شکل ۴–۱۶ تصاویر FESEM مربوط به نانوذرات دی اکسید تیتانیوم آلایش یافته با آهن
94	شکل ۴–۱۷ آنالیزEDAXدی اکسید تیتانیوم خالص
۹۵	شکل ۴–۱۸ آنالیز EDAXدی اکسید تیتانیوم آلایش یافته با آلومینیوم
٩۶	شکل ۴–۱۹ آنالیزEDAXدی اکسید تیتانیوم آلایش یافته با آهن
٩٩	شکل ۴-۲۰ نمودار های جذب و عبور لایه TiO ₂ فشرده
۱۰۱	شکل ۴-۲۱ نمودار طیف جذبی و تاوک لایه PbI2
۱۰۲	شکل۴-۲۲ نمایی از محلول PbI ₂ و پروسکایت
۱۰۳	شکل ۴-۲۳ طیف جذبی و رامان لایه پروسکایت دو مرحله ای چرخشی-چرخشی
۱۰۴	شکل ۴-۲۴ نمایه لایه پروسکایت دو مرحله ای چرخشی-غوطه وری
۱۰۵	شکل ۴-۲۵ نمودارهای رامان، جذب و تاوک لایه پروسکایت دو مرحله ای چرخشی-غوطه وری
۱۰۷	شکل ۴-۲۶ نمودارهای رامان و جذب پروسکایت یک مرحله ای
۱۰۹	شکل ۴–۲۷ نمایی از سلول های ساخته شده
۱۱۱	شكل ۴-۲۸ نمودار جريان-ولتاژ سلول خورشيدی

فهرست جدول ها

صفحه	عنوان
۶	جدول ۱-۱خواص فیزیکی بیشترین مواد فوتوولتایی رایج
۲۲	جدول ۲-۱ نتایج آنالیزEDAX برای آلایش۵٪لایه فشردهTiO2
۲٩	جدول ۲-۲ اندازه بلورک های نانو ذرات محاسبه شده با روش معادله شرر
۳۱	جدول ۲-۳ مقادیر فوتو ولتائی لایه متخلخل TiO₂ خالص و آلایش یافته سلول های پروسکایت
۳۶	جدول ۲-۴ مقادیر امپدانس سلول های خورشیدی پروسکایت
۴۱	جدول ۲-۵ پارامترهای فوتوولتائی سلول ها بر پایه لایه های متفاوت انتقال الکترون
٧۴	جدول ۴–۱ مقادیر زاویه ی قله پراش در فاز روتایل
۸۲	جدول ۴-۲ پارامتر های شبکه ای نانوپودر های سنتز شده
۸۳	جدول ۴–۳ درصد فاز های مختلف بلور
۸۵	جدول ۴–۴ مقادیر زاویه ی قله پراش در فاز آناتاز پودر اولیه
٨۶	جدول ۴–۵ مقادیر زاویه ی قله پراش در فاز آناتاز
۸۷	جدول ۴-۶ مقادیر زاویه ی قله پراش در فاز آناتاز برای آلایش آلومینیوم
٨٨	جدول ۴-۷ مقادیر زاویه ی قله پراش در فاز آناتاز برای آلایش برای آلایش با آهن
٨٩	جدول ۴–۸ مقایسه ویژگی های ذرات سنتز شده
٩۴	جدول ۴-۹ آنالیزEDAXدی اکسید تیتانیوم خالص
٩۵	جدول ۴-١٠ آنالیزEDAXدی اکسید تیتانیوم آلایش یافته با آلومینیوم
٩۶	جدول ۴–۱۱ آنالیزEDAXدی اکسید تیتانیوم آلایش یافته با آهن
٩٧	جدول ۴–۱۲ مقایسه درصد اتمی عناصر O و Ti در ترکیبات

۱۰/	۱۳-۱ مراحل ساخت سلول پروسکایت	جدول خ
۱١	۱۴-۱۲ مشخصات سلول خورشیدی	جدول ا

. فصل اول

معرفی سلول خورشیدی پروسکایت

انرژی خورشیدی، اصلی ترین منبع انرژی تجدیدپذیر است که به صورت تمام نشدنی و فراوان درسطح زمین دریافت می شود. فضای جو زمین از TW ۱۷۴۰۰۰ شار انرژی برخوردار است. توان بالقوه تابش خورشیدی که توسط برنامه سازمان ملل متحد در برآورد انرژی جهان ، در سال ۲۰۰۰ نشان داده شده ۴۹۸۳۷ ^۲EJ–۱۵۷۵ است که بسیار بالاتر از مصرف کل انرژی است که در سال ۲۰۱۲ برابر با ۵۵۹/۸ EJ بود. مقدار انرژی خورشیدی که توسط بخش های مختلف زمین دریافت می شود ، بستگی به عرض جغرافیایی منطقه مورد نظر دارد. درکشورهایی که که در زیر عرض ۴۵ درجه شمالی و بالاتر ۴۵ درجه عرض جنوبی جغرافیایی قرار دارند، به طور متوسط سالانه تابش خورشیدی بیش از ۱۶۰۰ kWh/m² است. انرژی خورشیدی را می توان براحتی برداشت کرد و به طور مستقیم توسط سلول فوتوولتائي به انرژي الكتريكي تبديل كرد. سلول فوتو ولتايي نوعي از دستگاه فوتوالكتريك است که خواص الکتریکی آن مانند جریان، ولتاژ و مقاومت، تحت تابش خورشید، تغییر می کند. سلولهای خورشیدی (^۳SCs) ازمواد نیمرسانا ساخته می شوند. هزینه تولید سلول های خورشیدی در کمتر از یک دهه به ۷۵٪ کاهش یافته است و در نتیجه سلول خورشیدی، خود را به عنوان یک سرمایه گذاری مناسب و جزو منابع متغیر انرژی معرفی کرده است و از انرژی ارزان قیمت خور شیدی بهره برده است [۴]. در سالهای اخیر استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به دلیل ویژگی های انوری و الکترونیکی منحصربه فرد آن مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. کاربردهای TiO_۲ درسلول های خورشیدی، حسگرها، کاتالیزورهای نوری ورنگدانه ها در رنگ ها، کرم های ضدآفتاب، مواد غذایی و غیره گزارش شده است. استفاده از نانو ساختارهای دی اکسیدتیتانیوم درسلول خورشیدی به عنوان لایه سدکننده حفره ولايه انتقال دهنده الكترون مرسوم است.

¹ Terawatt

² Exajoul

³ Solar cells

۲-۱ انواع سلول های خورشیدی

همانطور که در شکل (۱–۱) نشان داده شده است، سلول های خورشیدی با توجه به ترتیب توسعه در سه دسته سلول های نسل اول، دوم و سوم طبقه بندی می شوند. نسل اول سلول های خورشیدی (SCs) بر اساس بلور سیلیکون، نیمرسانای غالب برای فن آوری فتوولتائی ساخته شده است. بلور سیلیکونی(c-Si)



شکل(۱-۱) طبقه بندی صنعت فوتو ولتایی به همراه درصد فروش[۲]

در دو شکل تک بلور یا بس بلور متشکل از بلورهای کوچک موجود است. سلول های نسل دوم شامل لایه های نازک از CIGS^۳، ^۳CdTe و سیلیکون آمورف است که ضخامت لایه در آنها از چند نانومتر تا ده میکرون است و بسیار نازک تر از نسل اول متداول، از بلورهای فلزی ساخته شده است. تکنولوژی

¹ Crystal silicon

¹Cadmium Telluride

³ Copper-Indium-Gallium-Selenide

لایه نازک ارزانتر است، اما بازده تبدیل توان آنها (PCE^۱) نسبت به تکنولوژی c-Si رایج کمتر است. نسل سوم سلول های خورشیدی لایه نازک که در حال انجام تحقیق و توسعه است، شامل سلول خورشیدی با ترکیبات آلی، حساس رنگدانه ای، پلیمری، سولفید روی قلع مس (CZTS)، نانوبلور، میکروآمورف ها، نقاط کوانتومی^۲ و قطعات پروسکایتی است .

۱-۳ پروسکایت

دو اصطلاح پروسکایت و ساختار پروسکایت، به جای یکدیگر به کار می روند. پروسکایت یک ماده معدنی می باشد که برای اولین بار در کوههای اورال روسیه کشف شد و به افتخار کاشف معدن شناس، پروسکی، پروسکایت نامیده شد. ماده پروسکایت ترکیبی از کلسیم، تیتانیوم و اکسیژن با فرمول شیمیاییCaTiO3 می باشد. هر ساختاری شبیه ساختار ماده پروسکایت را "ساختار پروسکایت" می نامند. اصطلاح پروسکایت به ماده جاذب در سلول بر می گردد. پروسکایت ها یک گروه از مواد شیمیایی با فرمول شیمیایی RBX3 هستند. A و B کاتیون هستند و X یک آنیون است، بنابراین از لحاظ بار و ابعاد با هم قابل مقایسه نیستند A یک کاتیون و B دو کاتیون دارد و کاتیون A از B بزرگتر است. سلول خورشیدی پروسکایت شامل جزء پروسکایت، به طور کلی یک ترکیب آلی (معمولا متیل آمونیوم هالید)– غیر آلی (سرب یا با جایگزین قلع هالید) است که انرژی خورشیدی را جذب می کند و همچنین به عنوان یک حامل بار عمل می کند. شکل(۱–۲) ساختار بلوری هالید پروسکایت ها متشکل از متیل آمونیوم سرب هالیدها، RJNH3PS3 (CH3NH3) (I) ما خان را نشان می دهد که کاتیون ⁽¹ متی توسط PbX6 شش گوشی محصور شده است.

¹Power conversion efficiency

² Quantum Dot



شکل(۱-۲) ساختار بلوری هالید پروسکایت آلی فلزی[۵]

این نوع مواد ویژگی های برتری را برای استفاده درسلول خورشیدی به عنوان جاذب فوتو ولتائی نشان مي دهند كه خلاصه أن درجدول (۱–۱) أورده شده است. از جمله اين ويژگي ها مي توان به جذب نوری بالا اشاره کرد. لبه جذب پروسکایت، از ۸۰۰ nm می باشد. انرژی بستگی اکسیتون ها در پروسکایت، حدود ۰۲ ۳۳ /۰ می باشد و در دمای اتاق اکثر اکسیتون ها جدا شده و به حامل های آزاد بار تبديل مي شوند. ضريب جذب بالاي نانو بلورهاي پروسكايت باعث مي شود كه لايه پروسكايت در سلول های پروسکایتی نازک و درحدود ۳m ۴۰۰ باشد. ویژگی بعدی تحرک و طول پخش بالای الكترون و حفره مي باشد. جرم موثر الكترون و حفره ايجاد شده در پروسكايت كم مي باشد و در نتيجه تحرک حامل های بار بالاست. با توجه به زمان بالای بازترکیب الکترون- حفره در پروسکایت، طول پخش حامل ها بالا بوده و از ۱۰۰ nm تا ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰ نانومتر است. همچنین دارای مرزهای شبکه ای مناسب که بازترکیب الکترون- حفره را افزایش نمی دهند، تحمل نقص ساختاری و نقص های نقطه ای کم عمق عالی و میزان پایین بازترکیب سطحی می باشد. یکی دیگر از ویژگیهای بسیار جذاب مواد پروسکایت، گاف انرژی قابل تنظیم آن می باشد که می توان با تعویض هالوژن و استفاده از هالوژن های مناسب تر و همچنین ترکیبی از هالوژن های مختلف، پروسکایت هایی با رنگ ها و گاف های انرژی مختلف ایجاد کرد. انتقال الکترون/حفره متوازن و عمر حامل بار بیش از ns ۱۰۰ و گاف انرژی مستقیم از دیگر ویژگی های مواد جاذب پروسکایت است. به کار گرفتن مواد با گاف انرژی مستقیم منجر به جذب بیشتر نور و همچنین اتلاف کم انرژی می شود. در حقیقت در مقایسه با سایر سیستم

های فوتو ولتائی رایج، بسیاری از ویژگی های مناسب به عنوان ماده فعال در مقابل نور برای سلول های خورشیدی را دارد[۲]. یون های x آزاد هستند و می توانند در سراسر بلور آزادانه حرکت کنند و انرژی فعال سازی آنها eV 0 ست. مهاجرت یون، ناشی از تهی جا است. انرژی فعال سازی، به موقعیت هالیدها بستگی دارد. سلول های خورشیدی پروسکایت بخاطر فرایند تولید ساده و کم هزینه خود از سلول های خورشیدی سیلیکونی معمولی مزیت بیشتری دارند. ساخت سلول های سیلیکونی رایچ، شامل هزینه های فرایند چند مرحله ای است که در دما (0 C 0

	perovskite	Si	CIGS	GsAs	CdTe
گاف نواری/eV	١/۵	١/١	1/17	1/47	۱/۵
	(قابل تنظيم)				
ضریب جذب /-cm	۱ • ۴-۵	١٠٣	۱ • ^{۴-۵}	۱ • ۴-۵	۱۰۳
تحرک حامل ھا/ cm²V ⁻¹ s ⁻¹	تا ۲۰۰۰	10	<1.	۸۵۰۰	١٠
تراکم حامل ها/ cm ⁻³	1.18-14	1.18	1 • 10-18	١٠ ١٧	1+14-10
عمر حامل	> \ · · ns	ms	۵۰-۲۰۰ ns	< \ • • ns	۲۰ ns

جدول (۱-۱) ویژگی های فیزیکی مواد فوتوولتایی رایج [۶]

تحقیقات گسترده ای به طور عمده بر روی سلول های خورشیدی یدید سرب متیل آمونیوم انجام شده و بالاترین میزان PCE را با موفقیت به دست آورده اند (> ۲۰٪)، که بالاتر از سلول های خورشیدی

¹ CH₃NH₃Pbl₃ SCs

رنگدانه ای و آلی است. پیشرفت کشف مواد پروسکایت هیبرید آلی-غیر آلی برای تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی، نسل سوم دستگاه های فوتو ولتائی رامتحول کرده است[۲]. در مدت کمتر از نیم دهه تحقیق و توسعه در مورد سلول های خورشیدی پروسکایت ، بازده آنها تا بالای ۲۲٪ افزایش یافته است.

۴-۱ تاریخچه سلول های خورشیدی پروسکایتی

مواد پروسکایتی CH₃NH₃PbI3 و CH₃NH₃PbB7 به عنوان یک ماده فعال در برابر نور برای سلول های خورشیدی اولین بارتوسط کوجیما و همکاران با PCE ثبت شده ۸۸٫۳٪ استفاده شدند [۴]. بعدا این بازده با معرفی نقاط کوانتومی (QDS) CH₃NH₃PbI3 که با روش لایه نشانی چرخشی^۱ بر روی سطح نانو بلورهای TiO2 از طریق محلول پیش ساخته پروسکایت قرار داده شد، به ۶۵٫۶٪ افزایش یافت . توسعه سلول های خورشیدی چند لایه متخلخل که از ترکیب CH₃NH₃PbI3 به عنوان جمع کننده نور استفاده می کردند، بازده را به ۹/۹٪ افزایش داد. این لایه های پروسکایت، توسط واکنش بین متیل آمونیوم یدید و یدید سرب ایجاد شده و پس از آن روی یک زیرلایه متخلخل 20 تا با خخامت کمتر از میکرون انباشته می شوند و سپس توسط اسپایرو امتاد ^۲به عنوان رسانای حفره اشباع می شود. لی و همکاران او یک سلول خورشیدی با محلول پروسکایت نسبتا ارزان تر ارائه کردند و بازده را به ۱۰/۹۰٪ در یک دستگاه تک لایه ای رساندند [۴]. این سلول خورشیدی متخلخل با ساختار عالی، از آلومینای متخلخل⁷به عنوان یک سطح شیمیایی غیر فعال که باعث جذب بالای نور می شود و الکترون را مجبور به حرکت در لایه پروسکایت می کند، ساخته شده است. لی و همکاران او نشان دادند که به

¹ Spin Coat

² Spiro MeOTAD

³ Al₂O₃

سلول های خورشیدی نامتجانس مسطح (با تاکید بر خواص دوگانه لایه های نازک پروسکایت) که توسط روش های لایه نشانی بخار تولید شدند می تواند بازده را به بیش از ۱۵٪ در شرایط شبیه سازی کامل نور خورشید برسانند. این کشف نشان داد که سلول های خورشیدی با معماری ساده تر، با اجتناب از پیچیدگی های غیر ضروری مرتبط با نانو ساختارها می توانند کارایی بالاتری داشته باشند. گروه تحقیقاتی ژو و همکاران با ساخت لایه نازک پروسکایت با فرآیند بهبود یافته بازسازی تحت رطوبت معمولی، بازده را افزایش دادند. این روش به نوبه خود باعث کاهش بازترکیب حامل ها در لایه پروسکایت شده است. آنها همچنین ساز و کار انتقال الکترونی سلول خورشیدی را با استفاده از آلایش لایه انتقال الکترون TiO2 با ایتریم برای بالا بردن غلظت حامل بار و اصلاح الکترود اکسید قلع ایندیوم (TO) با کاهش تابع کار آن، بهره وری را تا ۱۹/۳٪ بهبود بخشیدند[۴].

جنگ و همکاران روش نوآورانه ای برای ساخت سلول خورشیدی⁽ (PHJ) پیوند ناهمگون مسطح معکوس تحت شرایط خلاء گزارش اند. لایه های سلول پروسکایت بر خلاف سلول های تک پیوندگاه p-n از تعداد لایه های بیشتری ساخته شده اند و فقط شامل یک پیوندگاه n-n نیستند و لایه پروسکایت هم الکترون و هم حفره تولید می کند. طراحی دستگاه سلول های خورشیدی PHJ می تواند از دو نوع، بسته به روش بکارگیری q-i-n استفاده شود: (الف) قطعه های رایج (ب) ساختار معکوس و به این ترتیب سلول خورشیدی مسطح با کارایی نزدیک به ۱۸٪ ایجاد می شود. روش آماده سازی لایه های سلول خورشیدی پروسکایت در خانواده سلول های خورشیدی لایه نازک و طراحی وسیله، عوامل کلیدی برای بازده بالای فرایند تبدیل نور به الکتریسیته هستند[۴].

¹ Planer hetero junction

۵-۱ ساختار سلول

طراحی سلول های خورشیدی پروسکایت، براساس ساختار استاندارد شکل(۱–۳)، نسبتا ساده است. یک شیشه رسانا یک لایه استخراج الکترون را پشتیبانی می کند (شبیه TiO₂ یا SnO₂). در بالای آن ماده فعال پروسکایت قرار داده می شود. یک ماده انتقال دهنده حفره ، روی لایه پروسکایت پوشانده می شود و تماس پشتی طلا معمولا به روش تبخیر حرارتی روی آن لایه نشانی می شود، هر چند قطعه در ساختار معکوس نیز کار می کند.



شکل(۱-۳) ساختار سلول پروسکایت الف)تصویر SEM برش مقطعی ب)نامگذاری لایه های سلول مربوطه[۶]

دو طراحی غالب سلول های خورشیدی پروسکایت وجود دارند: p-i-n و p-i-n و p-i-n که با عنوان لایه های چسبیده متخلخل و مسطح معروف هستند. سلولهای خورشیدی متخلخل پروسکایتی مشابه سلول های خورشیدی حساس شونده رنگدانه ای با رنگ حالت جامد هستند که در این ساختار مواد جاذب پروسکایت، منافذ داخل اسکلت را پر می کنند و در بعضی موارد یک لایه ای از پروسکایت در بالای این اسکلت نانو ذرات TiO₂ تشکیل می شود. سپس ماده انتقال دهنده حفره روی لایه ی پروسکایت لایه نشانی می شود و در نهایت یک لایه ای از فلز مورد نظر به عنوان الکترود مقابل لایه نشانی می شود شکل(۱–۳). لایه پروسکایت می تواند هم به عنوان حامل الکترون و هم به عنوان حامل حفره به کار رود. این ویژگی پروسکایت ها این توانایی را به پژوهشگران می دهد تا سلول های خورشیدی با ساختار مسطح بسازند که پروسکایت همزمان وظایف جذب نور، جدایش حامل های بار و انتقال حامل های بار بر عهده دارد. بنابر این سلولهای خورشیدی پروسکایتی مسطح به روش معکوس نیز ساخته می شوند. در این ساختار معکوس، استفاده از مواد آلی انتقال دهنده الکترون بجای لایه فشرده TiO2 می تواند از فرایند پخت دردمای بالا جلوگیری کند. حرارت برای ساخت این قطعه کمتر از C^o ۱۰۰ می باشد. به طور کلی سلولهای خورشیدی مسطح برای ساخت قطعه های قابل انعطاف بسیار مناسب هستند. مطابق شکل (۱-۴) در ساختار مسطح جمع کننده نور پروسکایت، به صورت لایه ای بین لایه های انتقال دهنده الکترون و حفره و الکترودها قرار داده می شود. لایه های انتقال الکترون و حفره، ضریب جمع آوری بار را افزایش می دهند و بازترکیب بین لایه ها را کاهش می دهند[۴].



شکل(۱-۴) طراحی های غالب سلول های خورشیدی پروسکایت(۷)

1-0-1 زيرلايه

زیرلایه فوتوالکترود به عنوان جمع آوری کننده الکترون برای جریان عمل می کند. بنابراین باید دارای رسانندگی خوبی باشد و با لایه نیمرسانای حساس شده اتصال اهمی برقرار کند. زیرلایه باید در ناحیه مرئی شفافیت بالایی داشته باشد تا بتواند بیشترین مقدار نور را از خود عبور دهد. همچنین باید در برابر دمای بالا در زمان پخت فوتوالکترود پایدار باشد. از اکسیدهای رسانای شفاف مانند اکسید قلع آلاییده

شده به فلوئور FTO^۱ و اکسید قلع آلاییده شده به ایندیوم ITO^۲ که بر روی شیشه لایه نشانی شدند به عنوان زیرلایه استفاده می شود. ITO دارای رسانندگی ویژه بالاتری نسبت FTO است. اما مقاومت ویژه ITO در دماهای بالاتر از C^o ۳۵۰ درجه به سرعت افزایش می یابد در حالیکه FTO پایدار باقی می ماند. تنها عامل محدودکننده، مقاومت اکسید رسانای شفاف است که نمی تواند به کمتر از مقدار ۱۰ اهم بر سانتیمتر مربع بدون از دست دادن قابل توجه عبور اپتیکی کاهش یابد[۸].

۲-۵-۱ لایه انتقال دهنده الکترون درسلول های خورشیدی پروسکایتی(ETL)

بازده تبدیل انرژی سلول های خورشیدی پروسکایت به سرعت از ۲۳/۸ تا ۲۲/۱٪ افزایش یافته است که اولین بار در سال ۲۰۰۹ گزارش شده است. برای این سلول ها لایه های انتقال الکترون نقش مشخصی را در انتقال الکترون ها و جلوگیری از حفره ها انجام می دهند. در اکثر سلول های پروسکایت TiO2^T به خاطر خواص الکترونی عالی به عنوان ماده انتقال الکترون، ترجیح داده می شود و از آن هم به عنوان لایه فشرده سدکننده حفره و هم لایه متخلخل که پروسکایت در آن نفوذ می کند و انتقال الکترون بهتر می شود، استفاده می شود. به عنوان مثال نوار رسانش TiO2 به خوبی با نوارهای لایه های فعال پروسکایت مطابقت می کند. بهر حال TiO2، ارزان قیمت، همساز با روش های مختلف لایه نشانی، دارای پایداری شیمیایی و رسانایی بالا است. اگرچه تهی جاهای اکسیژن، مکان های خالی بین اتم های Ti و مکان های گیراندازی در لایه های انتقال الکترون TiO2 وجود دارند که می توانند الکترون های تزریقی را جذب کنند و همانند مراکز بازتر کیب عمل کنند. این مکان های نقص و گیراندازی به طور حیرت آوری بازده و پایداری قطعه را پایین می آورند. بنابراین، ساخت یک لایه انتقال الکترون، با

¹ Flourine doped Tin Oxide

² Indium tin oxide

³ Titanium Dioxide

مهم است. پژوهش های قبلی نشان داده اند که انتقال الکترون در TiO₂ به طور موثری می تواند بوسیله آلایش یونهای فلزات مناسب افزایش یابد[۹].

1-0-1 لايه سدكننده حفره

هرچند ماده پروسکایت با توجه به خاصیت قطبی بودن خود تا اندازه ای حامل های بار ناشی از تابش فوتونی تولید شده را جدا می کند، اما وجود لایه انتقال دهنده الکترون و لایه انتقال دهنده حفره لازم می باشد. لایه های انتقال دهنده الکترون، در استخراج و انتقال الکترون های تولید شده فوتونی در سلول های خورشیدی پروسکایتی، مهم هستند. هدف اصلی ⁽ETLS انتقال الکترون های تولید شده فوتونی از لایه جاذب به لایه اکسید رسانای شفاف است و این کار به طور خودبه خودی مانع انتقال حفره ها می شود. بازتر کیب ناخواسته الکترون ها و حفره ها معمولا در طی فرایند انتقال بار اتفاق می افتد و بارها نابود می شوند. مثلا بازتر کیب الکترون ها و حفره ها معمولا در طی فرایند انتقال بار اتفاق می افتد و بارها مای لایه پروسکایت با حفره های لایه LTT³ و حفره های لایه پروسکایت یا بازتر کیب الکترون می شود. افزایش انتقال بار برای جلوگیری از بازتر کیب بارها، روشی موثر برای بهینه کردن بازده سلول می شود. افزایش انتقال بار برای جلوگیری از بازتر کیب بارها، روشی موثر برای بهینه کردن بازده سلول پروسکایت گفته می شود. بنابراین یک لایه ETL مناسب در کاهش جریان تاریکی و مقاومت سری و بالا بردن بلورینگی لایه پروسکایت تاثیرگذار است. با آن لایه سدکننده حفره در سلول های خورشیدی بالا بردن بلورینگی لایه پروسکایت تاثیرگذار است. بازم در کاهش جریان تاریکی و مقاومت سری و میرای ایجاد قابلیت بالای فوتوولتایی لازم است[۱۰]. یکی از مهمترین خصوصیات این لایه، ساختار متراکم آن می باشد. زیرا در صورت وجود تخلخل، پروسکایت با نفوذ در منافذ به زیرلایه رسیده و

¹ Electron transport layers

² Electron transport layer

³ Hole transport layer

بازتر کیب اتفاق می افتد. از TiO2 فشرده به عنوان لایه سد کننده حفره و انتقال دهنده الکترون استفاده می شود.

TiO₂ لایه نیمرسانای متخلخل

اخیرا بیشترین مطالعات بر روی سلول های خورشیدی متخلخل بوده است. ابتدا نانو بلورهای پروسکایت برای پرکردن منافذ درونی لایه متخلخل TiO2 استفاده شدند تا جذب نور را در سلول های خورشیدی رنگدانه ای افزایش دهند. اساس به کارگیری این لایه، افزایش سطح مقطع جذب می باشد. دلیل اصلی استفاده از TiO₂ آناتاز، لبه نوار رسانش مناسب آن (۴- تا ۴/۳ eV-) می باشد. طراحی متخلخل شامل استفاده از لايه متخلخل است و امكان استخراج سريع الكترون هاي توليد شده فوتوني پروسكايت، كوتاه کردن مسیر انتقال الکترون و عدم نیاز به بلورینگی با کیفیت بالا برای جمع آوری نور کافی را فراهم می کند. اگرچه در مقایسه با سایر ساختارها، سلول های خورشیدی پروسکایت متخلخل عموما ولتاژ مدار باز کمتری را از خود نشان می دهند و جذب نور کمتری در طول موج های کمتر از ۷۰۰nm دارند. عیب دیگر این طراحی، نیاز به پوشش بالای لایه پروسکایت است تا مانع از تماس بین لایه متخلخل و HTL شود که غالبا باعث ایجاد اتصال کوتاه می شود. هر چند نقش لایه متخلخل هنوز بخاطر بازده بالای PSCs مسطح یک موضوع مورد بحث می باشد که در رقابت به ۲۰/۷٪ رسیده است. TiO₂ معمولا به عنوان لایه متخلخل استفاده می شود زیرا ویژگی هایی مانند گاف انرژی نواری پهن eV ۳/۲ eV ، پایداری شیمیایی و حرارتی بالا، پایداری نوری بالا، غیر سمی بودن و قیمت پایین دارد. پروسکایت بس بلورى مى تواند به منافذ TiO2 نفوذ كند. اما پر كردن منافذ به شدت وابسته به ضخامت لايه متخلخل می باشد. لایه متخلخل TiO₂ با ضخامت بین ۴۴۰nm – ۲۶۰ برای پر کردن کامل منافذ TiO₂ متخلخل کافی است. یعنی مقدار فاصله بهینه برای تعادل بین جذب نور بیشینه و بازترکیب کمینه در مسیر بین این دو حد می باشد. بازده بالای قطعه شامل TiO₂ نازک متخلخل به چگالی بالای الکترون در TiO₂، بهبود میزان انتقال بار و بازده جمع آوری بار مربوط می شود. نیمرسانای ZnO نیز به عنوان جایگزین TiO₂ به طور وسیعی مطالعه شد. جدا از تحرک بالای الکترونی در مقایسه با TiO₂ و دمای پایین رسوب بستن ، سلول های ساخته شده با ZnO بازده پایینی ناشی از مشکل بازترکیب بیشتر دارند[۳].

TiO₂ آلایش TiO₂

یکی از راه های بهبود ویژگی های نوری و الکتریکی TiO2 آلایش است، یعنی عمدا ناخالصی را وارد ساختار TiO2 کنیم. در سلول های خورشیدی سیلیکونی، آلایش اغلب برای افزایش حامل های بار و در نتیجه بهبود رسانایی استفاده می شود. آلایش با دادن افزودنی با ظرفیت الکترونی بیشتر از ماده اصلی (آلایش نوع n) یا افزودنی با ظرفیت الکترونی کمتر از ماده اصلی (آلایش نوعq) ایجاد می شود. در مورد آلایش روع n) یا افزودنی با ظرفیت الکترونی کمتر از ماده اصلی (آلایش نوعq) ایجاد می شود. تاثیر معرود آلایش دوع n) یا افزودنی با ظرفیت الکترونی کمتر از ماده اصلی (آلایش نوعq) ایجاد می شود. با طرفیت معادل با گروه یونهای TiO2 می باشد. بهبود ویژگی های TiO2 ، با آلایش با عناصر با ظرفیت معادل با گروه یونهای TiO2 ظاهر می شود. آلایش با تعویض کاتیون های ⁺¹آ یا آنیون های ⁻²O حاصل می شود. آلایش های کاتیونی معمولا فلزات هستند و آلایش های آنیونی معمولا غیرفلزات هستند. لبه پایینی نوار هدایت از ترازهای Ti⁴⁴ تشکیل شده و با جابجایی⁺¹آبا یک کاتیون متفاوت ⁻²O حاصل می رود که ساختار نوار هدایت به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد. لبه بالایی نوار ظرفیت شامل انتظار می رود که ساختار نوار هدایت به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد. لبه بالایی نوار ظرفیت شامل نوارهای q²²O می باشد و با جابجایی ⁻²O با آنیون های متفاوت، انرژی نوار ظرفیت تحت تاثیر قرار بوارهای مو² می ناخالصی ها نباید خیلی با شعاع یونی که جایگزین می شود. تفاوت داشته باشد، می گیرد. شعاع اتمی ناخالصی ها نباید خیلی با شعاع یونی که جایگزین می شود. تفاوت داشته باشد، تا از اعوجاج شبکه و وارد شدن نقص های جدید که ممکن است قابلیت قطعه را مختل کنند، جلوگیری

1-۵-۳ لایه جاذب نور

لایه جاذب نور در سلول های خورشیدی پروسکایت، ماده پروسکایت می باشد. نیمرساناهای دیگر به کاربرده شده (مانند TiO2) نیز نور خورشیدی را متناسب با گاف انرژی خود جذب خواهند کرد اما سهم آنها در مقایسه با پروسکایت ناچیز است. جذب نور خورشید سبب تولید بار می شود و جفت حامل های بار مثبت و منفی از میان پروسکایت به الکترودهای مربوطه منتقل می شوند. هسته این قطعه (پروسکایت) دارای یک ترکیب عمومی ABX3 است که در آن A یک کاتیون تک ظرفیتی است (شبیه متیل آمونیوم ⁺²B1, فرمامیدیوم ⁺²(NH2) CS⁺.CH2 (NH2) و به جای B⁺²B و ⁺²B قرار می گیرد و x شامل I یا Br یا ID می باشد. موثر بودن این مواد، بوسیله خواص نوری الکترونیکی برجسته آنها ، ادغام کردن ضریب جذب و تحرک، انرژی بستگی پایین و طول پخش بلند متوازن حامل ها نمایان می شود[۶].

1-۵-۴ لایه انتقال دهنده حفره (HTL)

لایه انتقال دهنده حفره ، یک مولفه واجب برای رسیدن به بازده بالا درسلول های خورشیدی پروسکایتی است و نقش های حیاتی مانند سد انتقال الکترون به سمت آند، جمع آوری حفره های فوتونی ایجاد شده از پروسکایت و انتقال این بارها به سمت الکترود فلزی تماس پشتی و مانع شدن از تماس مستقیم بین لایه پروسکایت و الکترود فلزی دارد و باعث بهبود پایداری قطعه می شود. HTMs بازده انتقال حفره را بهبود می بخشد و همچنین Joc را با مشخص کردن شکاف سطوح انرژی شبه فرمی پروسکایت، تحت تاثیر قرار می دهد. برای HTM هم از مواد آلی و هم از مواد غیرآلی استفاده می کند. تا امروز متداول ترین ماده آلی انتقال دهنده حفره، اسپیرومئوتاد^۱ است که قیمت بالایی دارد و در حالت

¹ SPIRO MEOTAD

خالص به علت بازترکیب سریع حامل ها از رسانندگی پایین برخوردار است. بنابراین افزودنی ها و آلایش دهنده ها از قبیل ترکیبات کبالت ، TBP^۱ ترای بهبود رسانایی مورد نیاز هستند. معمولا LiTFSi⁷ برای بهبود رسانایی مورد نیاز هستند. معمولا LiTFSi⁷ را در استونیتریل حل می کنند و به محلول اسپیرومئوتاد اضافه می کنند و مشکل بازترکیب حامل ها تا حدود زیادی حل می شود**[۳].**

1-۵-۵ الکترود مقابل

کاتد وظیفه انتقال حفره ها به مدار را دارد. از الکترود های گوناگونی همچون نقره، طلا و پلاتین در این جهت استفاده شده است و مقاومت کم، مهمترین دلیل اسنفاده از این مواد است. در حال حاضر رایج ترین الکترود برای سلول های خورشیدی پروسکایت طلا می باشد. الکترود مقابل باید دارای ویژگیهای زیر باشد:

الف) کمترین خوردگی را در تماس با پروسکایت داشته باشد. ب) تابع کار آن بالا باشد. ج) باید بین الکترود و لایه نیمرسانا یک اتصال اهمی برقرار شود. اتصال اهمی به صورت اتصال فلز – نیمرسانا تعریف می شود که نسبت به مقاومت داخلی یا متوالی نیمرسانا دارای مقاومت اتصالی قابل چشم پوشی باشد. اگر اتصال اهمی رضایتبخش نباشد عمل قطعه را به طور قابل توجهی کاهش می دهد و می تواند جریان مورد لزوم را با افت ولتاژی عبور دهد که در مقایسه با افت در ناحیه فعال قطعه کوچک است[۸].

¹ 4-tert-butylpyridine

² lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

۱-۶ صنعتی سازی

با وجود اینکه سلول های خورشیدی پروسکایتی یک پتانسیل قوی دارند و بدلیل بهبود پیوسته بازده و ویژگی های قابل تنظیم، ساخت در دماهای پایین و قابلیت پرینت روی سطوح منعطف، می توانند نسل بعدی در تولید صنعتی قطعات فوتو ولتایی باشند، هنوز بعضی موانع جدی قبل از صنعتی شدن وجود دارد. برای مثال انتخاب مواد با هزینه کم و تهیه آسان برای لایه انتقال حفره و الکترود پشتی ضروری است. همچنین انتخاب زیرلایه رسانا، شناسایی روش های ساخت در اندازه های بزرگ و توسعه پیش نویس های افزایش عمر مناسب، موضوعات کلیدی هستند که در حال حاضر به وسیله جامعه علمی بین المللی در حال بررسی هستند.

۱-۷ جمع بندی

در این بخش ابتدا لزوم استفاده از سلول خورشیدی توضیح داده شد. سپس نسل های مختلف سلول های خورشیدی با هم مقایسه شدند. ویژگی های پروسکایت به عنوان ماده اصلی در سلول خورشیدی پروسکایتی و برتری های آن نسبت به سایر مواد بررسی شد. سیر تحول ساخت سلول پروسکایتی از ابتدا تا کنون بررسی شد و ساختارهای کلی سلول خورشیدی با هم مقایسه شدند. ساختار سلول استاندارد متخلخل n-i-p که در این پژوهش ساخته ساخته شد به طور کامل معرفی شد و ویژگی ها و وظایف انواع لایه های سلول توضیح داده شد. در مورد لایه های انتقال الکترون، شامل دو لایه فشرده و متخلخل و TiO2 ماده اصلی ساخت این لایه ها و دلیل آلایش این ماده توضیح بیشتری داده شد و در انتها صنعتی سازی سلول بررسی شد.

فصل دوم

مروری بر مقالات

درسالهای اخیر استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به خاطر خواص نوری و الکترونی آن و استفاده های زیاد ان درسلول های خورشیدی، حسگرها، فوتوکاتالیست ها و رنگدانه ها در رنگها و کرم های ضد افتاب، مواد غذایی و غیره توجه زیادی را به خود جلب کرده است. استفاده از نانوساختارهای دی اکسید تيتانيوم درسلول خورشيدي به عنوان لايه سدكننده حفره و لايه انتقال دهنده الكترون مرسوم است. گاف نواری زیاد و سطوح لبه باند مناسب برای تزریق و استخراج بار و مقاومت بی نظیر در مقابل خوردگی نوری و غیرسمی بودن و هزینه پایین ساخت، آن را به یک ماده مناسب برای ساخت سلول خورشیدی تبدیل کرده است. دی اکسید تیتانیوم دارای سه فاز روتایل (تتراگونال) با گاف نواری ۳/۰۵ و آناتاز (تتراگونال) با گاف نواری ۲/۲ و بروکیت (اورتورومبیک) با گاف نواری ۲/۹۵ eV می باشد که ازمیان آنها روتایل دارای بیشترین پایداری است و آناتاز بخاطر فعالیت الکترونی بیشتر، توجه زیادی را به خود جلب کرده است[۱۲]. دی اکسید تیتانیوم با فاز روتایل دارای گاف مستقیم و با فاز آناتاز هم دارای گاف نواری مستقیم و هم غیر مستقیم است[۱۳]. نوع روش های سنتز به کار برده شده، فازهای مختلف ماده را به دست می دهد. دی اکسیدتیتانیوم متخلخل پر از نقص های شبکه ای می باشد که در طول سنتز ایجاد می شوند. نقص های شبکه ای با واردکردن ناخالصی تحت تاثیر قرار داده می شوند. در مورد آلایش هم نوع ماده ناخالصی و هم محلی که ماده در شبکه دی اکسید تیتانیوم وارد می شود مهم هستند. در سال۲۰۱۴ گروه اسنایس، آلایش آلومینیوم را به لایه فشرده TiO2 اضافه کردند و در نتيجه رسانايي اين لايه بدليل كاهش تهي جاهاي اكسيژن تا چندين مرتبه بزرگي افزايش پيداكرد[۱۴]. ژو و همکاران او گزارش دادند که الایش ایتریم با لایه فشرده TiO₂، قابلیت ارسانایی و استخراج بار های لایه را افزایش داد و بازده سلول را تا۱۹/۳٪ افزایش داد[۱۴]. علاوه براین آلایش TiO2با ۲۰)Sm,(15)Cd,Zn,(16)Sn,Mg,(17)Nb,(18)Li,(19)Au نيز گزارش شده اند. اگرچه مطالعات محدودی روی آلایش TiO2 با آهن در سلول های پروسکایت گزارش شده اند. مطالعات قبلی آلایش آهن در TiO2 به بهبود خواص کاتالیزوری نوری، فعالیت نور مرئی یا تنظیم ساختارگاف نواری
معطوف بودند تا بهبود خواص الکتریکی برای کاربرد در سلول های خورشیدی پروسکایت. برای مثال یالسین و همکاران دریافتند که خواص فعالیت نور مرئی و فوتوکاتالیستی ذرات TiO₂ با آلایش آهن بهبود پیدا می کند و نتیجه مشابهی نیز توسط ژو و همکاران گزارش شده است[۱۴].

۲−۲ آلایش TiO₂ فشرده با Fe

PSCs و همکاران از آلایش یونهای Fe^{3+} در TiO₂ و استفاده از آن به عنوان PSCs در TiO₂. به آسانی از ترکیب محلول گزارش داده اند[1۴]. پیش ماده های محلول آلایش Fe^{3+} در TiO₂ TiO₂ به آسانی از ترکیب محلول گزارش داده اند[14]. پیش ماده های محلول آلایش Fe^{3+} در محلول TiO₂ به دست می آیند. در Fe(NO₃)₃ با نسبت های مناسب شامل ۵/.//۱//۲/و۵/ مولی در محلول TiO₂ به دست می آیند. در نتیجه به طور واضح مشاهده شد که رسانایی با یک مرتبه بزرگی افزایش می یابد و ولتاژ حد پر شدن تنیجه به طور واضح مشاهده شد که رسانایی با یک مرتبه بزرگی افزایش می یابد. و بازده از ۲۵/۹۹/ برای TiO₂ تنیجه به طور واضح مشاهده شد که رسانایی با یک مرتبه بزرگی افزایش می یابد. و بازده از ۲۵/۹۹/ برای TiO₂ TiO₂ خد پر شدن the all (VTFL) در لایه آلایش یافته درمقایسه با نمونه خالص کاهش می یابد. و بازده از ۲۵/۹۹/ برای TiO₂ TiO₂ TiO₂ (or TiO₂)/Meso می یابد. و بازده از FTO/Fe³⁺-TiO₂ (or TiO₂)/Meso می باشند. شکل ۲–۱ آمده است سلول های خورشیدی پروسکایتی متخلخل شامل SEM (Cor TiO₂)/Meso مربوط سلول های خورشیدی پروسکایتی متخلخل شامل TiO₂ مربوط و چ، عکس های Meso مربوط به درش مقطعی ۲–۱ (د) نشان می دهد که لایه های نازک بلوری با دانه های بلوری بار کنی هم می استند. عکس های Maco مربوط درش مقطعی ۲–۱ (د) نشان می دهد که لایه های نازک بلوری با دانه های بلوری بزرگ تهیه شده اند. شکل ۲–۱ (د) نشان می دهد که با افزایش تراکم آلایش، رنگ محلول ها به طور منظم به قرمز تبدیل شکل ۲–۱ (د) نشان می دهد که با افزایش تراکم آلایش، رنگ محلول ها به طور منظم به قرمز تبدیل شرک ۲–۱ (د) نشان می دهد که با افزایش تراکم آلایش، رنگ محلول ها به طور منظم به قرمز تبدیل شرک ۲–۱ (د) نشان می دهد که با افزایش تراکم آلایش، دیک محلول ها به طور منظم به قرمز تبدیل

¹ Trap filled limit voltage



شکل۲-۱ (الف) ساختار سلول خورشیدی پروسکایت متخلخل (ب) عکس هایSEMز SEMز (ج) و (ج) FTO/Fe³⁺-TiO₂ (د) عکس SEM برش مقطعی از سلول آلایش یافته (ه) محلول های خالص و آلایش یافته با آهن2TiO)

برای بررسی توزیع عناصر آهن، طیف توزیع انرژی EDS در پنج نقطه برای آلایش ۵٪ مولی در جدول (۱-۲)یادداشت شده است . مقدار میانگین درصد اتمی۶/۴٪ می باشد. نتایج نشان می دهد که آهن بطور یکنواخت درTiO2 توزیع شده است.

موقعيت	Fe/Ti(%)
١	۵/۹
٢	۵/ ۷
٣	۶/۵
۴	٧/١
۵	۶/٨
میانگین	۶/۴

جدول ۲-۱ نتایج آنالیز EDAX برای آلایش ۵٪ لایه فشرده (۱۴)(۱۴)

برای توضیح ساختار شبکه، تحلیل پراش پر تو X انجام شد. مطابق شکل ۲-۲(الف) همه لایه های فشرده TiO₂ آلایش یافته با درصدهای مختلف، دارای فاز آناتاز هستند. زیرا شعاع یونی ⁺³Fe بسیار شبیه ⁺¹Ti می باشد و آلایش +Fe³⁺ نمی تواند پارامتر شبکه TiO₂ را تغییر دهد. در شکل ۲-۲(ب) آنالیز جذب لایه های فشرده Fe³⁺- TiO₂ افزایش فعالیت نور مرئی با جابجایی قرمز را نشان می دهد. جذب با افزایش تراکم آلایش زیاد می شود. این می تواند به تشکیل سطوح انرژی آلایش آهن در بین گاف نواری TiO₂ نسبت داده شود. الگوی XRD لایه نازک پروسکایت MAPbI₃ مربوط به لایه های فشرده آلایش یافته و بدون آلایش نشان داده شده در شکل ۲-۲(ج)، یک ساختار بلوری یکسان را تایید می کند. طیف جذبی نشان داده شده در شکل ۲-۲(د) تغییر ناچیزی از اثرات آلایش در جذب ناحیه مرئی را نشان می دهد. منحنی های چگالی جریان-ولتاژ شکل ۲-۳(الف) تایید می کنند که سلول های آلایش یافته با ۱٪مولی آهن بهترین بازده را دارند. شکل ۲–۳(ب) نشان می دهد که تهی جاهای اکسیژن یا Ti^{3+} بخاطر تبدیل Ti^{4+} به TiO_2 شکاف های تیتانیوم، حاصل نقص های تناسب عنصری غالب بر شبکه TiO_2 هستند. بنابراین نقص های +Ti³⁺ می تواند یک سطح انرژی کم عمق زیر نوار رسانش ایجادکند و مانند یک مکان گیراندازی الکترون عمل کند و الکترونها را به دام بیاندازد و رسانش و بازده انتقال الکترون را کاهش دهد. مطابق شکل۲–۳(ج) دو یون ⁺⁴Fe می توانند جایگزین دو+Ti³⁺ مجاور نقص اکسیژن شوند. متعاقبا این جانشینی نقص تھی جاھای اکسیژن یا تله ھا را درلایه فشردہ منفعل می کند یا از بین می برد.



شکل ۲-۲ (الف) الگوی پراشXRD از نمونه های خالص و آلایش یافته با آهن TiO₂ (ب) منحنی های جذب -UV VIS از نمونه های خالص و آلایش یافته لایه های فشرده (ج) الگویXRD از لایه نازک پروسکایت با لایه خالص و آلایش یافته (د) خطوط جذبی سلول های با ساختار Fe³⁺-TiO₂/Perovskite یا PFTO/TiO₂(۱۴)

انتقال الکترون های تولید شده در اثر تابش فوتونی در لایه ها بوسیله نقص های بار-فضا محدود می شود. زمانی که مراکز تله، حامل های آزاد تولیدشده فوتونی را می گیرد، چگالی حامل های آزاد کاهش می یابد و منجر به جریان کمتر با شیب کمتر در ولتاژ یکطرفه می شود. اگرچه همانطور که ولتاژ، پیوسته افزایش می یابد، همه تله ها پر می شوند و اگر ولتاژ از نقطه کینک بگذرد جریان سریعا بطور غیر خطی با یک شیب تندتر افزایش می یابد. نقطه کینک ولتاژ آستانه پرشدن تله ها (VTFL) است. می توان مقدار VTFL را با محاسبه نقطه تقاطع دو شیب تخمین بزنیم. بنابراین VTFL بوسیله چگالی حالت های تله (Nt) می تواند مشخص شود.

$$V_{\rm TFL} = \frac{eN_t d^2}{2\epsilon\varepsilon_{\rm o}} \tag{1-T}$$

که در ان *P* بار الکترونی عنصر، d وع به ترتیب ضخامت و ثابت دی الکتریک نسبی لایه فعال و 50 نفوذپذیری خلا هستند. بر طبق معادله بالا می توان دید که با افزایش چگالی تله ها ، VTFL افزایش می نفوذپذیری خلا هستند. بر طبق معادله بالا می توان دید که با افزایش چگالی تله ها ما در در ایه فشرده IO کاهش می دهد، یابد. برای تایید اینکه آلایش ⁺⁴ Fe ، بطور موثر چگالی تله ها را در لایه فشرده مارد TiO کاهش می دهد، منحنی جریان-ولتاژ برای قطعه های آلایش یافته با آهن و بدون آلایش با ساختار نشان داده شده در زیر مجموعه شکل ۲-۴(الف) اندازه گیری شد. منحنی غیر خطی شکل ۲-۴(الف) وجود بارهای فضایی را (درشکاف های بین اتم های تیانیوم و یا تهی جاهای اکسیژن) مشخص می کند. برای بهترین شرایط آلایش آهن، منحنی جریان-ولتاژ بیشتر خطی است.



شکل ۲-۳ (الف) منحنی هایJ-V سلول های خورشیدی پروسکایت بر پایه TiO₂خالص و آلایش یافته(ب) نقص های TiO₂ خالص(ج) جانشانی+Fe³ درمکان نقص تهی جاهای اکسیژن منفعل شده +Ti(۱۴)

VTFL برای ۱٪مولی آلایش تقریبا ۴۵/۰ ولت است که کاملا از نمونه خالص کمتر است. (۶۴/۰ولت) و شکل۲-۹(الف) یک اختلاف مشخص در جریان بین نمونه خالص و آلایش یافته نشان می دهد. نتیجه نشان می دهد که چگالی مکان های تله در نمونه آلایش یافته بسیار کمتر از نمونه اولیه است. احتمالا به دلیل اینکه آلایش آهن بارهای فضایی را فروکش می کند، چگالی حامل ها و رسانایی TiO2 افزایش

می یابد. این نتایج با آزمایش اثر هال قابل تایید است. منحنی های رسانایی بر طبق تراکم آلایش ها و نتایج اثر هال در مجموعه شکل ۲-۴(الف) و شکل ضمیمه درون آن نشان داده شده است. جدول نشان می دهد که رسانایی +TiO₂- Fe³ در مقایسه با نمونه اولیه یک مرتبه بزرگی افزایش می یابد، که احتمالا در نتیجه افزایش چگالی حامل ها وکاهش مکان های تله درETL می باشد.

شکل۲-۴(ب) منحنی پسماند سلول ها است. تحت بهترین تراکم آلایش دهنده آهن، یک بازده بالای ۱۸/۰۱٪ با روبش معکوس و بازده ۱۷/۲۲٪ با روبش مستقیم برای سلول های پروسکایت پایه به دست آمد و یک کاهش نرم پسماند در مقایسه با نمونه های بدون آلایش مشاهده شد. این ممکن است بخاطر مشارکت یونهای آهن در غیرفعال کردن نقص های الکترونی یا مکان های گیراندازی ایجاد شده بوسیله نقص های تناسب عنصری اکسیژن وارد شده در شبکه TiOz باشد. منفعل کردن، استخراج الکترون های آزاد را افزایش داد و پسماند سلول را فرونشاند. شکل ۲-۴(ج) یک چگالی جریان حالت پایدار برای سلول پایه آلایش یافته را نشان می دهد، در حالیکه سلول پایه بدون آلایش دارای چگالی جریان برای سلول پایه آلایش داداو یک بازده ۱۲/۱۳٪ بعد از ۲۰۵۲ کار تحت ولتاژ ۷ ۸/۰ در جهت روبش معکوس برای سلول پایه آلایش یافته را نشان می دهد، در حالیکه سلول پایه بدون آلایش دارای چگالی جریان پایدار ۱۹/۲۴ mA/cm²



شکل ۲- ۴(الف) نمودار لگاریتمی منحنی های I-V قطعه های با2TiO خالص و آلایش یافته با آهن با ساختار FTO/TiO₂ (or TiO₂)/meso-TiO₂/MAPbI₃/Spiro-OMeTAD/Au J-V (ب) منحنی های orFe³⁺-TiO₂/Au (ب) منحنی های FTO/%1w mol

۲-۳ آلایش TiO2 فشرده با Al

اسنایس و همکاران او آلایش TiO₂ با آلومینیوم جهت کاربرد در سلول خورشیدی رنگدانه ای و پروسکایت را بررسی نمودند[۹]. در این پژوهش جزئیات ماهیت شیمیایی سطوح اکسید تیتانیوم در حضور اکسیژن و نور و نقش آن در بازدهی و پایداری سلول بررسی شد. نتایج نشان داد که کاهش بازده سلول های رنگدانه ای هنگامی که سلول در معرض نور خورشید در یک اتمسفر خنثی قرار بگیرد، قابل جبران است. این کاهش بازده به وسیله کمبود اکسیژن در TiO₂ ایجاد می شود و ادعا می شود که این امر بوسيله آزاد شدن فوتون هاي القا شده سطحي از اكيسژن هاي جذب سطحي ايجاد مي شود. اين امر به طور موثر با آلایش لایه TiO₂ متخلخل یا لایه فشرده TiO₂ استفاده شده در سلول پروسکایت با کاتیون های آلومینیوم کاهش می یابد و باعث افزایش هدایت TiO₂ با چند مرتبه بزرگی می شود. سلول های خورشیدی پروسکایت بر پایه ساختار عالی متخلخل، نیاز به لایه متخلخل TiO₂ را دارند. سپس این لایه با پایه عایق متخلخل که عمدتا Al₂O₃ بود جایگزین شد، هرچند هنوز یک لایه فشرده TiO₂ استفاده می شود. یک لایه فشرده با ضخامت ۵۰ nm از TiO₂ به دست آمده به روش شیمیایی سل-ژل با مقادیر مختلف آلایش آلومینیوم ۲/۵ ، ۱ ، ۲/۵ و ۵٪ آماده شد و سلول پروسکایت با استفاده از آنها با دارابودن لایه متخلخل آلومینا به ضخامت ۴۰۰nm ساخته شد. Voc برای آلایش های مذکور، افزایش قابل ملاحظه ای را نشان داد اما مقدار بازده کلی هیچ گونه بهبودی را در مقایسه با سلول بدون آلایش نشان نداد که احتمالا در نتیجه کاهش Jsc می باشد (با افزایشVoc مقدار Jsc کم می شود). بهینه سازی به کاهش مقدار آلایش به ۳/۰٪ منجر می شود که سلول ساخته شده با این آلایش افزایش مقدار Jsc وافزایش بازده ۱۳/۸٪ را در مقایسه با لایه فشرده خالص که بازده ۱۱/۱٪ را دارد، نشان می دهد شکل (۲–۵) [۹].



شکل ۲-۵ خواص الکترونیکی سلول های خورشیدی آلایش یافته با آهن: منحنی های J-V ثبت شده زیر نور شبیه سازی شده AM1.5(100mw/cm²)، همراه با جریان تاریکی (الف) سلول های خورشیدی رنگدانه ای با آلایش و بدون آلایش (ب) سلول های خورشیدی پروسکایتی با آلایش و بدون آلایش[۹]

۲-۲ آلایش TiO₂ متخلخل با Mg و Al

پیاسیری و همکاران تاثیر آلایش لایه متخلخل TiO₂ با آلومینیوم و منیزیم را بررسی کردند [5].آلایش روی ساختار شبکه ، ریخت شناسی و اندازه نانو ذرات TiO₂ تاثیر می گذارد جدول (۲-۲). این تغییرات مکان های گیراندازی و تله ها را کاهش می دهد و در حقیقت آستانه گاف نواری TiO₂ خالص را تنظیم می کند.



شکل ۲-۶ محاسبه گاف نواری بر مبنای طیف جذبی(۵)

جدول ۲-۲ اندازه بلورک های نانو ذرات محاسبه شده با روش معادله شرر (۵)

Pure TiO ₂	$20.7~\pm~0.2$
0.1 mol% Al TiO ₂	$24.2~\pm~0.2$
0.5 mol% Al TiO ₂	17.1 ± 0.2
1.0 mol% Al TiO ₂	$22.0~\pm~0.2$
$0.1 \text{ mol}\% \text{ Mg TiO}_2$	$22.7~\pm~0.2$
0.5 mol% Mg TiO ₂	19.0 ± 0.2
1.0 mol% Mg TiO ₂	22.7 ± 0.2
-	

در این گزارش آلایش لایه متخلخل TiO2 با بهینه سازی درصد مولی AI و Mg بازده سلول پروسکایت

را برای اولین بار افزایش داده است. حضور آلایش دهنده های Al وMg در TiO₂ بوسیله آنالیز EDS اثبات شده است. عکس های SEM شکل ۲–۷ (ب تا د) کلوخه نانوذرات آلایش یافته TiO₂ را نشان می دهد که ذرات بزرگتر تشکیل داده تا تخلخل کافی داشته باشند. اندازه و تخلخل لایه متخلخل TiO₂ مور عوامل مهمی برای تشکیل بلور پروسکایت هستند که بازده جمع آوری نور و استخراج حامل بار به طور مشخصی به آن وابسته است.



شکل ۲-۷ (الف) الگوی XRD نمونه های خالص و آلایش یافته با Al و Mgعکس های SEM برای

(ب) TiO_2 (د) 0.5mol%Mg TiO₂ (ج) 0.5mol% Al TiO₂ (ب)

آلایش منیزیم گاف نواری TiO₂ را افزایش می دهد در حالیکه آلایش آلومینیوم آن را کاهش می دهد شکل (۲-۶). همان طور که از جدول (۲-۳) مشخص است آلایش منیزیم نرخ بازترکیب الکترون و

حفره را کاهش می دهد، بنابراین J_{sc} و V_{oc} را افزایش می دهد. کاهش گاف نواری در اثر آلایش آلومینیوم باعث افزایش انتقال الکترون شده و در نتیجه J_{sc} و J_{sc} را افزایش می دهد. افزایش FF در آلایش آلومینیوم، در نتیجه افزایش تحرک الکترون است که نتیجه خاصیت رسانایی آلومینیوم می باشد. آلایش لایه متخلخل TiO₂ با درصد مولی بهینه AI و Mg می تواند آستانه CBM دی اکسید تیتانیوم و LUMO لایه جاذب پروسکایت را به خوبی تنظیم کند تا بازده سلول را بهبود ببخشد. در حالت نسبی آلایش AL

Anode	FF	<i>V_{oc}</i> (V)	J_{SC} (mA cm ⁻²)	PCE (%)	$R_s (\Omega \text{ cm}^2)$	R_{sh} (Ω cm ²)
Pure TiO ₂	0.618	1.00	18.62	11.49	10	254
0.1 mol% Mg TiO ₂	0.601	1.06	19.22	12.27	6.1	201
0.5 mol% Mg TiO ₂	0.607	1.06	19.00	12.24	6.6	227
1.0 mol% Mg TiO ₂	0.604	1.02	17.34	10.64	5.3	267
0.1 mol% Al TiO ₂	0.610	1.06	19.79	12.77	7.4	326
0.5 mol% Al TiO ₂	0.630	1.07	20.86	14.05	6.4	330
1.0 mol% Al TiO ₂	0.628	1.07	20.57	13.88	6.8	353

جدول ۲-۳ مقادیر فوتو ولتائیک لایه متخلخل TiO₂ خالص و آلایش یافته سلول های پروسکایت

۵-۲ آلایش TiO2 متخلخل با W

شی شانگ گو و همکاران خمیر خالص TiO₂ و آلایش یافته با تنگستن را به روش هیدروترمال با نسبت های مولی ۱۰۰۰،۱۰۰ و ۱۰۰۰۰۲ تهیه کردند و آنها را به روش دو مرحله ای به عنوان لایه متخلخل سلول خورشیدی پروسکایت در شرایط یکسان آماده کردند[۲].

الگوی XRD شکل (۲–۸) پودر TiO2 خالص و آلایش یافته با تنگستن، قله های فاز آناتاز را نشان می دهد. حضور فاز روتایل نیز مشاهده می شود. شدت قله فاز روتایل با افزایش میزان W کاهش می یابد و در ppm ۱۰۰۰۰ ناپدید می شود. از الگوی XRD هیچ قله WO³ آشکار نشده است در حالیکه نتایج XPS حضور W را اثبات کرده اند. بر مبنای این واقعیت که شعاع یونی (.60p.m)⁶⁺W و شعاع یونی (60.5p.m)⁴ Ti⁺⁴ خیلی شبیه هستند می توان نتیجه گرفت که W با جابجایی با یون های Ti⁺⁴ در ساختار TiO₂ شرکت کرده است.



شكل ۲-۸ الكوهاي XRD پودر TiO2 خالص و آلايش يافته با W(۲)

ریخت شناسی و ترکیب لایه TiO₂ با آنالیز SEM/EDS بررسی شد. از این آنالیز نتیجه می شود که لایه ها یک ساختار نوعی متخلخل و با اندازه ذرات یکسان دارند و ریخت شناسی لایه ها یکسان است. از عکس های SEM شکل (۲-۹) فهمیده می شود که TiO₂ به شکل نانو ذره است و علیرغم آلایش، دارای اندازه میانگین SEM ۲۰ ۲۰ می باشد. فضای صفحه شبکه TiO₂ برای TiO₂ بدون آلایش مطابق با صفحه (۱۰۱) از فاز آناتاز TiO₂ در حدود ۳۵nm/۱۰ست. می توان نتیجه گرفت که سطح آلایش استفاده شده اثر ناچیزی روی ریخت شناسی TiO₂ داشته است. طیف SDS برای آلایش موانی و ۱۰۰۰۰ پودر TiO₂، حضور عنصر W را در نمونه های آلایش یافته TiO₂تایید می کند. نسبت وزنی و اتمی هر عنصر نیز در داخل شکل (۲-۹) آمده است.



شکل ۲-۹ عکس SEM سطحی از (الف) لایه TiO2 خالص (ب) ۵۰ppm (ج) ۵۰ (ج) N۰۰ (د) (د) ۱۰۰ (ه) TiO2 سطحی از (الف) لایه تاک خالص (ب) ۲۰۰۰ و W در لایه آلایش یافته V۰۰۰ و W در لایه آلایش یافته TiO2 و TiO2 و TiO2

اندازه گیری های نقشه عنصری EDS طوری چیده شده اند که توزیع W را در لایه های TiO₂ توزیع شده یافته نشان دهند. از شکل ها واضح است که اتم های W بطور همگن در لایه های IiO₂ توزیع شده اند، که حدس زده می شود که اتم های W در نمونه های آلایش یافته با موفقیت آلایش یافته اند. برای نمونه های ۵۰ مدس زده می شود که اتم های W در نمونه های آلایش یافته با موفقیت آلایش یافته اند. برای نمونه های ۵۰ م. ۵۰ و ppm ۲۰۰۰ نشان دادن حضور W در TiO₂ بخاطر غلظت پایین آنها کاملا سخت است. اگرچه در نمونه های آلایش یافته با موفقیت آلایش یافته اند. برای سخت است. اگرچه در نمونه های آلایش یافته با موفقیت آلایش یافته اند. برای سخت است. اگرچه در نمونه های آلایش یافته با موفقیت در نمونه و تحت شرایط یکسان تهیه شده اند، الگوی XRD نمونه های آلایش یافته با 2012 که با همین روش و تحت شرایط یکسان تهیه شده اند، الگوی XRD نمونه ها یک جلوگیری تدریجی از تبدیل فاز آناتاز به روتایل را نشان داد. این انتها الکترونی و خواص مجموعه ، هدایت الکتریکی لایه های 2012 که روی TiO₂ به روتایل را نشان داد. این چنجلی است که می توان نتیجه گرفت که عنصر W با موفقیت در نمونه وارد شده است. برای بررسی انتقال الکترونی و خواص مجموعه ، هدایت الکتریکی لایه های 2012 که روی TiO₂ بررسی شد. رسانایی الکتریکی بطور مستقیم از شیب منحنی های V-I هر نمونه با S و L مشابه بدست آمد. رسانایی الکتریکی جلور معکوس با مقاومت $\frac{L}{\rho}$ مینایی الکتریکی بطور مستقیم از شیب منحنی های V-I هر نمونه با S و L مشابه بدست آمد. رسانایی الکتریکی بطور معکوس با مقاومت $\frac{L}{\rho}$ مینانسب است بطوریکه $\frac{L}{s}$ و م مقاومت و S مساحت سطح و بطور معکوس با مقاومت یا شیلی الکتریکی لایه های TiO بطور منظم با میزان آلایش W زیاد می شود L مند نمی دهد که لایه های آلایش یافته با W قابلیت انتقال الکترون طولانی تری و می از می می می می می نه و بران و برای می شود در و ای می می ده که لایه های آلایش الکتریکی لایه های TiO بطور منظم با میزان آلایش W زیاد می شود که نمان می دهد که لایه های آلایش یافته با W قابلیت انتقال الکترون طولانی تری دارند و برای جمع

آوری و انتقال الکترون بهتر است. تحرک بالاتر الکترون لایه ETL به حذف جابجایی نامتوازن بار در PSCs منجر می شود بطوریکه قبلا حفره های تولید شده بوسیله فوتون، سریعتر از الکترون ها توزیع می شدند. تحرک الکترون بطور واضح افزایش می یابد، در نتیجه به استخراج الکترون کافی منجر می شود. شکل(۲–۱۰) یک جابجایی مثبت پتانسیل آستانه جریان های ۱۰۰۰ و ppm ۱۰۰۰ را نشان می دهد که مشخص می کند که نوار رسانش 201 به سمت پایین حرکت می کند. موقعیت کمینه نوار رسانش (CBM) مربوط به کام خاص و الایش یافته که از اندازه گیری های Vo محاسبه شده است در شکل ۲–۱۰ (ج) نشان داده شده است. جابجایی به سمت پایین GB می تواند به تزریق و است در شکل ۲–۱۰ (ج) نشان داده شده است. جابجایی به سمت پایین قرکت می کند. موقعیت کمینه نوار رسانش (DBM) مربوط به 200 خاص و الایش یافته که از اندازه گیری های Vo محاسبه شده است در شکل ۲–۱۰ (ج) نشان داده شود. است. جابجایی به سمت پایین GB می تواند به تزریق و است در شکل ۲–۱۰ (ج) نشان داده شده است. جابجایی به سمت پایین BD می تواند به تزریق و است در شکل ۲–۱۰ (ج) نشان داده شده است. جابجایی به سمت پایین BD می تواند به ترون و است تریق و انتقال الکترون ها نسبت داده شود. اما ممکن است به کاهش V₀ منجر شود.



شکل ۲–۱۰ (الف) منحنی هایV-I و(ب) ولتامتری دوره ای برای لایه های خالص و آلایش یافته با W با زیرلایه FTO (ج) نمودار سطوح انرژی سلول های خورشیدی پروسکایتی پایه کربنی بدون انتقال دهنده حفره(۲)

در طیف جذبی لایه های TiO₂ خالص و ۱۰۰۰ و ppm ۱۰۰۰۰ با افزایش تراکم آلایش دهنده ها یک جابجایی قرمز لبه جذب مشاهده، بنابراین گاف نواری کاهش می یابد که به جابجایی مثبت نوار رسانش بعد از آلایش W نسبت داده می شود. خواص فوتوولتایی تحت تابش استاندارد AM1.5G (100mw/cm²) اندازه گیری شدند. مقادیر میانگین Voc,Jsc,FF و PCE برای بیش از ۴۰ سلول برای هر مقدار آلایش اندازه گیری شدند. نتایج بوضوح نشان می دهند که سلول های آلایش یافته ppm م مقدار آلایش اندازه گیری شدند. نتایج بوضوح نشان می دهند که ملول های آلایش یافته بهبود ۱۰۰۰ مقادیر Jsc , Jsc و FF بیشتری از نمونه های بدون آلایش دارند که ممکن است در نتیجه بهبود انتقال الکترونی بعد از آلایش W باشد. بازده سلول های خورشیدی بدون انتقال دهنده حفره بر مبنای الکترود شمارنده کربن تا بیش از ۱۲٪ با آلایش ۱۰۰۰ بهبود یافت. بهبود Sc از بهبود تزریق الکترون و بازدهی بهتر انتقال الکترون استخراج شده بوسیله نیروی اعمال شده کافی در نتیجه جابجایی مثبت نوار رسانش برحسب ترتیب آلایش ناشی می شود. بنابراین افزایش قابلیت انتقال الکترون می تواند بر مبنای قانون رسانش ۲-۲ توضیح داده شود.

 $\sigma = ne\mu \tag{(Y-Y)}$

که در آن P بار عنصر، n غلظت الکترون، و μ تحرک الکترونی می باشند. آلایش ⁺⁶ W بجای ⁺H دو الکترون آزاد ایجاد می کند که غلظت الکترون ها را بالا می برد و بنابراین رسانایی بیشتری بوسیله چگالی جریان فوتونی ایجاد شود. قابلیت پراکندگی نور بالاتر با آلایش نمونه ممکن است باعث افزایش *بوpm* چگالی جریان فوتونی ایجاد شود. قابلیت پراکندگی نور بالاتر با آلایش نمونه ممکن است باعث افزایش *ITO2* چگالی جریان فوتونی ایجاد شود. قابلیت پراکندگی نور بالاتر با آلایش نمونه ممکن است باعث افزایش *ITO2* شده باشد. بهبود *FF* در نتیجه افزایش غلظت بارهای سطحی *ITO2* است. سلول های با *ppm* در الایش دارای کاهش *PCE JVoc,FF* شامل افزایش بازترکیب بارها در نتیجه جابجایی غیر دلخواه به سمت پایین لبه نوار رسانش هستند. بنابراین با افزایش تراکم آلایش، تعداد نقص های زیاد، باعث افزایش بازترکیب بارها در تایجه عبر دلخواه به سمت پایین لبه نوار رسانش هستند. بنابراین با افزایش تراکم آلایش، تعداد نقص های زیاد، باعث افزایش بازترکیب بارها در تتیجه جابجایی غیر دلخواه به سمت پایین لبه نوار رسانش هستند. بنابراین با افزایش تراکم آلایش، تعداد نقص های زیاد، باعث افزایش بازترکیب بارها در نتیجه مای زیاد، باعث افزایش بازترکیب بارها و عامل بدتر کردن انتقال الکترون هستند. در نتیجه *ITO* در تاول باعث افزایش بازترکیب الکترون در سلول باعث افزایش بازترکیب الکترون در سلول باعث افزایش بازترکیب الکترون در سلول باعث افزایش بازترکیب درها و عامل بدتر کردن انتقال الکترون هر مطالعه انتفال و بازترکیب الکترون در سلول مهای خورشیدی است. اولین نیم دایره، فرایند انتقال حفره را نشان می دهد(*Rhole*) در حالیکه نیمدایره دوم مقاومت بازترکیب را (*Rnol*) در سطح بین *TiO2/Perovskite* نشان می دهد. نمودارهای می دهد. نمودارهای می دوم مرفره با می در می می در در مایند استفال می دوم را نشان می دهد. نمودارهای می دوم مقاومت بازترکیب را (*Rnol*) در سلول نیم می دوم در دانه داده شده است و منحنی های بدست آمده با استفاده از مدار مدار رازش شده اند و مقادیر در جدول (۲–۴) آورده شده اند.

¹ Fill factor



شکل ۲–۱۱ نمودارهای نایکویست سلول های خورشیدی پروسکایت و منحنی های برازش شده آنها بر پایه TiO2 خالص و آلایش یافته ، مجموعه داخلی مدل مدار معادل برای برازش کردن نمودار نایکوئست می باشد.(۲)

جدول ۲-۴ مقادیر امپدانس سلول های خورشیدی پروسکایت(۲)

Samples	$R_{s}(\Omega)$	R _{hole} (Ω)	$R_{rec}(\Omega)$
Pure	27.7	73.3	74.6
1000 ppm	31.0	59.5	101.9
10000 ppm	21.5	77.2	45.4

با در نظر گرفتن انتقال بار سریعتر و بازترکیب کمتر، سلول با ۱۰۰۰ ور مقایسه با TiO₂ خالص مقد/ر R_{hole} کمتر و R_{rec} بیشتری دارد. جابجایی به پایین مناسب نوار هدایت، پاسخگوی کاهش بازترکیب است و در نتیجه جبران مناسب و ثابت ماندن Voc را برای ۱۰۰۰ ppm آلایش W در فوتوآند TiO₂ همانند TiO² خالص شرح می دهد. به هرحال، برای سلول ۱۰۰۰۰ مقد/ر R_{rec} کاملا کوچک است، که مشخص کننده بازترکیب شدید حامل ها است و باعث کاهش بازده قطعه می شود.

۲-۶ آلایش TiO₂ متخلخل با Zn

مینگ چونگ وو و سایر همکاران با آلایش مقادیر متفاوت Zn با TiO₂ در لایه استخراج الکترون باعث افزایش قابلیت فوتوولتایی سلول PSCs شدند[۳]. آنها برای سنتز و آلایش از ترکیب دو روش سل-ژل و آبی-گرمایی استفاده کردند. نانوذرات سنتز شده با روش چاپ صفحه ای در ETL استفاده شدند. سپس ریخت شناسی سطح، ساختار بلوری، زاویه تماس، دینامیک انتقال بار، تحرک الکترون و رسانایی الکتریکی لایه های نازک با آلایش متفاوت بررسی شدند. در ادامه ^۱ KPFM برای آنالیز پتانسیل سطحی لایه های پروسکایت با آلایش های متفاوت استفاده شد تا رفتار استخراج الکترون را تحت تابش نور با طول موج های مختلف بررسی کند. سطح انرژی آلایش های مختلف با طیف شناسی نوری الکترونی فرابنفش (UPS) و طیف شناسی جذب UV-VIS تخمین زده شد.

نتایج نشان داد که آلایش ۵٪ مولی بهترین توافق مشخصه نواری را با پروسکایت دارد. در نهایت میانگین PCE مربوط به PSCs با لایه آلایش یافته از ۱۳/۱ به ۱۳/۱٪ افزایش یافت. برای سنتز Zn:TiO ابتدا PSCs مربوط به PSCs با لایه آلایش یافته از ۱۳/۱ به ۱۳/۵ محلول اسید استیک M ۵/۱۲ در ظرف 17/9 از ۱۲/۵ و ۵/۱۲ به استا ایزوپروپانول اضافه شد. مقدار ۹۰*m*ا محلول اسید استیک M ۵/۱۲ در ظرف دیگری تهیه شد. محتوای ظرف دوم به ظرف اول ریخته شد و با چرخش مداوم در حمام یخ برای *N* ۱۲ ادامه یافت. محلول شفاف در دمای 2° ۰۸ به مدت h مرارت داده شد و رنگ محلول سفید نیمه ادامه یافت. محلول شفاف در دمای 2° ۰۸ به مدت h مرارت داده شد و رنگ محلول سفید نیمه شفاف شد. سپس محلول داخل اتوکلاو در دمای 2° ۰۸ به مدت h مرارت داده شد و رنگ محلول سفید نیمه شفاف شد. سپس محلول داخل اتوکلاو در دمای 2° ۲۰ به مدت h مرارت داده شد و رنگ محلول سفید نیمه مشاف شد. سپس محلول داخل اتوکلاو در دمای 2° ۲۰ به مدت h مرارت داده شد و رنگ محلول سفید نیمه شدان محلول شفاف در دمای 2° ۲۰ به مدت h مرارت داده شد و رنگ محلول سفید نیمه مخلف شد. سپس محلول داخل اتوکلاو در دمای 2° ۲۰ به مدت h مرارت داده شد و منترینوئیل و اتیل سلولز مخورات 100 به دست آید. یک مخلوط ۲۳٪ وزنی از نانوذرات 100 با آلفا-ترپینوئیل و اتیل سلولز مختود آدی ترک ای در 100 با آلفا-ترپینوئیل و اتیل سلولز مختود آد در ای در 100 به دست آید. یک مخلوط ۲۰٪ وزنی از نانوذرات 100 با آلفا-ترپینوئیل و اتیل سلولز مختود آد در 100 به محتود 100 با آلفا-ترپینوئیل و اتیل سلولز مختود مختاف 100 به محتود 100 با آلفا-ترپینوئیل و اتیل سلولز مختود 100 به محتود 100 با آلفا-ترپینوئیل و اتیل سلولز مختود 100 با آلفا-ترپینوئیل محتود 100 به محتود 100 با آلفی مختود 100 به محتود 100 به محتود 100 با آلفا-ترپینوئیل و اتیل محتود مختود 100 با آلفا مرد 100 با آلفا-ترینو 100 با آلفا-ترپینوئیل و اتیل مختود مختود 100 با آلفی مختود 100 با آلفی محتود 100 با آلفی مختود 100 با آلفی

¹ Kelvin probe force microscopy

² α-terpineol (C₁₀H₁₈O)



شکل ۲–۱۲ عکس های SEM نشان دهنده ساختار میکرونی سطح (الف) TiO2 متخلخل بدون آلایش و مقادیر متفاوت Zn:TiO2 متخلخل شامل (ب) ۱٪ مولی (ج) ۳٪ مولی (د) ۵٪ مولی (ه) ۷٪ مولی (و) توزیع اندازه ذرات TiO2 متخلخل با سطوح متفاوت آلایش(۳)

منحنی های *J-V* مربوط به *PSCs با PSCs تحت* نور شبیه سازی شده استاندارد خورشید 100mw/cm²,AM1.5G با کمک سلول مرجع سیلیکونی با فیلتر *KG-5 ا*ندازه گیری شدند. اندازه گیری های قطعه با روبش معکوس(۱/۲ تا *۲۰*/۲–) و مستقیم (۲/۰– تا *۲*/۱) انجام شد. گام ولتاژ در ۱۰mV و زمان تاخیر ۵۰ ms تنظیم شد. ساختار میکرونی سطح و توزیع اندازه ذرات با آلایش های مختلف که بر روی شیشه *FTO* پوشش داده شده اند در شکل (۲–۱۲) نشان داده شده است. اتیلن

سلولز با حرارت $^{\circ}$ ۵۰۰ می تواند کاملا جدا شود. همه لایه های آلایش یافته ساختار متخلخل يكنواختي دارند. علاوه بر اين اندازه ذرات با افزايش سطح آلايش، افزايش مي يابد. هنگامي كه آلايش روی تا ۷٪ مولی افزایش می یابد، اندازه ذرات از 2/7n<u>m ± 13/8 (ب</u>دون آلایش) به 3/2n<u>m ± 17/5 (</u> افزایش می یابد. هنگامی که Zn در TiO₂ آلایش می یابد، افزایش اندازه ذرات ممکن است در نتیجه نرخ مختلف هیدرولیز و چگالش باشد. اجازه جایگزینی Zn به شبکه TiO₂ به وسیله قانون پائولینگ مشخص می شود. فاصله d₁₀₁ *مربوط* به TiO₂ آناتاز نیز افزایش می یابد زیرا شعاع اتمی ⁺Zn²⁺ (74pm) از شعاع اتمی (*Ti⁴⁺(60.5pm* بزرگتر است. ساختار متخلخل Zn:TiO₂ یک زمینه متخلخل برای جانشانی و نفوذ لایه پروسکایت می باشد. تعداد زیادی از PSCs با بازده بالا بر پایه طراحی متخلخل بنا شده اند. اثر آلاینده Zn روی ساختار بلوری و بلورینگی Zn:TiO₂ متخلخل اندازه گیری شد. مشخص شد که همه قله های پراش Zn:TiO₂ متخلخل به ساختار بلوری TiO₂ آناتاز چهار گوشی مربوط می شود. این نتایج مشارکت یون Zn در شبکه آناتاز را نشان می دهد. وقتی آلایش Zn افزایش می یابد مشخصه TiO₂ *آناتاز* (۱۰۱)کاهش می یابد، با در نظر گرفتن اینکه کاهش بلورینگی در نتیجه رسوب Zn آلایش یافته در بلور TiO₂ است. علاوه براین، در نتیجه شعاع یونی بزرگتر Zn²⁺(74pm) در مقایسه با (60.5pm) الما تاه ۵۵ آناتاز (۱۰۱) به آرامی به زاویه های پراکندگی کوچکتر جابجا می شود. طیف جذبی UV-VIS مقادیر مختلف Zn:TiO₂ متخلخل در شکل ۲–۱۳ (ج) نشان داده شده است. یک جابجایی اندک قرمز لبه جذب بعد از آلایش Zn وجود دارد. ورود Zn می تواند یک نوار جدید در گاف نواری TiO₂ ایجاد کند و ساختار الکترونی را تغییر دهد. اینجا گاف نواری از ۳/۷۴ eV (بدون آلایش) به ۳/۶۷ eV (آلایش ۲٪مولی) کاهش یافته است که از نمودار تاوک محاسبه شده است. نمودارهای J-V سلول ها با آلایش های مختلف در شکل ۲–۱۳(د) نشان داده شده است. خلاصه خصوصیات فوتوولتائی در جدول (۲-۵) ذکر شده است.



شکل۲-۱۳ (الف) الگوهای XRD (ب) طیف جذبی UV-VIS (ج) نمودار تاوک آلایش های مختلف TiO₂ شکل۲-۱۳ (الف) الگوهای *XRD (ج) متخلخل* (د) نمودارهای *J-V* سلول های پروسکایت با آلایش های مختلف *TiO2* (۳)

14	١
())

Sample Name	J_{sc}	V _{oc}	FF	PCE
	(mA/cm ²)	(V)	(%)	(%)
Non-doped meso-TiO ₂	19.8±0.6	0.98±0.01	67.2±2.4	13.0±0.5
1.0 mol% meso-Zn:TiO ₂	20.2±0.4	1.00 ± 0.01	69.5±1.5	14.0 ± 0.1
3.0 mol% meso-Zn:TiO ₂	21.1±0.2	1.03 ± 0.01	70.2±1.2	15.2±0.3
5.0 mol% meso-Zn:TiO ₂	21.6±0.6	1.05 ± 0.02	74.5±1.6	16.8±0.6
7.0 mol% meso-Zn:TiO ₂	19.8±0.5	1.06±0.01	73.6±2.0	15.4±0.4

آنها همچنین دینامیک حمل بار را با استفاده از طیف ^۱ PL بررسی کردند شکل (۲-۱۴). نمونه با

۸٪ مولی meso-Zn:TiO₂ بیشترین کاهش PL را داشت. کاهش شدت PL به استخراج الکترون های



شکل ۲-۱۴ طیف PL نمودارهای قطعه های با ساختار CH3NH3PbI3/meso-Zn:TiO2/dense TiO2/FTO (۳)

کافی از CH₃NH₃PbI3 به TiO₂ نسبت داده می شود. همچنین رفتار نابودی ناپایدار PL برای هر نمونه اندازه گیری شد. موقعیت نوار رسانش و ظرفیت مقادیر مختلف آلایش با UPS آنالیز شدند. نمودار

photoluminescence

سطوح انرژی با آلایش های مختلف در شکل (۲–۱۵) نشان داده شده است. هنگامی که سطح آلایش از ۰ تا ۷٪ مولی افزایش یابد، پیش بینی شد که بیشینه نوار ظرفیت از ۷/۸۷– تا ۷/۴۹ *eV* افزایش داشته باشد و کمینه نوار رسانش از ۴/۱۳– تا ۳/۸۰*eV– ج*ابجا شود. اگر چه فهمیده شد که کمینه نوار رسانش *CH₃NH₃PbI* باید در ۲/۹۰*eV– ج*ایگزیده شود. تزریق الکترون از *CH₃NH₃PbI* به رسانش *Reso-Zn:TiO₂ باید در ۷ meso-Zn:TiO₂ جایگزیده الکترون در CH₃NH₃PbI باعث افزایش شدت <i>PL* و زمان واپاشی میانگین می شود.

نتایج توضیح دادند که قطعه پروسکایت با Vmol% meso-Zn:TiO₂ دارای J_{sc} کمتر و V_{oc} بیشتر است. اگرچه کمینه نوار رسانش ۵*mol% meso-Zn:TiO*2 به مینیمم نوار رسانش ۵*CH*3NH3PbI3 نزدیک است. تنظیم مناسب نوار بین CH₃NH₃PbI₃ و ۵*mol% meso-Zn:TiO*2 می تواند بازده انتقال الکترون را بهبود دهد.



شکل ۲-۱۵ نمودار سطوح انرژی مقادیر مختلف آلایش TiO2 متخلخل با Zn از طریق اندازه گیری UPS (۳)

۲-۷ جمع بندی

در این فصل ابتدا مقدمه ای در مورد کاربرد و ویژگی های فازهای مختلف TiO₂ و دلیل آلایش های مختلف لایه TiO₂ در سلول های خورشیدی پروسکایت بیان شد. سپس سه مقاله در مورد آلایش آهن و آلومینیوم و منیزیم در لایه فشرده TiO₂ مرور شد. دو مقاله نیز درباره آلایش تنگستن و روی در لایه متخلخل *TiO*2 بررسی شدند. در ساخت محلول ها از روش های آبی-گرمایی و سل-ژل و یا ترکیبی از این دو روش استفاده شده است. در همه این مقاله ها تاثیر تراکم های متفاوت آلایش با آنالیزهای متفاوت، روی بازده سنون سازه گیری شده است.

فصل سوم

معرفي روش کمي سنترومشخصه پابي

در علم و فناوری نانو، پس از رشد مواد و ساخت قطعات ، موضوع آنالیز و مشخصه یابی نمونه ها ، از اهمیت اساسی برخوردار است. به عنوان مثال نوع و مقدار ناخالصی ها، شکل و توزیع اندازه ذرات و ساختار بلورین در ماهیت و کیفیت محصول نهایی موثر است. بنابراین نمونه های بدست آمده باید از نظر ریخت شناسی سطح، مشخصه یابی نوری، الکتریکی، ساختاری و غیره مورد بررسی قرار گیرند تا تشکیل نانوساختار مورد تایید قرار گرفته و ویژگی های فیزیکی آنها مشخص شود. در ادامه به برخی از این روش ها می پردازیم.

UV-VIS مطالعه ویژگی های نوری با روش طیف نگاری UV-VIS

طیف نگار نوری مرئی- فرا بنفش دستگاهی است که می تواند درصد نور عبوریافته، جذب شده و یا بازتاب شده از نمونه را به صورت تابعی از طول موج اندازه گیری نماید. در این دستگاه نور توسط یک منبع نور، تولید شده و پس ازگذشتن از میان نمونه موردنظر نور، به صورت طیفی منتشر می شود، سپس توسط حسگرها آشکارسازی می شود. خروجی طیف نگار همیشه نموداری از شدت نور نسبت به طول موج است.

۲-۲-۳ روش های تجربی برای بدست آوردن مقدار انرژی گاف نیمرسانا

نیمرساناها براساس نوع گاف انرژی خود به دو دسته نیمرسانا با گاف انرژی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم بندی می شوند. ضریب جذب اپتیکی ۲ از رابطه بیرلامبرت بدست می آید، که می توان آن را به شکل زیر باز نویسی نمود:

$$\alpha = \frac{1}{t} \operatorname{Ln} \frac{T_{o}}{T}$$
 (1-7)

$$\alpha h \upsilon = A(E - E_g)^n \tag{Y-W}$$

که درآن α ضریب جذب اپتیکی ماده و *h*u انرژی فوتون و *E*g انرژی گاف نواری و *A* یک مقدار ثابت است. عدد توان *n* بستگی به طبیعت انتقال درطول فرایند جذب دارد. که به ترتیب بازای گذار های مستقیم مجاز و غیر مجاز $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ و برای گذار های غیرمستقیم مجاز و غیرمجاز ۳و ۲ = *n* می باشد. برای بدست آوردن گاف انرژی کافی است نمودار تغییرات *n*^(1/n) را بر حسب *hu* رسم نموده ، با برون یابی قسمت خطی نمودار از روی محل تقاطع خط مماس بر منحنی با محور انرژی مقدار *E*g بدست می آید.

۳-۲-۳ وابستگی گاف انرژی به اندازه نانوذرات

یکی از پارامترهای مهمی که گاف انرژی نانوذرات را تحت تاثیر قرارمی دهد، اندازه یا قطر نانوذرات می باشد. در واقع وقتی اندازه نانوذرات خیلی کوچک می شود (کمتر از nm ۱۵) ابعاد نانوذرات از مرتبه طول موج فوتون می گردد و پدیده ی حبس کوانتومی رخ می دهد. براساس پدیده حبس کوانتومی، فوتون ها درفضای بین نانوذرات، گیر می افتند و مقدار گاف انرژی بیشتر می شود در این صورت گاف انرژی به اندازه $\frac{h^2\pi^2}{2\mu r^2}$ از گاف انرژی ماده بزرگتر است. که r شعاع اندازه نانوذره و μ جرم کاهش یافته الکترون و حفره است.

$$E=Eg+\frac{h^2\pi^2}{2\mu r^2}$$
(\mathcal{T}-\mathcal{T})

دستگاه مورد استفاده در اندازه گیری ها ساخت کارخانه shimadzu ژاپن می باشد که در شکل (۱-۱) نشان داده شده است. اندازه گیری طیف عبوری، جذب و بازتاب لایه های نازک و طیف عبوری، جذب برای محلول ها در بازه ۱۹۰ الی ۱۱۰۰ نانومتر می باشد.



شکل (۳-۱) دستگاه طیف سنج Uv-Vis مستقر در دانشگاه صنعتی شاهرود

۳-۳ آناليز SEM-EDS

در پژوهش های مربوط به بررسی خواص مواد نانوساختار، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) یکی از مهمترین و پرکاربردترین دستگاه هایی است که بر اساس برهم کنش الکترون با ماده کار می کند و در اغلب مطالعات، برای تعیین اندازه و شکل مواد نانوساختار از این میکروسکوپ استفاده می شود. سیگنالهای مورد استفاده توسط SEM برای تولید تصویر نتیجه برهم کنش پرتو الکترون با اتمهای نمونه مورد آزمون در عمقهای متفاوت میباشد. از نمایش نتایج حاصل بر روی یک نمایشگر، تصویری شکل میگیرد که همانند تصویر تلویزیون همواره در حال جاروب کردن صفحه نمایشگر است به این ترتیب و بسته به اندر کنشی که خواص آن ثبت گردیده، تصویری حاصل می شود که می تواند خصوصیت ریخت شناسی یا ترکیب عنصری نمونه در لایه های سطحی آن را بیان کند. شکل (۳-۲)



شکل (۳–۲) نمایی از دستگاه *FESEM*

در سیستم EDS نمونه به وسیله پرتو الکترونی بمباران می شود. در اثر برخورد الکترون ها به نمونه، برخی از الکترون های اتم از ، جای خودشان خارج می شوند. برای رسیدن اتم به حالت تعادل، الکترون از ترازهای بالاتر به محل خالی ایجاد شده مهاجرت کرده، جای خالی را پر می کند. برای انجام این عمل، الکترون های تراز بالاتر که دارای انرژی بیشتری هستند، باید بخشی از انرژی خود را از دست بدهند تا به سطح انرژی تراز جدید رسیده، پایدار شوند که در این حالت، انرژی به صورت پرتو X منتشر می شود. مقدار انرژی آزاد شده به ترازهایی که الکترون از آن جدا شده یا به آن مهاجرت کرده، بستگی دارد. از طرفی، اتم های هر عنصر در حین انتقال از ترازی به تراز دیگر پرتو X (با مقدار انرژی منحصر به فرد) از خودشان ساطع می کنند. بنابراین با اندازه گیری مقدار انرژی پرتو X آزاد شده در حین بمباران الکترونی یک نمونه، می توان نوع اتم موجود در آن را مشتخص کرد که نتایج آن به صورت طیف *EDS* نشان داده می شود. این نمودار بر اساس میزان دریافت انرژی X از هر تراز انرژی رسم شده است. هر یک از قله های نشان داده شده در این نمودار، به یک اتم خاص اختصاص دارد. قله های با است. هر یک از قله های نشان داده شده در این نمودار، به یک اتم خاص اختصاص دارد. قله های با آرتفاع بیشتر به معنی غلظت بیشتر عنصر مورد نظر در نمونه است. نکته دارای اهمیت در خصوص تفاوت در نوع پرتو آزاد شده است. به طور مثال، اگر الکترون از تراز L به تراز X مهاجرت کند، به پیک آزاد شده، پیک *Alpha و* به قله ناشی از رفتن الکترون از تراز M به تراز X مهاجرت کند، به پیک *TESCAN BRNO-Mira3* و به قله ناشی نشر میدانی مدل دستگاه دستگاه *ENS* می ا *LMU*

۳-۴ آناليز **XRD**

از دستگاه پراش پرتو X در شناسایی انواع ویژگی های بلوری مواد استفاده می شود. دستگاه XRD بخش های مختلفی شامل منبع پرتوی ایکس، نمونه، آشکارساز و فیلترهای اپتیکی (نوری) پرتوی ایکس تشکیل می شود. اساس عملکرد آن مطابق قانون براگ، به این صورت است که پرتوی ایکس در زوایای مختلف به نمونه تابیده و پس از پراکندگی، توسط آشکارساز دریافت می شود و شدت آن براساس زاویه های مختلف به نمونه تابیده و پس از پراکندگی، توسط آشکارساز دریافت می شود و شدت آن براساس زاویه مختلف به نمونه تابیده و پس از پراکندگی، توسط آشکارساز دریافت می شود و شدت آن براساس زاویه های مختلف به نمونه تابیده و پس از پراکندگی، توسط آشکارساز دریافت می شود و شدت آن براساس زاویه مختلف به نمونه تابیده و پس از پراکندگی، توسط آشکارساز دریافت می شود و شدت آن براساس زاویه های مختلف برخورد، به صورت نموداری نمایش داده می شود که اگر تداخل سازنده صورت گرفته باشد، شدت پرتوی پراشیده و به بیش ترین مقدار خود می رسد و اگر تداخل ویرانگر صورت گرفته باشد، شدت پرتوی پراشیده کم است. مواد مختلف به دلیل چیدمان و نظم های متفاوت اتمی دارای الگوی پراش متفاوتی هستند. نمودار برای شدت پرتو بر حسب θ رسم

میشود که در برخی زوایای خاص قله مشاهده می شود. مواد آمورف هیچ گونه قله ای ایجاد نمی کنند. مواد با ترکیب شیمیایی یکسان می توانند فازهای بلوری متفاوتی داشته باشند که با الگوی پراش اشعه ایکس شناخته خواهند شد. با توجه به شدت نسبی قله فازها، می توان مقدار نسبی فازها را در یک مخلوط فازی مشخص کرد. هر ماده ای در زوایای خاصی قله می دهد. برای آنکه متوجه شویم درون نمونه یک ماده ی خاص وجود دارد، باید در طیف به دست آمده، همه ی زوایای مربوط به قله های اصلی آن ماده مشاهده شود. گاهی تفاوت کوچکی در زوایای قله ها در مطابقت با الگو مشاهده می شود که به دلیل خطای دستگاهی آزمایشگاهی است و قابل صرف نظر کردن است. همچنین برخی قله ها که شدت کمی دارند و در طیف الگو وجود دارند، در الگوی XRD مشاهده نمی شوند و حذف شده اند، نیز قابل صرف نظر کردن هستند. به منظور آنالیز کمی، روشهای مختلفی وجود دارد که ساده ترین و ابتدایی ترین روش، روش شرر است. در روش شرر، ابتدا قله های ماده را مشخص کرده، شدت و زاویه ی هر قله از طیف به دست آمده استخراج می شود و با استفاده از قانون براگ، فاصله ی بین صفحات بلوری(d) را محاسبه کرد. (با توجه به قانون براگ می توان دریافت که هرچه قله در زاویه ی کمتر باشد، فاصله ی صفحات بیش تر است). در مرحله ی بعد می توان با محاسبه ی عرض قله در نصف شدت، بیشینه ها را به طور تقریبی محاسبه کرد. برای این منظور، ابتدا شدیدترین قله را در زاویه ی در نظر گرفته و پهنای قله را در نصف شدت پیک به دست می آوریم. توجه داشته باشید که اینhetaمقدار باید بر حسب رادیان باشد. اکنون با استفاده از رابطه ی شرر می توانیم اندازه ی تقریبی بلورک (D)را محاسبه کنیم.

 $D = 0.9 \times \lambda / \beta \cos \theta \tag{(f-r)}$

با توجه به رابطه ی شرر می توان دریافت که هرچه اندازه ی ذرات ماده کوچک تر باشد، پهنای تمام در نیم بیشینه (*FWHM*) بزرگ تر است، یعنی قله پهن تر و شدت آن کمتر است، یعنی قله نانوذرات در مقایسه با مواد معمولی شدت کمتر و پهنای بیش تری دارند[۲۲].

در این پایان نامه از دستگاه (XRD D8-Advance, Bruker, Cu Kα1 (λ= 0.15406 nm با هدف شناسایی ویژگی های بلور استفاده شده است که نمایی از آن در شکل (۳–۳) آمده است.



شکل (۳-۳) دستگاه XRD موجود در دانشگاه دامغان

۳-۵ آنالیز رامان

برهم کنش نور با ماده در ناحیه مادون قرمز می تواند به صورت جذب یا پراکندگی صورت گیرد. اگر پرتوهایی که به ماده برخورد می کنند، به صورت ناکشسان پراکنده شوند، پراکندگی رامان رخ داده است. این نوع پراکندگی همراه با جابجایی انرژی بین مولکول و فوتون فرودی است، به طوری که طول موج فوتون تغییر کرده و بخشی از انرژی آن به ماده منتقل شده است. میزان تفاوت در طول موج ها

¹ Full Width of Half Maximum

وابسته به ساختار مولکولی ترکیبات بوده و با تجزیه و تحلیل این تغییرات انرژی امکان مطالعه ساختار مولکولی ترکیبات متعددی فراهم شده است. دستگاه طیف سنجی رامان برای طیف وسیعی از کاربردها از جمله شناسایی، تأیید و بررسی خواص متفاوت مواد مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه مورد استفاده در این پایان نامه، محصول شرکت Avantes مدل uRaman-532-Ci است که نمایی از آن در عکس(۳–۴) آمده است. این دستگاه دارای یک میکروسکوپ کانفوکال جهت آنالیز نقطه به نقطه میکروسکوپی و بررسی سطح نمونه می باشد. مشخصات فنی : لیزر با طول موج ۵۳۲ *nm* (قابل استفاده برای مواد اشتعال زا) و گستره طیف سنجی¹-۴۰۰۰ cm - ۴۰۰۰ و قدرت تفکیک طیف سنجی cm ¹ ۶ و تمام یهنای نیم بیشینه لیزر (FWHM) O.O2 nm می باشد. این دستگاه قابلیت طیف سنجی برای نمونه های جامد و مایع را در ابعاد و حجم مختلف داراست. طیف رامان شناخت بیشتری از ترکیب فازی نمونه های *TiO*۲می دهد. رامان به آلایش های فازی کم، بسیارحساس است که ممکن است توسط XRD آشکار نشود و برای پیدا کردن حالت چرخشی، ارتعاشی و دیگرحالت های فرکانس پایین در یک سیستم استفاده می شود. هرماده یک طیف مشخصی دارد و بدین وسیله می توان آلایش ها را تشخيص داد. آلايش ها حالت ها را تغيير مي دهند و به اين ترتيب مي توان اثر نفوذ ناخالصي رادر شبکه بلوری TiO_r اندازه گیری کرد. طیف نگاری رامان به ویژه برای تشخیص تهی جاهای اکسیژن مفىد است.



شکل (۳-۴) دستگاه رامان موجود در دانشگاه صنعتی شاهرود

۳-۶ کورہ الکتریکی

کوره های الکتریکی عموما جهت ایجاد اتمسفرهای کنترل شده یا خلا با استفاده از لوله های سرامیکی فلزی یا کوارتز ارائه می گردد و اغلب به دو صورت افقی و عمودی عرضه می شوند. در این پایان نامه از کوره آترا مدل AF 18/1200 برای اعمال حرارت استفاده شد. شکل (۳–۵)



شکل (۳-۵) کوره الکتریکی موجود در دانشگاه صنعتی شاهرود

۳-۷ گلاوباکس

در آزمایشگاه هایی که از مواد سمی، یا مواد حساس به اکسیژن یا آب استفاده می شود، گلاوباکس یک ضرورت است. گلاوباکس فضایی بسته با شرایط کنترل شده را ایجاد کرده و امکان انجام آزمایش های حساس یا ساخت ترکیباتی که به محیط بی اثر و قابل کنترل نیاز دارند را فراهم می آورد . در انجام این پایان نامه از گلاوباکس VBOX1-HIM ساخت شرکت backer استفاده شده است شکل (۳–۶).



شکل (۳-۶) دستگاه گلاوباکس موجود در دانشگاه صنعتی شاهرود

۸-۳ اندازه گیری خواص فوتوولتائی سلول خورشیدی

شبیهساز نور خورشیدی تحت تابش نور قرار می گیرد و به ولتاژ معکوس وصل می شود و بعد از تولید انرژی الکتریکی، نمودار ولتاژ بر حسب جریان از آن روبش می شود. دستگاه جریان سلول خورشیدی را در ولتاژهای مختلف اعمالی اندازه گیری می کند. قابلیت تنظیم نرخ روبش ولتاژ اعمالی وجود دارد. داده های تولید شده قابل ذخیره و انتقال به رایانه هستند. شبیه ساز طیف خورشیدی جهت اندازه گیری های استاندارد سلول های خورشیدی (AM1.5) بکار می رود که بر اساس نور LED عمل می کند و نور خورشید را از mn ۱۰۰۰ – ۳۸۰ شبیه سازی می کند . میزان اختلاف طیفی دستگاه با خورشید کمتراز %۵ می باشد ودارای جک مکانیکی جهت تنظیم فاصله نمونه و نیز دیود نوری استاندارد شده جهت اندازه گیری شدت نور تک تک LED ها و نیز شدت کل می باشد. برای آزمایش هایی که بخش *I*I طیف باعث تخریب نمونه می شود می توان این بخش را به صورت انتخابی حذف کرد. نمونه ها بر روی یک پایه که روی یک جک متحرک قرار دارد نصب می شوند و این باعث می شود که موقعیت
نمونه و لامپ بدون تغییر باشد. فاصله نمونه تا لامپ به وسیله دیود نوری کنترل می شود به صورتی که شدت² SIM-1000 و دستگاه جریان شدت² MW/cm² مین گردد[۲۳] از شبیه ساز شریف سولارمدل SIM-1000 و دستگاه جریان –ولتاژ 26 V-۱ شکل ۳-۷ (الف) و (ب) در این پایان نامه استفاده شده است.



شکل ۳-۷ (الف) دستگاه شبیه ساز نور خورشید و (ب) دستگاه اندازه گیری *۷-۱* سلول خورشیدی در دانشگاه صنعتی شاهرود

۹-۳ لایه نشانی کند و پاش

دستگاه کند و پاش رومیزی مدل DSR1 با ابعاد کوچک به روش کند و پاش اقدام به لایه نشانی با استفاده از هدف هایی از جنس فلزات نجیب مانند طلا، پلاتین و پالادیوم نموده و عمدتا به عنوان پوشش دهنده جهت ایجاد اتصالات اهمی روی نمونه مورد استفاده قرار گرفت. با کنترل اتوماتیک یا دستی فرایند خلأ سازی و لایه نشانی می توان لایه هایی با دقت ضخامت ۱ نانومستر تولید کرد. سیستم لایه نشانی در خلاء مدل DSR1 برای ایجاد لایه های نانومتری ، ایجاد اتصالات الکتریکی بسیار ظریف در حوزه نانو تکنولوژی و میکرو الکترونیک بسیار قابل استفاده می باشد. [۲۴]



شکل (۸–۳) دستگاه کند و پاش رومیزی موجود در دانشگاه صنعتی شاهرود

۳-۱۰ دستگاه لایه نشانی چرخشی

اساس کار این دستگاه مبتنی بر نیروی گریز از مرکز است. در این روش زیرلایه بر روی صفحه دواری که قابل چرخیدن است قرار می گیرد که قبل از آن زیرلایه به وسیله اعمال یک خلأ ناچیز بر روی نگه دارنده محکم شده است. سپس مقدار معینی از محلول حاوی ماده مورد نظر در مرکز زیرلایه چکانده می شود. سپس با وارد کردن پارامترهای مورد نیاز لایه نشانی از قبیل زمان، سرعت و شتاب، صفحه شروع به چرخش می کند. در اثر چرخش زیرلایه، یک لایه بسیار نازک از ماده مورد نظر در روی سطح آن پهن می شود و پس از خشک شدن زیرلایه، ماده بر روی زیرلایه، لایه نشانی می شود. برانی می شود. براساس



شکل (۳–۹)دستگاه لایه نشانی چرخشی موجود در دانشگاه صنعتی شاهرود

۳-۱۱ روش های لایه نشانی پروسکایت

روش لایه نشانی پروسکایت یک عامل کلیدی برای به دست آوردن قابلیت بالا است زیرا پوشش سطحی ، بلورینگی، ضخامت وکیفیت لایه مخصوصا ریخت شناسی وخواص جابجایی پروسکایت را تعیین می کند. روش های مختلفی برای لایه نشانی پروسکایت استفاده می شود که رایج ترین آنها شامل لایه نشانی یک مرحله ای و دو مرحله ای چرخشی – چرخشی ، چرخشی – غوطه وری، چرخشی – تبخیری، تبخیری – تبخیری می باشند.

۳-۱۱-۱ روش لایه نشانی دومرحله ای:

الف-روش لایه نشانی دو مرحله ای چرخشی برپایه محلول : در این روش که طرحواره آن در شکل (۳-۱۰) بطور جداگانه قابل مشاهده است، هر دو پیش ماده به به صورت محلول بر روی زیرلایه، به روش چرخشی لایه نشانی می شود. در این روش، محلول PbI₂ در DMF بر روی زیرلایه با روش چرخشی، لایه نشانی می شود و سپس محلول ایزوپانولی MAI با همان روش بر روی آن لایه نشانی می شود. در نهایت با حرارت دهی پروسکایت تشکیل خواهد شد .

ب-روش دومرحله ای غوطه وری: در این روش، PbX₂ (X=I,Cl) در حلال DMSO یا DMF حل می شود سپس با روش لایه نشانی چرخشی، بر روی زیرلایه، لایه نشانی می شود. سپس زیر لایه در محلول ایزوپروپانولی MAI غوطه ور می شود تا لایه جاذب پروسکایتی تشکیل شود. در نهایت با حرارت دهی پروسکایت، لایه نشانی تکمیل می شود. بر خلاف روش قبل از نقاط قوت این روش این است که با توجه زمان غوطه وری، غلظت محلول MAX و دمای فرایند رشد، می توان اندازه بلورها و کیفیت سطح لایه جاذب را کنترل کرد

۳-۱۱-۲ روش لایه نشانی تک مرحله ای

لایه نشانی لایه ی جاذب پروسکایتی به روش تک مرحله ای به این صورت انجام می گیرد که محلول پیش ماده های (شامل PbX₂ و MAX) با نسبت مولاریته یکسان به روش لایه نشانی چرخشی بر روی زیرلایه، لایه نشانی می شود. و در نهایت پس از حرارت دهی لایه ی جاذب MAPbX₃ تشکیل می شود. در این روش غلظت محلول، سرعت چرخش و دمای بازپخت پس از لایه نشانی بر عملکرد نهایی سلول خورشیدی تاثیر می گذارد.

۳-۱۱-۳ روش تبخیری

الف-روش دومرحله ای چرخشی-تبخیری: در این روش ، ابتدا محلول PbX_2 در DMF به شکل چرخشی، بر روی زیرلایه، لایه نشانی می شود، سپس در دمای $^{\circ}$ ۱۰۰ به مدت ۱۰دقیقه خشک می شود. سپس این لایه آماده شده در محیط N_2 در معرض بخار MAX قرار می گیرد.

ب-روش دومرحله ای تبخیری ترتیبی: برخلاف روش تبخیری تک مرحله ای که هر دو منبع بطور همزمان تبخیر میشود. در این روش، ابتدا PbX₂ به روش تبخیری لایه نشانی و سپس در مرحله بعد *MAX* نیز به روش تبخیری به روش تبخیری و برهم کنش دو پیش ماده لایه ی پروسکایت ، تشکیل می شود. اندازه بلورها در روش دومرحله ای تبخیری در مقایسه با روش تک مرحله ای، بزرگتر است که در انتقال حامل های بار موثرتر عمل می کند. همچنین این روش کنترل بهتری بر مورفولوژی سطح به همراه دارد .

۳-۱۲ روش ساخت سلول پروسکایت

برای آمادهسازی زیرلایه ابتدا لازم است، برای جلوگیری از اتصال کوتاه، سطحی برابر با یک سوم زیرلایه پاک شود تا در این قسمت لایه ی FTO از روی شیشه پاک شود. برای این کار، از پودر زینک و محلول HClدو مولار استفاده میشود. بدین صورت که ابتدا پودر زینک به میزان کم روی قسمت مورد نظر ریخته میشود و سپس یک قطره (بسته به میزان سطح مورد نظر) از اسید چکانده میشود. بعد از انجام واکنش و از بین رفتن FTO ، سلول با آب دیونیزه شستشو داده میشود. به منظور جلوگیری از پخش اسید و پودر زینک و خوردگی سایر قسمتهای FTO ، میتوان از چسب استفاده کرد. بعد از عملیات اچ کردن، نوبت به شستشوی زیرلایه یا FTO ها میرسد. از آنجا که این سلولها به شدت به آلودگی حساس هستند، این مرحله بسیار مهم است. FTOها را در آب و صابون شستشو داده و به مدت ۱۰ دقیقه در حمام التراسونیک قرار داده میشوند. سپس همین کار به ترتیب در محلولهای استون، اتانول و ایزوپروپانول انجام میشود. البته در بین هر مرحله میتوان زیرلایهها را در آب داغ دیونیزه شستشو داد. برای شستشوی نیز بهترین گزینه استفاده از دستگه UV-Ozone



شکل (۳–۱۰)روش های لایه نشانی (الف) تک مرحله ای و دومرحله ای (ب) غوطه وری (ج) و(د) تبخیری همزمان و دومرحله ای(۴)

لایه فشرده اکسید تیتانیوم، لایهای پیوسته و با حداکثر ضخامت ۹۰ نانومتر است که بر روی تمام شیشه به جز قسمتی که از لایهی FTO که به عنوان الکترود استفاده می شود، پوشش داده می شود. دو محلول حاوی اتانول، TTIP HCl با هم ترکیب شده، از فیلتر سلولوزی عبور داده می شوند و بر روی شیشه با استفاده از دستگاه لایه نشانی دورانی، لایه نشانی می شوند. بعد از این اعمال، این لایه معمولا در ۱۲۵ درجه سانتی گراد خشک شده و در ۵۰۰ درجه به مدت ۳۰ دقیق آنیل می شود. اتانول در همه مواردی که در سلول استفاده می شود باید بدون آب با خلوص بالا باشد.

برای تهیه سوسپانسیون لایه متخلخل TiO₂ از خمیر دی کسید تیتانیوم و اتانول با نسبتهای مختلف استفاده می شود. در مقالهها، این دو ماده با نسبتهای مختلف ۱ به ۶، ۱ به ۱، ۸ به ۱۳ و نسبتهای دیگر مخلوط می شوند. ماده بدست آمده پس از مخلوط شدن (با استفاده از همزن مغناطیسی) برای

مدت ۲ دقیقه در حمام التراسونیک قرار داده می شود. سپس می توان با استفاده از دستگاه لایه نشانی دورانی آن را اعمال کرد. بعد از لایه نشانی، مانند لایه فشرده TiO₂ ، در ۱۲۵ درجه خشک و در ۵۰۰ درجه به مدت ۳۰ دقیقه آنیل می شود.

در این قسمت از روش دو مرحلهای لایه نشانی Perovskite (شکل ۳–۱۱) که استفاده از آن بسیار رایج است، استفاده می شود. برای تهیه محلول Pbl₂ ابتدا مقدار مشخصی از Pbl₂ و DMF (به عنوان حلال) برای تهیه محلول با مولاریته مشخص با هم ترکیب شده و برای مدت ۱ ساعت در دمای ۸۰ تا ۱۰۰ درجه بر روی همزن مغناطیسی قرار داده می شود تا محلولی کاملا شفاف حاصل شود. بهتر است از مرحله تولید Pbl2 تمامی مواد و فرآیندها (به منظور جلوگیری از ورود رطوبت و اکسیژن و درنتیجه کاهش پایداری سلولها) در گلاوباکس انجام شود. محلول مورد نظر با استفاده از دستگاه لایه نشانی چرخشی بر روی زیرلایه، لایه نشانی شده و در دمای ۸۰ تا ۱۲۰ درجه آنیل میشود. سپس برای تهیه محلول متيل آمونيوم يديد (MAI) ، بسته به تعداد نمونهها، مقدار مورد نياز از يودر MAI (سفيد رنگ) برداشته و در حالي كه بر روى همزن مغناطيسي است، حلال ايزوپروپانول بدون آب، قطره قطره تا رسیدن به غلظت مورد نظر، به آن اضافه می شود. در ادامه برای لایه نشانی این محلول، از روش غوطهوری استفاده می شود. در این روش، ابتدا زیر لایه در محلول MAI تهیه شده غوطه ور شده (تا زمانی که لایهی قهوهای رنگ روی آن تشکیل شود) و سپس در محلول ایزوپروانول برای چند ثانیه غوطهور می شود. بعد از آن نمونه سریع بر روی اسپین کوت قرار داده شده و برای حدود ۲۰ ثانیه با دور و سرعت مشخص خشک می شود. سپس، برای آنیل نهایی، در دمای ۸۰ تا ۱۲۰ درجه قرار داده می شود.



شكل (۳-۱۱) لايه نشاني دومرحلهاي لايه پروسكايت.

در ساخت لایه انتقال دهنده حفره، سلول های ساخته شده با ماده Piro-OMETAD برای لایه انتقال دهنده حفره، معمولا بالاترین بازده را داشتهاند. البته این ماده بسیار گران است و پایداری سلول را تحت تاثیر قرار می دهد. این لایه با استفاده از اسپایرو محلول در کلرو بنزن، تهیه می شود. برای تهیه ی محلول مورد نظر دو محلول لازم است. برای ساخت محلول ۱، پودر Spiro-OMETAD و حلال های کلروبنزن و Pipio-OMETAD و Spiro-OMETAD و حلال ۱۰ پودر Spiro-OMETAD و حلال های کلروبنزن و met. برای ساخت محلول ۱، پودر Bis(trifluoromethane) و حلال های کلروبنزن به پودر Bis(trifluoromethane) sulfonamide lithium salt می شود. بعد از ساخت هر دو محلول، مقدار مشخصی از محلول دوم به محلول اول اضافه می شود و سپس محلول نهایی به مدت ۳۰ دقیقه در دمای 2°۶ در حال هم زدن بر روی استیرر قرار داده می شود. بعد از این مرحله، محلول توسط فیلتر با اندازهی ۲۵/۵ در حال هم زدن بر روی استیرر قرار داده می شود. بعد از این محلول بر روی نمونه (FTO/Block TiO2/Mesoporous TiO2/ Perovskite) ریخته و لایه نشانی توسط دستگاه لایه نشانی چرخشی انجام می شود. لایه طلا به دلیل تابع کار و سطح انرژی مناسب در کنار لایه اسپایرو با سطح انرژی گزینه بسیار مناسبی برای لایهنانی الکترود در این نوع از مناسب در کنار لایه اسپایرو با سطح انرژی گزینه بسیار مناسبی برای لایه نشانی الکترود در این نوع از می شود[25].

۳-۱۳ مشخصه های سلول خورشیدی

مهمترین پارامترهایی که در توصیف عملکردی سلول خورشیدی استفاده می شوند شامل ولتاژ مدار باز، جریان اتصال کوتاه، بیشترین توان تولیدی سلول و فاکتور پرشدگی می باشند. بهینه سازی قابلیت فوتو ولتائی نیازمند بیشینه کردن این سه عامل است.

حداکثر جریان حامل های نوری تولید شده در سلول خورشیدی زمانی که دو پایانه سلول به هم متصل باشند چگالی جریان *J(v)* تولید شده، در ولتاژ ، توسط سلول به دست می آید :

که J_{dark} چگالی جریان تاریک می باشد. مقدار ولتاژ اندازه گیری شده زمانی که دو سر سلول به هم وصل نیست و جریانی از آن عبور نمی کند ولتاژ V_{oc} می باشد. این مقدار ماکزیم ولتاژی است که سلول تولید می کند. فاکتور پر شدگی نسبت حداکثر توان تولیدی توسط سلول به حاصلضرب J_{sc} .

$$\eta = \frac{Pmax}{Pin} = \frac{IscVocFF}{Pin}$$
(Y-T)



شکل (۳-۱۲) نمودار جریان-ولتاژ ومشخصه های سلول خورشیدی پروسکایت

۳-۱۴ مقاومت های مزاحم

مقاومت تماس ها و اتلاف جریان در اطراف لبه های قطعه، توان تولیدی را با کاهش چگالی جریان خالص کم می کند. یک مدار معادل برای شبیه سازی این قبیل سلول های خورشیدی در شکل نشان داده شده است. بطوریکه دو مقاومت مزاحم با مقاومت سری (*R*_s) و مقاومت موازی (*R*_{sh}) نامگذاری شده اند.



شکل ۳–۱۳ مدار معادل سلول پروسکایت شامل مقاومت های سری و موازی(۷)

مقاومت های سری از مقاومت مواد سلول در مقابل شارش جریان و از مقاومت تماس ها ناشی می شود و در چگالی جریان های بالا قابل توجه اند. مقاومت های موازی از جریان های نشتی در اطراف لبه ها ، در میان سلول و بین تماس های با قطبیت مختلف، ناشی می شوند. اثر مقاومت قطعه در نمودار جریان-ولتاژ همانند کاهنده چگالی توان ماکزیمم دیده می شود. همانطور که در شکل زیر دیده می شود. هر چه R_s کمتر و R_s بیشتر باشد، ($R_s=0,R_{sh}$) مطلوب تر است[۷].



شکل ۳–۱۴ اثر مقاومت های سری و موازی در نمودار جریان- ولتاژ(۷)

۳-۱۵ جمع بندی

در این قسمت از پایان نامه انواع دستگاه های مورد استفاده در سنتز و مشخصه یابی TiO₂ و ساخت سلول خورشیدی پروسکایت و روش های سنتز آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. روش های لایه نشانی پروسکایت به عنوان مهم ترین لایه سلول توضیح داده شد. مشخصه یابی نوری نمونه ها، گاف نواری، الگوی پراش پرتو X ، FESEM و مشخصه های مهم سلول خورشیدی پروسکایت و عوامل تاثیرگذار بر بازده سلول نیز بررسی شدند.

فصل جہارم

سنترو آلايش TiO₂ وساخت سلول

خور شدی بروسکایتی

۴–۱ مقدمه

در این فصل ابتدا روش های سنتز TiO₂ خالص و آلایش یافته به دو روش هیدروترمال و هیدروترمال بهبود یافته و به دست آوردن فازهای روتایل و آناتاز توضیح داده می شود. سپس استفاده از روش سل ژل برای بدست آوردن نانو ورقه های مسطح فشرده و استفاده از نانوذرات برای لایه متخلخل سلول خورشیدی توضیح داده می شود و نتایج مشخصه یابی ها بررسی می شود. در ادامه روش و نتیجه ساخت سلول خورشیدی پروسکایت با استفاده از نانوذرات سنتز شده توضیح داده می شود.

۲–۴ سنتز TiO₂

۴-۲-۴ مواد مورد نیاز و روش های انجام آزمایش

دراین پایان نامه از تیتانیوم ایزوپروپوکساید (%98(TiC₁₂H₂₈O4)),معروف به TTIP ، آب دو بار تقطیر ، هیدروکلریک اسید ((%HCI,37، اتانول مطلق(C2H5OH)، نیترات آهن(Fe(NO₃)3.9H₂O)، نیترات آلومینیوم (Al(NO₃)3.9H₂O) همگی ازشرکت مرک برای سنتز نمونه ها استفاده شد.

۲-۲-۴ بدست آوردن دی اکسیدتیتانیوم با فاز روتایل

اولین کار انجام شده سنتز نانو ذرات روتایل TiO2 بوده که باروش آبی – گرمایی انجام شد و روش انجام در ادامه آورده شده است(۲۶). برای این منظور مقدار ۲۰ml اسیدکلریدریک و*ml* ۲۰ آب دو بار تقطیر را با هم مخلوط کرده و با استفاده از همزن مغناطیسی آنها خوب حل شدند. بعد ازگذشت حدود نیم ساعت، *ml* تیتانیوم ایزوپروپوکساید به آن اضافه شد. دوباره حدود نیم ساعت صبر شد تا واکنش انجام شود، سپس محلول را درون ظرف تفلونی ریخته شد و درون رآکتور گذاشته شد و راکتور را درون آون گذاشته و کوره در دمای ۱۸۰ درجه به مدت ۵ ساعت تنظیم شد و یک ساعت هم برای رسیدن به این دما قرار داده شد[۲]. پس از اینکه دمای راکتور به دمای اتاق رسید در ظرف به آرامی باز شد. پودر سفید رنگ دی اکسیدتیتانیوم به ته ظرف چسبیده است. مایع اضافی دور ریخته شد و پودر باقیمانده با آب دو بار تقطیر شستشو داده شد. سپس پودر را از ته ظرف جدا کرده و آنرا در دمای C ° ۱۱۰ قرار داده تا خشک شود. در این قسمت مشاهده شد که حلالیت پودر درآب خوب است. ویژگی های پودرهای بدست آمده توسط آنالیزهای نوری و رامان و الگوی پراش پرتو X مورد مطالعه قرار گرفت.



شکل ۴-۱ نمودارهای جذب و تاوک دی اکسید تیتانیوم روتایل

۲-۲-۴ آلایش TiOz با سدیم

برای آلایش با سدیم مقدار ۱٪ مولی کلرید سدیم را در محلول داخل تفلون ریخته و مرحله بالا تکرار شد. برای آلایش آهن و آلومینیوم به روش هیدروترمال مشابه بالا مراحل کار تکرار شد ولی پس از خشک کردن پودر ها مشاهده شد که یک لکه رنگی در وسط ظرف حاوی پودر ایجاد شده که می شود نتیجه گرفت که آلایش به خوبی صورت نگرفته و از ماده اصلی جدا شده است. بنابراین از روش های دیگر با عنوان هیدروترمال بهبود یافته برای آلایش این دو عنصر استفاده شد.

UV-VIS آناليز ۳-۲-۴

از نمودار جذب شکل ۴–۱(الف) مشاهده می شود که میزان جذب دی اکسید تیتانیوم در ناحیه مرئی کم می باشد و بیشتر در ناحیه فرابنفش قرار دارد. لبه جذب در ابتدای طیف نور مرئی قرار دارد. مقدار گاف نواری با استفاده از نمودار تاوک با احتساب گاف نواری مستقیم مقدار *eV* محاسبه شد که نشان می دهد با این میزان آلایش، گاف نواری افزایش یافته است[29].



شکل ۴-۲ نمودارهای جذب و تاوک دی اکسید تیتانیوم آلایش یافته با سدیم

از مقایسه دو نمودار ۴–۱(الف) و ۴–۲(الف) جذب مشاهده شد که نویزهای نمودار جذب کاهش پیداکرده اند و لبه جذب به سمت ناحیه فرابنفش جابجا شده است و از مقایسه نمودار های تاوک دو نمونه آلایش یافته و بدون آلایش، مشخص شد که گاف نواری نیز کمی افزایش پیدا کرده است که دلیلی بر وجود آلایش در نمونه است. چسبندگی ذرات سنتز شده زیاد می باشد و گلوله مانند هستند و زود در محلول ته نشین می شدند و حتی با چرخش توسط همزن مغناطیسی و آلتراسونیک براحتی از هم جدا نمی شدند. با توجه به اینکه از نانو پودر به دست آمده برای ساخت یکی از لایه های سلول پروسکایت استفاده می شود و در این سلول ضخامت لایه انتقال الکترون زیاد نیست و صاف و هموار بودن لایه مهم است، این ذرات برای استفاده در لایه های نانومتری مناسب نیستند و باید از روشی استفاده شود که چسبندگی ذرات در آن کم باشد و ذرات یک دست باشند.

۲-۴-۴ آنالیز XRD



الگوی پراش پرتو X دی اکسید تیتانیوم با فاز روتایل در شکل (۴–۳) نشان داده شده است.

شكل ۴-۳ طيف XRD دى اكسيد تيتانيوم روتايل

با استفاده از کارت ۱۲۷۶–۲۱ قله های (۱۱۰) ۲۷/۴۲ = θ و (۱۰۱) ۳۶/۰۴ و (۱۱۱) ۴۱/۴ و (۲۱۱) ۴۴/۰۸ و (۲۱۱) ۵۴/۲ و (۲۲۰) ۵۶/۶ و (۲۰۰) ۶۲/۷۶ و (۳۱۰) ۶۹ و (۱۱۲) ۶۹/۷۶ و (۲۰۲) ۷۶/۶ وجود فاز روتایل با ساختار چهار گوشی را مشخص می کنند و فاز دیگری از دی اکسید تیتانیوم در نمونه آشکار نشده است(۳۰). اندازه بلورک ها با استفاده از معادله شرر محاسبه شد[11].

$$D = 0.9\lambda/\beta \ COS\theta \tag{1-f}$$

که در آن D اندازه میانگین بلورک ها و $\lambda=0.154nm$ طول موج XRD و β تمام پهنا در نصف بیشینه بر حسب رادیان و حاصل دستگاه است و θ مربوط به زاویه قله براگ است. با استفاده از اطلاعات آنالیز، اندازه نانوبلورک ها nm

استفاده از رابطه ویلیامسون هال مقدار دقیق تری از اندازه دانه و سایر کمیت ها می دهد:

$$\beta \cos\theta = \frac{0.9\lambda}{d} + 4A\epsilon Sin\theta \tag{(7-f)}$$

طبق جدول (۴–۱) وشکل (۴–۴) و با استفاده از رابطه ویلیامسون – هال برای ۶ قله اول، اندازه تقریبی ذرات مقدار مقدار ۲۲/۷ nm ۲۲/۷ محاسبه شد که مقدار آن اختلاف ناچیزی با رابطه شرر دارد و کرنش شبکه برابر ۰/۰۰۲۱ بدست آمد.

اندیس میلر	20	b	β	sinθ	Bcosθ
11.	۲۷/۳۶	•/٢••	•/•• • • • • • • • • • • • • • • • • •	•/٣٣	•/••¥٩
۱ • ۱	۳۶/۰۲	•/٢•١	•/•• \ \ 79	۰/٣٠	•/••¥A
۲۰۰	٣٩/١٠	•/١۵١	•/••۶۲۳	• /٣٣	•/••&٨
)))	41/22	•/188	•/••۶٩٣	۰/۳۵	•/••۶۴
۲۱.	۴۳/۹۵	•/711	•/•• \ ۶\	• /٣٧	•/•• A •
711	54/21	•/747	•/••٩٩۵	۰/۴۵	•/•• \ \

جدول ۴-۱ مقادیر زاویه ی قله پراش در فاز روتایل، تمام پهنا در نیمه بیشینه برای شش قله اول



شکل ۴-۴ محاسبه اندازه دانه و کرنش شبکه دی اکسید تیتانیوم روتایل با استفاده از شش قله اول

۴-۲-۵ آنالیز رامان

قله های مشخصه فاز روتایل ۸۲۶،۲۳۶٬۲۳۶٬۲۴۷٬۲۳۶٬۱۴۳ (^{۲-}cm) ۸۲۶ هستند که تقریبا با قله های بدست آمده از نمونه های سنتز شده ۱۳۶، ۲۳۷، ۴۳۵ ، (¹⁻۶۰۲) ۶۰۴ مطابقت می کنند و بیانگر تشکیل فاز روتایل هستند و فقط اندکی جابجایی دارند که این جابجایی احتمالا مربوط به تغییر در شبکه بلوری به خاطر وجود مقادیر کم فازهای ناخالصی می باشد.



شکل ۴-۵ طیف رامان دی اکسید تیتانیوم روتایل

با توجه به اینکه سنتز به روش آبی – گرمایی بالا باعث بوجود آمدن فاز روتایل دی اکسید تیتانیوم شده است و فاز آناتاز به دلیل طول عمر بیشتر اکسیتون ها دارای فعالیت بیشتری نسبت به روتایل می باشد و هدف از این سنتز نیز استفاده از ماده بدست آمده در سلول خورشیدی می باشد، بنابراین روش سنتز عوض شده و از روش آبی – گرمایی بهبود یافته استفاده می شود. هر چند استفاده از نانومیله های فاز روتایل در کارهای قبلی بازده مناسبی از خود نشان داده است (۳۱). قله های ۱۴۳، ۴۴۷، ۶۱۲، روتایل در کارهای قبلی بازده مناسبی از خود نشان داده است داده می شوند. می شوند.

۳-۴ بدست آوردن دی اکسیدتیتانیوم با فاز آناتاز

در دمای $(2^{\circ} 0^{\circ})$)اتاق مقدار M مایع TTIP داخل بشر حاوی M ۵۰ اتانول ریخته شد و توسط همزن مغناطیسی حل شدند. در ظرفی دیگر مقدار M ۲۵ اتانول با همان حجم آب دو بار تقطیر ، مخلوط شده و به آرامی درون ظرف اول اضافه شد. پس ازگذشت مدت ۳۰ دقیقه سوسپانسیون سفیدرنگی تشکیل می شود. سپس محلول را از فیلتر عبور داده و پودر به دست آمده با اتانول شستشو داده شد. ماده بدست آمده با اتانول شستشو معیدرنگی تشکیل می شود. سپس محلول را از فیلتر عبور داده و پودر به دست آمده با اتانول شستشو اخاه شد. ماده بدست آمده رادردمای ۱۰۰درجه خشک کرده و آسیاب می شود[۱۰]. پودر حاصل دی اکسیدتیتانیوم آمورف نامگذاری می شود. آنالیز XRD فاز آناتاز نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بدست آمده را تاییو می بدست آمده را تایید کرد، البته درصد کمی فاز بروکیت همراه داشتند. در ادامه مقدار g /۰۰ از دی اکسیدتیتانیوم بدست آمده را در اm ۲۱/۵ آب دو بار تقطیر حل و در داخل تفلون ریخته شد. تفلون را داخل راکتور گذاشته به کوره انتقال داده شد و دمای کوره را روی 2° ۰۰ به مدت ۲۲ساعت تنظیم شد. پس از سرد شدن کوره و رسیدن به دمای اتاق، محصول به دست آمده را از فیلتر عبور داده و در را ماع مدا را داخل دی اکسید تیتانیوم بدست آمده را در اm ۲۰/۵ آب دو بار تقطیر حل و در داخل تفلون ریخته شد. تفلون را داخل راکتور گذاشته به کوره انتقال داده شد و دمای کوره را روی 2° ۰۰۰۰ به مدت ۲۲ساعت تنظیم شد. پس از سرد شدن کوره و رسیدن به دمای اتاق، محصول به دست آمده را از فیلتر عبور داده و در را داخل داده شد . آنالیز M ما ۲۰۰ زی دی اکسید تیتانیوم بدست آمده را تایید کرد ،

برای آلایش با آهن و آلومینیوم مراحل قبلی انجام شد. تنها تفاوت این است که مقدار ۱٪ مولی نیترات آهن [۶] و ۱٪ مولی نیترات آلومینیوم [۸] را جداگانه قبل از انجام مرحله گرمایی- آبی در تفلون ریخته و مراحل بالا عینا تکرار شد. در نهایت از سه نوع پودرهای بدست آمده آنالیز خواص نوری و طیف رامان و پراش پرتو X و ریخت شناسی و آنالیز عنصری گرفته و با هم مقایسه شدند[11].

۴–۳–۱ مطالعه خواص نوری نانوذرات

بااستفاده از UV-Vis ، و نمودار طیف جذبی مشاهده شد که قله جذب تمام نمونه ها در ناحیه فرابنفش است که خود دلیل گاف نواری پهن نمونه های سنتز شده است وجذب ناحیه مرئی ناچیز است و ناخالصی های آهن و آلومینیوم لبه جذب را به ناحیه قرمز جابجا کرده اند و این موضوع تایید می دهد

که ناخالصی درساختار دی اکسید تیتانیوم نفوذکرده و تهی جاها کاهش پیدا می کند از طرفی میزان جذب نور مرئی نیز افزایش پیدا کرده است و باعث افزایش بازده سلول های خورشیدی می شود. طبق رابطه تاوک، انرژی گاف نواری نمونه ها تعیین شد (شکل ۴–۱) و گاف نواری مستقیم با استفاده از نمودار تاوک حدود V/ ۸۵ و ۷ مرای آلایش با آهن و ۷ ۸ ۸ ۲ رای آلایش با آلومینیوم بدست آمد که با وارد کردن ناخالصی گاف نواری کاهش پیدا کرده است که با رای آلایش با آلومینیوم برای در می شود. طبق مرای آلایش با آهن و ۷ م ۳ رای آلایش با آلومینیوم بدست آمد که با وارد کردن ناخالصی گاف نواری کاهش پیدا کرده است که با کارهای قبلی در توافق است[5]. این موضوع نیز باعث افزایش انتقال الکترون شده و در نتیجه مادی و Voc را افزایش می دهد و مطابق رابطه بازده سلول خورشیدی باعث افزایش ایش و Fr وری نور خورشید می شود.



شکل(۴-۶) طیف جذب و عبور نور نمونه های خالص TiO₂ و آلایش یافته با آهن و آلومینیوم

نتایج بیانگر کاهش گاف انرژی با وارد شدن آلایش است وآلایش آلومینیوم کاهش گاف بیشتری دارد. بنابراین طول موج لبه جذب افزایش یافته و وارد محدوده جذب نورمرئی (جابجایی قرمز) می شود. در ضمن میزان جذب نیز در ناحیه های مختلف افزایش یافته است. این می تواند به تشکیل سطوح جدید انرژی آلایش آهن و آلومینیوم در بین گاف نواری TiO₂ نسبت داده شود. شعاع یون های^{۴+} Fe⁺³,Ti و Al^{r+} می باشد. شعاع یونی ناخالصی آهن به شعاع یونی ناخالصی آهن به شعاع یونی تيتانيوم نزديك است و شعاع يوني آلومينيوم مشابه تيتانيوم مي باشد و هنگام قرارگرفتن آنها بجاي تیتانیوم نظم شبکه بلوری به هم نمی خورد. تیتانیوم چهار ظرفیتی و آلومینیوم وآهن سه ظرفیتی p و n هستند و آلایش از نوع P می شود که چون مقدار آلایش کم است ممکن است تاثیری بر نوع nبودن ذرات سنتز شده نداشته باشند. نوع n و p بودن TiO₂ و مقدار حامل ها با آزمایش اثر هال مشخص می شود. آلایش دهنده ها، درتهی جاهای اکسیژن وارد می شوند[۲] و جای خالی آنها را اشغال می کنند. در اثر آلایش، الکترون های اضافی در ساختار وارد نمی شوند بلکه تله های گیراندازی الکترون، کاهش می یابد و در نتیجه ترابری الکترون بهتر صورت می گیرد و جریان الکتریکی افزایش می یابد. بنابراین استفاده ازدی اکسیدتیتانیوم آلایش یافته باعث بالا رفتن بازدهی در سلول های خورشیدی می شود. اینکه کدامیک از مواد برای استفاده در آلایش TiO₂ سلول خورشیدی مناسب تراست، با تجربه بدست می آید و با توجه به کارهای قبلی[14] و[5] که بیشترین بازده سلول خورشیدی پروسکایت آلایش یافته با آهن و آلومینیوم را با حدود یک درصد مولی آلایش بدست آورده اند، در این پژوهش آنها با هم مقایسه می شوند. با توجه به اینکه برای آنالیزهای مختلف سلول های زیادی نیاز می باشد، آلایش با درصدهای مختلف و برای عناصر مختلف کار را پیچیده می کند و بنابراین از این امر اجتناب شد.



شکل(۴-۲) نمودار تاوک برای نمونه های خالص TiO₂ و آلایش یافته با آهن و آلومینیوم

۴-۳-۴ طیف نگاری رامان

قله های موجود در ۱۹۴ و ۱۹۷ و ۳۹۹ و ۵۱۶ و (¹-cm) ۶۳۹ مربوط به فازآناتاز هستند. قله های موجود در (¹ - Cm) ۳۶۹، ۳۲۰، ۲۴۶ مربوط به A1g,B1g,B2g فازهای بروکیت هستند که شدت آنها ضعیف است و نشانگر وجود مقدار کم فاز بروکیت در ترکیب است. در نمونه های آلایش یافته قله ها کمی جابجا شده اند که دلیلی بر حضور ناخالصی در ساختار می باشد. قله های اصلی رامان در ۱۴۴, ۳۹۴,


شکل ۴-۸ طیف رامان نمونه های خالص TiO₂ و آلایش یافته با آهن و آلومینیوم

۴-۳-۳ آنالیز ساختاری

آنالیز XRD اندازه و فاز ذرات بلوری را مشخص می کند. شکل(۴–۹) الگویXRD نانوذرات TiO2 ذاتی و آلایش یافته با آهن و آلومینیوم را نشان می دهد. قله های مشاهده شده در راستای صفحات (۱۰۱) ، (۲۰۰) و (۲۰۰) به ترتیب در زوایای ۲۵،۳۸/۵ و [°]۴۸ مشخصه تشکیل فاز آناتاز با ساختار بلوری می باشند و قله در راستای صفحه (۱۲۱) در[°]۲۰/۸ مشخصه فاز بروکیت می باشد. شدت قله های صفحه های بلوری فاز آناتاز (۱۰۱) و (۲۰۰) و (۲۰۰) از بقیه قله ها بیشتراست که نشان دهنده تشکیل مقدار بیشتر فاز آناتاز می باشد. چون مقدار آلایش کم است بلورینگی و اندازه نانو ذرات تغییرات کمی داشته اند، همچنین هیچ فاز بلوری شامل اتم های آهن و آلومینیوم در طیف دیده نمی شود. شدت قله (۱۰۱) با افزودن ناخالصی کاهش پیدا کرده که بیانگر این است که احتمالا ناخالصی مانع رشد بلوری شده است و قله (۱۲۱) كمي افزايش داشته كه نشان مي دهد فاز بروكيت مقدار كمي افزايش يافته است. الگوي یراش پرتو X پودر بدست آمده از مرحله اول سنتز که هنوز مرحله آبی – گرمایی روی آن اعمال نشده است نیز دارای ساختار بلوری می باشد و با اعمال این مرحله فقط درصد آناتاز کمی افزایش داشته و درصد بروکیت کمی کاهش داشته است که می توان نتیجه گرفت مرحله اول سنتز برای بدست آوردن نانو پودر دی اکسید تیتانیوم با فاز آناتاز کافی است و این موضوع باعث صرفه جویی در وقت و هزینه سنتز مي شود، ولي براي آلايش عناصر ناگزير از انجام مرحله دوم سنتز مي باشيم. با استفاده از رابطه شرر، میانگین اندازه گرد شده بلورک های پودر دی اکسیدتیتانیوم آمورف ۸nM و دی اکسیدتیتانیوم آناتاز ۹/۵ nm و آلایش یافته با آهن n۰ سرو آلایش یافته با آلومینیوم ۱۱ nm بدست آمده است که نشان می دهد با آلایش ، اندازه بلورک ها افزایش کمی داشته است. اندازه گیری نسبت به قله مربوط به صفحه (۱۰۱) انجام شده است که بیشترین شدت را دارد و مشخصه فاز آناتاز است شکل (۴– ۹). پارامتر های شبکه نیز موفقیت آمیز بودن رشد دی اکسید تیتانیوم در فازهای مربوطه را تایید می کند جدول (۲-۴).

جدول ۴-۲ پارامتر های شبکه ای نانوپودر های سنتز شده TiO2

فاز	а	b	С
آناتاز	3/1/401	3/1/201	9/5189
بروكيت	۵/۴۵۵۸	٩/١٨١٩	6/1429
روتايل	4/2922	4/2922	2/9092

در جدول (۴–۳) مقادیر فازهای مختلف آناتاز و بروکیت در سنتز های متفاوت نشان داده شده است که نشان می دهد در مرحله اول سنتز درصد بالایی از پودر، دارای فاز آناتاز می باشد و با انجام مرحله دوم سنتز درصد فاز آناتاز کمی افزایش افزایش یافته و با وارد کردن ناخالصی کاهش پیدا کرده است. انجام کار سرد و تغییر شکل پلاستیکی بر روی فلزات، منجر به تغییر محسوس در پهنای خطوط پراش پرتو ایکس می شود. بخشی از تغییر شکل قله، مربوط به ریز شدن دانه ها و بخشی دیگر مربوط به افزایش کرنش شبکه می باشد.

جدول ۴-۳ درصد فاز های مختلف بلورهای سنتز شده

مادہ	آناتاز٪	بروكيت٪
Tio2 آمورف	84/34	٧/٩٩
Tio ₂	۸۹/۱ <i>۶</i>	4/40
Fe-Tio ₂	٨٧/٧٠	10/2+
Al-Tio ₂	۸۸/۴۵	٨/٧٠



شکل ۴-۹ طیف XRD نمونه های TiO₂ (a) آمورف و (b) خالص و (c))آلایش یافته با آهن و (d)آلومینیوم

با استفاده از رابطه ی ویلیامسون- هال و الگوی پراش پرتوی X، اگر داده های مربوط به $\beta cos \theta$ بر حسب $sin \theta$ برای چندین پیک در الگوی پراش پرتو ایکس در زوایای مختلف، رسم شود بایستی بر روی یک خط راست واقع شوند که از روی شیب آن می توان کرنش و از روی عرض از مبداء می توان اندازه دانه (*d*) را تعیین کرد. محاسبات مربوط به دانه های با فاز آناتاز پودر اولیه با استفاده از داده های جدول (۴–۴) و رسم نمودار شکل (۴–۱۰) با روش ویلیامسون انجام شده است که در آن اندازه تقریبی ذرات ۷/۵۸ نانومتر وکرنش شبکه ۰۹۱۵ می

جدول ۴-۴ مقادیر زاویه ی قله پراش در فاز آناتاز پودر اولیه، تمام پهنا در نیمه ماکزیمم برای چهار قله اول

اندیس میلر	20	b	β	Sinθ	βcosθ
۱۰۱	20/61	•/400	•/•١٨٧	•/٢٢	•/•18
171	۳./۹۹	•/۵۳۸	•/•**1	•/٢٦	•/• * 1
• • ۴	۳۸/۰۷	• / ٧ • ۵	•/• ٢٨٩	•/٣٢	•/• * V
۲	47/•1	•/071	•/•٢١۴	۰/۴۰	•/•19



شکل ۴-۱۰ محاسبه اندازه دانه و کرنش شبکه دی اکسید تیتانیوم آناتاز اولیه با استفاده از چهار قله اول

برای پودر آناتاز سنتز شده به روش آبی-گرمایی با استفاده از داده های جدول (۴–۵) و رسم نمودار شکل (۴–۱۱) محاسبات به روش بالا انجام شده است که اندازه تقریبی ذرات ۹/۲۴ نانومتر وکرنش مساوی ۰/۰۰۵۱ بدست آمد که نشان می دهد پس از عملیات آبی – گرمایی اندازه بلورک ها اندکی افزایش و کرنش کاهش داشته است.

جدول ۴–۵ مقادیر زاویه ی قله پراش در فاز آناتاز، تمام پهنا در نیمه ماکزیمم برای چهار قله اول

انديس	20	b	β	sinθ	βcosθ
ميلر					
1 • 1	20/22	•/٣٨۶٣	•/•١٥٨	•/٢١	•/•184
171	٣./٧٧	•/47•1	•/• \ \ \ \	•/٢٦	•/• ١٧•
••۴	۳۷/۹۶	•/?•٧٣	•/•749	•/٣٢	•/• **?
۲	41/99	•/4797	•/•1٧٩	۰/۴۰	•/•19٣



شکل ۴–۱۱ محاسبه اندازه دانه و کرنش شبکه دی اکسید تیتانیوم آناتاز با استفاده از چهار قله اول

برای پودر آناتاز سنتز شده به روش آبی-گرمایی و آلایش یافته با آلومینیوم با استفاده از داده های جدول (۴–۵) و رسم نمودار شکل (۴–۱۱) محاسبات به روش بالا انجام شده است که اندازه ذرات ۸/۳۵ نانومتر وکرنش ۶۰۰۰/۰ بدست آمد. که نشان می دهد پس از عملیات آبی – گرمایی و آلایش با آلومینیوم اندازه بلورک ها اندکی افزایش و کرنش کاهش داشته است.

جدول ۴-۶ مقادیر زاویه ی قله پراش در فاز آناتاز، تمام پهنا در نیمه ماکزیمم برای چهار قله اول برای آلایش

آلومينيوم

βcosθ	Sint	β	b	20	اندیس میلر
•/•189	•/٢١	•/•14	•/٣۴١٣	20/21	۱۰۱
./. 190	•/٢٦	•/• 1 V	•/۴١٧۵	۳۰/۸۲	171
•/• *19	•/٣٢	•/• * *	•/209•	۳۷/۹۵	۴
•/• 179	•/4•	•/•14	•/٣۴۴۵	۴۸/۰۳	۲



شکل ۴-۱۲ نمودار محاسبه اندازه دانه و کرنش شبکه دی اکسید تیتانیوم آناتاز برای آلایش آلومینیوم

با استفاده از چهار قله اول

برای پودر آناتاز سنتز شده به روش آبی-گرمایی و آلایش داده شده با آهن با استفاده از داده های جدول (۲-۲) و رسم نمودار شکل (۴–۱۳) محاسبات به روش بالا انجام شده است که برای چهار قله اول اندازه ذرات ۷/۲۸ نانومتر وکرنش ۰/۰۰۸۵ به دست آمدکه نشان می دهد پس از عملیات آبی – گرمایی و آلایش با آهن اندازه بلورک ها و کرنش اندکی کاهش کاهش داشته است.

جدول ۴–۷ مقادیر زاویه ی قله پراش در فاز آناتاز، تمام پهنا در نیمه ماکزیمم برای پنج قله اول برای آلایش برای

اندیس میلر	20	В	β	sinθ	βcosθ
۱ • ۱	20/01	•/٣٩•	./.141	•/٢٢	•/•144
١٢١	۳۱/۰۷	•/٣٣٢	•/•189	•/٢٦	•/•١٣١
••۴	۳۸/۱۳	•/۵١٣	•/•٢١١	•/٣٢	•/•١٩٩
221	47/41	•/٢١٨	•/••٨٩	•/٣۶	•/••^
221	۴۸/۰۸	•/٣٧٩	•/•109	•/4•	•/•144

آلایش با آهن



شکل ۴-۱۳ محاسبه اندازه دانه و کرنش شبکه دی اکسید تیتانیوم آناتاز برای آلایش آهن

با استفاده از چهار قله اول

اندازه ذرات سنتزشده از این روش کمتر از ۱۰*nm* می باشد و بنابراین رفتار محدودیت کوانتومی از خود نشان می دهند و این امر بزرگ تر شدن گاف نواری ذرات سنتز شده در این مرحله را توجیه می کند. محاسبات نشان می دهد که اندازه بلورک های دی اکسید تیتانیوم آمورف بعد از اعمال سنتز آبی – گرمایی افزایش داشته که بیانگر افزایش فاز آناتاز می باشد.

نام ذره	روش سنتز	درصد	FWHM	اندازه	اندازه	فاز	گاف	درصد اتمی
		ناخالصي		ذره(nm)	ذره (nm)	بلورى	نواری(ev)	ناخالصى
				رابطه شرر	ويليامسون			
					هال			
Tio ₂	هيدروترمال	•	•/••¥	۲۰	۲۲/۷	روتايل	٣/•۶	•
Tio ₂	هيدروترمال	•	•/እ۶٨	٩/۵	٩/٢۴	آناتاز	٣/٢	•
	بهبوديافته							
TiO2	هيدروترمال بهبوديافته	•	•/٩٩۵	٨	۷/۵۸	آمورف		•
Fe-	هيدروترمال	٪۱ مولی	/ A • A	١٠	۷/۲۸	آناتاز	٣	•/77
Tio ₂	بهبوديافته							
Al-	هيدروترمال	۱٪ مولی	•/٧٢٩	۱۱	۸/۳۵	آناتاز	۲/۸۵	۰/٣۶
Tio ₂	بهبوديافته							

پس از آلایش با آهن اندازه بلورک ها اندکی کوچکتر شده است و تقریبا یکسان است که احتمالا بخاطر یکی بودن شعاع های یونی +4Ti و +7e³⁴ می باشد و پس از آلایش با آلومینیوم اندازه بلورک افزایش پیدا کرده است که می توان آن را به بزرگتر بودن شعاع یونی ⁺³ *Al* از ⁺⁴ *Ti* نسبت داد. جابجایی در قله دارای شدت بیشینه (۱۰۱) پراش پرتو *x* نمونه ها از ۲۵/۴۳۷ آمورف به ۲۵/۳۳۳ برای دی اکسید تیتانیوم آناتاز و ۲۵/۴۳۸ برای آلایش با آهن به ۲۵/۳۴۸ برای آلایش با آلومینیوم با تمام پهنا در نصف بیشینه به ترتیب برابر با ۲۹/۹۵ ، ۲۸/۸۰ ، ۲۸/۸۰ ، ۲۲/۹۹ وجود دارد که طبق فرمول شرر با کاهش پهنای نیمه بیشینه اندازه ذرات افزایش یافته است و با محاسبات روش ویلیامسون – هال مطابقت دارد.

۴-۳-۴ آنالیز ریخت شناسی

برای مشاهده شکل و اندازه ظاهری و درصد عناصر پودر نانوذرات از آنالیز FESEM-EDAX و اندازه ظاهری و درصد عناصر پودر نانوذرات از آنالیز که متابدهنده ۲۰ ۸۷ وجریان باریکه موجود در پژوهشکده بوعلی مشهد استفاده شد. آنالیز با ولتاژ شتابدهنده ۲۰ ۲۰وجریان باریک و ۱۸۸ صورت گرفته است. همانطور که در شکل دیده می شوند عکس ها نمایانگر اندازه های بسیار ریز و شکل تقریبا کلوخه ای ذرات هستند و ذرات به شکل کروی خیلی شبیه هستند. با ایجاد آلایش کلوخه ها منظم تر و بزرگتر شده اند واین باعث می شود تا تخلخل کافی داشته باشند و نفوذ پروسکایت در منافذ TiO2 افزایش یابد و در نتیجه انتقال و استخراج الکترون ها بهتر صورت بگیرد.



شکل ۴–۱۴ تصاویر FESEM برای دی اکسیدتیتانیوم خالص



شكل ۴–١۵ تصاوير FESEM مربوط به نانوذرات دى اكسيد تيتانيوم آلايش يافته با آلومينيوم


شكل ۴-۱۶ تصاوير FESEM مربوط به نانوذرات دى اكسيد تيتانيوم آلايش يافته با آهن

۴-۳-۴ آنالیز عنصری

مشخصه یابی عنصری برای ترکیبات سنتز شده انجام شد و نمودارهای آنالیز عنصری و جداول درصد عناصر دی اکسید تیتانیوم خالص مطابق شکل (۴–۱۷) که در آنها حضور عنصر تیتانیوم و اکسیژن تایید شده است و جدول (۴–۹)، آلایش یافته با آهن مطابق شکل (۴–۱۸) و جدول (۴–۱۰) که در آنها حضور عنصر تیتانیوم و اکسیژن و آهن تایید شده است و آلایش یافته با آلومینیوم مطابق شکل (۴–۱۹) و جدول (۴–۱۱) که در آنها حضور عنصر تیتانیوم و اکسیژن و آلومینیوم تایید شده است، در زیر آمده است.



شكل ۴-۱۷ آناليز EDAXدی اكسيد تيتانيوم خالص

Elt	Line	Int	Error	W%	A%
0	Ка	9.1	4.5593	37.63	64.37
Ti	Ка	246.7	0.9706	62.37	35.63
				100.00	100.00

جدول ۴-۹ درصد وزنی و اتمی درآنالیز EDAXدی اکسید تیتانیوم خالص



شكل ۴–۱۸ أناليزEDAXدى اكسيد تيتانيوم ألايش يافته با ألومينيوم

جدول ۴–۱۰ درصد وزنی و اتمی آنالیزEDAXدی اکسید تیتانیوم آلایش یافته با آلومینیوم

Elt	Line	Int	Error	W%	A%
0	Ка	79.8	32.7054	66.73	85.59
Al	Ка	5.7	3.5095	0.48	0.36
Ti	Ка	342.2	0.6181	32.79	14.05
				100.00	100.00

شکل ۴–۱۹ آنالیز EDAXدی اکسید تیتانیوم آلایش یافته با آهن



جدول ۴–۱۱ درصد اتمی و وزنی آنالیز EDAXدی اکسید تیتانیوم آلایش یافته با آهن

Elt	Line	Int	Error	W%	A%
0	Ка	63.9	18.9048	62.88	83.56
Ti	Ка	359.2	0.8319	36.54	16.22
Fe	Ка	3.3	0.3565	0.58	0.22
				100.00	100.00

بررسی و مقایسه نتایج EDAX با پودر استاندارد ۲۵ P که در آن Ti مقدار ۲۳/۰۲٪ و O مقدار ۷۶/۹۸٪ دارد نشان می دهد که پس از آلایش میزان انحراف نسبت درصد اتمی Ti O کمتر شده است جدول

(۹–۹). نسبت اتمی $T_{0}O$ در نمونه بدون آلایش تقریبا ۱ به ۲ می باشد ولی در نمونه آلایش یافته این نسبت تغییر پیدا کرده است. مقدار اکسیژن در نمونه های آلایش یافته افزایش یافته است که ممکن است مطابق رابطه های (۴–۳) و (۴–۴) به دلیل تابش فوتون به سطح بلور و تشکیل الکترون و حفره و در نتیجه آویزان شدن مولکول های O_{2} سرگردان به سطح بلورک باشد. یا اینکه مطابق کارهای قبلی اکسید فلزات روی سطوح تشکیل شده باشد و درصد اکسیژن را افزایش دهد[۳۳]. یا ممکن است میزان خلا دستگاه کافی نبوده و چون اکسیژن به صورت گاز در محیط وجود دارد دقت اندازه گیری پایین می آید. از پودرهای استفاده شده در این قسمت قبلا آنالیز XRD گرفته شده بود واین عامل نیز می تواند باعث اکسید شدن مواد و افزایش مقدار اکسیژن شده باشد[34].

$$TiO_2 + h\upsilon \rightarrow h_{vb}^{+} + e_{cb}^{-} \tag{(7-4)}$$

$$O_2 + e_{cb} \rightarrow O_2^{-} \tag{(f-f)}$$

عنصر	0%	Ti%	درصد انحراف 0
پودر استاندارد	४९,९٨	۲۳,۰۲	•
TiO ₂	۶۴ , ۳۷	30,98	-17
Al-TiO ₂	۸۵,۵۹	۱۴,۰۵	+11
Fe-TiO ₂	۸۳,۵۶	18,77	+ A

جدول ۴-۱۲ مقایسه درصد اتمی عناصر O و Ti در ترکیبات TiO2

۴-۴ ساخت سلول

روش لایه نشانی مورد استفاده در ساخت سلول خورشیدی ، لایه نشانی چرخشی است. در این نوع لایه نشانی ، غلظت محلول ، سرعت لایه نشانی، و مدت چرخش از عوامل مهم تاثیر گذار بر ضخامت لایه هستند و باید برای هر لایه با تجربه به دست آیند. ضخامت های مناسب رایج برای TiO₂ فشرده حدود ۵۰ nm و برای TiO₂ متخلخل حدود ۲۰۰ nm و برای لایه پروسکایت حدود ۳*m* ۴۰۰ می باشند. برای ساخت سلول ابتدا FTO با مقاومت تقریبی [/ ۴۰Ω با ابعاد N· cm×۱۰ cm و ضخامت mm ۳ را انتخاب کرده و در اندازه های ۱/۳*cm*×۱/۳*cm* داده شد. سپس روی FTO ها را با چسب اسکاچ پوشانده شد بطوریکه حدود mm ۳ از FTO آزاد بماند. سپس مقداری پودر زینک رویFTO پاشیده شد و محلول رقیق شده هیدروکلریک اسید با آب با نسبت ۳:۱روی آن ریخته شد. به کمک یک مسواک نرم یا گوش پاک کن FTO پاک شد و این قسمت تا انتهای کار برای لایه های بعدی پاک می شود و در انتها لایه طلا روی آن پوشش داده شد و از این قسمت به عنوان کاتد استفاده می شود. در انتهای لایه نشانی ها، حدود چند میلی متر از طرف مقابل اچ شده پاک شد تا به FTO برسیم و این قسمت به عنوان اتصال آند استفاده می شود. سپس مراحل شستشو ادامه داده شد. زیرلایه ها را ابتدا در ۰/۱ HCL مولار سپس اتانول و سپس استون و ایزوپروپانول مرک هرکدام به مدت ده دقیقه تحت التراسونیک قرار داده می شود و سپس با آب دو بار یونیزه شستشو داده شدند. زیرلایه ها را بوسیله سشوار یا آون خشک شدند. سپس زیرلایه ها را به مدت ۱۵ min تحت تابش UV قرارداده شدند. لازم به یادآوری است که بهتراست لایه ها را قبل از هر لایه نشانی تحت تابش UV --Ozone قرار داده شوند تا آلودگی ها بخصوص احتمالا چربی ها از روی لایه پاک شوند[۳۵]. قبل ازلایه نشانی FTO ها را در دمای C° ۵۰۰ به مدت یک ساعت قرار داده می شد.

برای لایه نشانی لایه فشرده TiO_2 ، ابتدا مقدار μ ۳۶۹محلول TTIP در T/۵۳ ml اتانول حل می شود و روی همزن مغناطیسی گذاشته می شود تا هم بخورد. سپس در یک بشر دیگر μ ۳۵ از HCL37% در ۲/۵۳ *ml* اتانول حل می شود. محلول اولی قطره به قطره به دومی اضافه می شود و مدت min در ۲/۵۳ *ml* می شود تا حل شوند، سپس محلول را ازفیلتر ۲۲۰ *mn* ۲۲۰ عبور داده می شود. *μ* ۲۵۰ از محلول (سل بلاک) به روش چرخشی – پوششی لایه نشانی می شود. لایه سدکننده برای جلوگیری از بازگشت (سل بلاک) به روش چرخشی – پوششی لایه نشانی می شود. لایه سدکننده برای ملوگیری از بازگشت (سل بلاک) به روش چرخشی – پوششی ای می شود. سیس محالف اچ با اتانول پاک می شود. سپس زیرلایه ها را در آون در دمای O° ۵۰۰ به مدت یک ساعت قرار داده می شود[۳۶]. از لایه مورد نظر طیف جذب و عبور گرفته شد و این نمودار ها با طیف های جذبی و عبوری دی اکسید تیتانیوم مطابقت می کنند و بیانگر تشکیل این ماده آمورف می باشند. شکل(۴–۲۰)



شکل ۴-۲۰ نمودار های جذب و عبور لایه TiO₂ فشرده

در ادامه لایه متخلخل TiO₂ لایه نشانی می شود. برای انجام این مرحله ابتدا محلول TiO₂ به نسبت ۱۵ mg/ml اتانول یا نسبت وزنی ۵/۵: ۱آماده کرده و توسط همزن آن را به مدت یک شبانه روز حل کرده و حدود یک ساعت توسط التراسونیک ذرات به هم چسبیده را از هم جدا می شوند. باید دقت شود که در صورت داغ شدن ظرف آنرا ازآب خارج نموده تا سرد شود. در ادامه لایه متخلخل شبیه قسمت بلاک لایه نشانی چرخشی – پوششی شده و همان قسمت قبلی پاک می شود. لازم به ذکر است که در این مرحله خمیر TiO2 درست نشد و چون اندازه ذرات نیز کوچک بود لایه نشانی به خوبی انجام شد ولی این امر ممکن است باعث نازک شدن لایه متخلخل TiO₂ شود و لایه نازک اثر مثبتی روی انتقال الکترون ها نداشته باشد و باعث افت عملکرد قطعه شود. ازTiO₂ آلایش یافته نیز برای مقایسه با سلول های مرجع نیز استفاده شد که مواد مورد استفاده جهت آلایش آهن و آلومینیوم می باشد. محلول آنها را نیز به همان نسبت قبلی آماده کرده و از آنها برای لایه نشانی متخلخل استفاده شد.

برای لایه نشانی پروسکایت سه روش مقایسه شده اند. روش لایه نشانی پروسکایت یک عامل کلیدی برای به دست آوردن قابلیت بالا است زیرا پوشش سطحی ، بلورینگی ،ضخامت وکیفیت لایه مخصوصا مورفولوژی وخواص جابجایی پروسکایت را تعیین می کند. ابتدا از روش لایه نشانی دو مرحله ای چرخشی-چرخشی و سپس لایه نشانی دو مرحله ای چرخشی -غوطه وری استفاده شده است و روش سوم که به لایه نشانی تک مرحله ای چرخشی معروف است[۳۷].

روش اول: برای انجام لایه نشانی مرحله اول ابتدا محلول ۱ مولار Pbl2 را در حلال DMF/DMSO (با نسبت ۲/۱) تهیه شده و به مدت ۱۰دقیقه دردمای $^{\circ}$ ۱۸۰ حرارت داده شد. بعد از این زمان محلول زرد رنگ شفافی درست شد که برای لایه نشانی آماده می باشد و می توان از این محلول در روزهای بعدی نیز استفاده کرد، البته قبل از استفاده، مرحله حرارت دهی باید تکرار شود. نکته مهم در این روش بعدی نیز استفاده کرد، البته قبل از استفاده، مرحله حرارت دهی باید تکرار شود. نکته مهم در این روش ورق پارافیلم استفاده کرد، البته قبل از استفاده، مرحله حرارت دهی باید تکرار شود. نکته مهم در این روش ورق پارافیلم استفاده کرد، البته قبل از استفاده، مرحله حرارت دهی باید تکرار شود. نکته مهم در این روش ورق پارافیلم استفاده شده بود، افزایش فشار بخار محلول باعث می شد که محلول از ظرف بیرون بریزد و در این صورت مولاریته محلول به هم می ریزد و کیفیت لایه نشانی مناسب نخواهد بود. از طرف دیگر و در این صورت بریزد میگری محلول به معاول به محوش آید و حتی با وجود اینکه از ورق پارافیلم استفاده شده بود، افزایش فشار بخار محلول باعث می شد که محلول از ظرف بیرون بریزد و در این صورت مولاریته محلول از طرف دیگر و در این صورت مولاریته محلول به هم می ریزد و کیفیت لایه نشانی مناسب نخواهد بود. از طرف دیگر مدر در این صورت مولاریته محلول به هم می ریزد و کیفیت لایه نشانی مناسب نخواهد بود. از طرف دیگر (با محلول (- محلول (- محلول (- محلول (- محلول به محم می روز و کیفیت لایه نشانی مناسب نخواهد بود. از طرف دیگر در دمای حدود ۶۰ درجه روی همزن قرار داده شد تا خوب حل شده و مایع زرد رنگ شفافی به دست آمد شکل (۴–۲۲). سپس مقدار ایل ۱۰۵ از محلول را با سرعت ۲۰۰۶ به مدت ۲۰۲۰ به مدت ۲۵ انه روی زیرلایه آمد شکل (۴–۲۲). سپس مقدار ایرا در این مرحله از لایه مورد نظر طیف جذبی و رامان گرفته شد[۳۸]. شکل (۴–۱۲) به مدت ۲۵] می در این گرفته شد (۳۸]. شکل (۴–۱۲)



شکل ۴-۲۱ نمودار طیف جذبی و تاوک لایه Pbl2

گاف نواری لایه Pbl₂ مقدار ۲/۳eV بدست آمد که با کارهای قبلی سازگار است[۳۹]. یکی از مشکلات مشاهده شده این بودکه Pbl₂ کامل درحلال حل نمی شد که این مشکل احتمالا مربوط به ساختار ماده و یا تاثیر رطوبت می باشد. برای حل این مشکل چند راهکار مطالعه و آزمایش شد:

اولین راه حل این است که محلول در دستگاه التراسونیک گذاشته شود که باز هم مقداری از ماده حل نمی شد. خشک کردن PbI_2 و حرارت دادن آن در دمای 2° ۲۰۰ درجه در خلا نیز مفید بود و باعث حل شدن بهتر می شود. حلال *DMF* مورد استفاده جهت تهیه محلول نیز باید بدون آب باشد. راه حل بعدی فیلترکردن مواد است. راه حل مناسب تر که در این پایان نامه استفاده شد، این است که ابتدا *PbI2* را در *DMF* حل کرده سپس محلول، از صافی عبور داده شود، ناخالصی ها را دور ریخته و مایع باقیمانده در محل بدون رطوبت خشک شود. پودر باقیمانده یدید سرب خالص است. راه حل نهایی استفاده از *HCL* به نسبت ۸/مولار به سایر مواد حل شونده است مقدار کم هیدروکلریک اسید باعث حل شدن کامل یدید سرب در حلال می شود که در بعضی مقالات از این روش استفاده شده است(۰۰).



شکل (۴-۲۲) نمایی از محلول Pbl₂ و پروسکایت

برای مرحله دوم محلول ۳۰ *mg/ml* ۳۰ از *MAI* را در ایزوپروپانول حل کرده و برای مرحله لایه نشانی محلول و زیرلایه در دمای ۶۰ درجه نگه داشته شد. همدما نبودن باعث عدم یکنواختی لایه و گاهی تبخیر قسمتی از آن می شد. مقدار *μ*۲۰۰*۲* از محلول با قطره چکان روی زیرلایه ریخته شد و چند ثانیه صبر می شد تا محلول در زیرلایه نفوذکند. سپس دستگاه با سرعت ۸۰۰۰ *rpm/s* به مدت ۲ ۳۰روشن شده و پس از اتمام چرخش روی هیتر به مدت ده دقیقه در دمای $^{\circ}$ ۹۰ گذاشته شد تا ترکیبات آلی تبخیر شده و بلور پروسکایت به خوبی تشکیل شود (معادله ۴–۱) . لایه ای به رنگ قهوه ای تیره تشکیل می شد که البته رنگ لایه پروسکایت تا حدودی به دمای هیتر بستگی داشت. گرمای طولانی مدت باعث از هم پاشیدگی پروسکایت می شود . از لایه مورد نظر طیف جذبی و رامان گرفته شد که با تجربه های قبلی در توافق است[۴1]. همانطور که از نمودار شکل (۴–۲۲) دیده می شود لبه جذب پروسکایت در حدود*mn* ۸۰۰ می باشد. قله های طیف رامان در ۸۸ ، ۱۳۱ ما ۲۰ (*cm*⁻¹).



شکل ۴-۲۳ طیف جذبی و رامان لایه پروسکایت دو مرحله ای چرخشی-چرخشی

روش دوم: دراین روش ابتدا *PMF/DMSO* محلول یک مولار *Pbl*₂ تهیه شد. مولاریته استفاده شده برای *Pbl*₂ معمولا بین ۸/۰تا۵/۱مولاراست که با توجه به شرایط تعیین می شود. حلال *DMF/DMSO* با نسبت ۹/۱ می باشد. ابتدا لایه *Pbl*₂ به روش لایه نشانی چرخشی در دور ۵۰۰۰ به مدت ۲۰ یا ۲۰۰۰ یا ۳۰۰۰ دور برای ۲۰ می باشد. ابتدا لایه *Pbl*₂ به روش لایه نشانی چرخشی در دور ۵۰۰۰ به مدت ۲۰ یا بهتر دور برای ۲۰ می باشد. ابتدا لایه *Pbl*₂ به روش لایه نشانی *جرخشی در دور ۵۰۰۰* به مدت ۲۰ یا ۲۰۰۰ دور برای ۲۰ می باشد. ابتدا لایه *Pbl*₂ به روش لایه نشانی *جرخشی در دور ۵۰۰۰* به مدت ۲۰ یا بهتر دور برای ۲۰ می باشد. ابتدا لایه *Pbl*₂ به روش لایه نشانی *جرخشی در دور ۵۰۰۰* به مدت ۲۰ یا ۲۰۰۰ دور برای ۲۰۰۰ به مدت ۱۵ می باشد. ابتدا لایه *Pbl*₂ به روش لایه نشانی *جرخشی در دور ۵۰۰۰* به مدت ۲۰۰۵ به مدت ۲۰۰۶ یا ۲۰۰۰ دور برای ۲۰۰۰ به مدت ۱۵ می باشد. ابتدا لایه *Pbl*₂ به روش لایه نشانی *جرخشی در دور ۵۰۰۰* به مدت ۱۵ می بهتر دور برای ۲۰۰۵ به نشانی شد. سپس زیرلایه در دمای *C*

و صیقلی تشکیل شد که نشانگر این است که یدید سرب، بلوری شده است[۴۳]. سپس زیرلایه به مدت حدود min ۵ در محلول MAI در ۲-پروپانول (حدود 10mg/ml) فرو برده شد که در اینجا مشاهده شد لایه پروسکایت تغییر رنگ می دهد و تقریبا قهوه ای شد شکل(۴–۲۴) . در ادامه زیر لایه به مدت حدود min ۲۰(وی گرمکن گذاشته شد که در این قسمت لایه پروسکایت تقریبا به رنگ سیاه درمی آید. پس از تشکیل پروسکایت می معمولا یکنواخت نیست که دراین صورت پیشنهاد می شود قبل آزگذاشتن لایه روی همانطور که در شد که در این قسمت لایه پروسکایت تقریبا به رنگ سیاه درمی آزگذاشتن شد که در این قسمت لایه پروسکایت تقریبا به رنگ سیاه درمی آید. پس از تشکیل پروسکایت، لایه معمولا یکنواخت نیست که دراین صورت پیشنهاد می شود قبل آزگذاشتن لایه روی هیتر توسط فشارگاز نیتروژن خشک شود. از لایه بدست آمده طیف جذبی و رامان گرفته شد که همانطور که در شکل (۲۵–۲۴) دیده می شود لبه جذب پروسکایت در mm ۸۰۰ قرار دارد و گاف نواری *P* ۵/۱ برای نمونه بدست آمد که با کارهای قبلی در توافق است.



شکل (۴-۲۴) نمایه لایه پروسکایت دو مرحله ای چرخشی-غوطه وری



شکل ۴-۲۵ نمودارهای رامان، جذب و تاوک لایه پروسکایت دو مرحله ای چرخشی-غوطه وری

روش سوم: روش ساده برای ساخت پروسکایت عبارت است از روش تک مرحله ای که برای انجام آن ابتدا۴۶۱ میلی گرم از Pbl₂را دریک میلی لیتر DMF ریخته شد (محلول یک مولاراز آن تهیه شد). سپس ۱۵۹ mg از پودر MAI به آن اضافه شد و محلول بدست آمده روی گرمکن در دمای $^{\circ}$ ۶۰ قرار داده شد و صبر شد تا با کمک همزن حل شوند. محلول حاصل پروسکایت است که به رنگ زرد می باشد. برای جداسازی ذرات درشت تر محلول را از فیلتر nn ۲۲۰ عبور داده می شود تا لایه ای صاف حاصل شود. هنگام لایه نشانی ماده پروسکایت و زیرلایه در دمای یکنواخت $^{\circ}$

نفوذ پروسکایت در تخلخل ها بهت صورت بگیرد و تشکیل بلور بهتر انجام شود. ماده پروسکایت بدست آمده را به روش لایه نشانی چرخشی، ابتدا در دور ۲۰۰۰ به مدت ۲۰ ۶ لایه نشانی می شود. لایه نشانی یروسکایت بالا به روش یک مرحله ای انجام، سپس بطور متوالی در دور ۴۰۰۰ به مدت ۲۰ ۶ قرار داده می شود و در حدود ۶ ثانیه آخر آنتی سالونت (پاد حلال) کلروبنزن لایه نشانی می شود تا به تشکیل بهتر بلور کمک کند(۴۴)و(۴۵)و(۴۶). در نهایت از لایه های سنتز شده آنالیز جذب و رامان گرفته شد. شکل(۴-۲۶) قله های طیف رامان پروسکایت در ۴۱و ۹۹و۱۶۶،۱۴۷و(cm⁻¹)۲۱۳ مشاهده می شوند که قله های۴۱و ۹۹در توافق با قله های ۴۰, (۵۴), (۶۳), ۷۱, ۹۴, ۱۰۸, ۱۳۵, (*cm⁻¹)*, ۱۴۵ حاصل از کارهای تجربی قبلی است و قله های ۱۶۶٬۱۴۷ و (۲۰m(cm⁻¹) ۲۱۳ مربوط به کاتیون MA هستند [41,42] . از بین روش های لایه نشانی پروسکایت انجام شده روش دوم بدلیل بلوری شدن بهتر لایه و جذب مناسب برای لایه نشانی مناسب تر تشخیص داده شد و در ساخت سلول در این پایان نامه از این روش استفاده شد. در ادامه لایه انتقال دهنده حفره لایه نشانی شد که بهترین ماده جهت این قسمت اسپایرو می باشد. برای این کار mg از اسپایرو را در یک میلی لیتر کلروربنزن حل کرده و $0 \cdot \mu$ از محلول را در دور ۵۰۰۰ و زمان ۳۰۶ روی پروسکایت لایه نشانی شد و در دمای ² ۷۰ به مدت ۱۰*min* حرارت داده شد و مدت h ۱۲در یک مکان تاریک گذاشته شد. البته برای افزایش عملکرد لایه بهتر است که مقدار ITFSI (520mg/ml) مقدار IT/Δ از ماده TBP از وITFSI (520mg/ml) ازمحلول IT/Δ μ l زمانه شود. برای الکترودیشتی با استفاده از ماسک یک ناحیه فعال ۱۰ mm²روی لایه اسپایرو ایجاد کرده و روی آن یک لایه طلا درحدود ۱۰۰*nm* به روش کند و پاش نشانده می شود. شکل (۴–۲۷)

¹ Anti Solvent



شکل ۴-۲۶ نمودارهای الف) جذب و ب) رامان پروسکایت یک مرحله ای

در جدول (۴–۱۳) کلیه مراحل ساخت سلول خورشیدی پروسکایت به همراه مواد شیمیایی و فرمول ماده و تجهیزات لازم برای ساخت آورده شده است.

تجهيزات	فرمول شيميايي	مواد شیمیایی	فرآيند	مراحل ساخت
گوش پاک کن	Zn	پودر زينک	اچ کردن	سلول
چسب اسکاچ	HCl (37%)	هيدروكلريك اسيد	-	پروسکایت
	F:SnO ₂	زيرلايه FTO	-	
همزن مغناطیسی، دستگاه		تهيه لايه فشرده	-	
چرخش پوشش، آون،	ساخت فرآيند مواد شيميايى فرمول شيميايى تحيار لول $[] T > \zeta_{ci}$ پور زينك $[] T > \zeta_{ci}$ پور زينك $[] T > \zeta_{ci}$ مكايت $[] T < Ci < [] T > Ci_2 (J > Ci < Ci $			
كوره		(TTIP)	-	
	HCI (37%)	هيدروكلريك اسيد		
	С2Н5ОН	اتانول	-	
همزن مغناطیسی، گرمکن	C ₁₀ H ₁₈ O	آلفا ترپينئول	خمير TiO ₂ وكربن	-
	C23H24N6O4	اتيل سلولز	-	
	С2Н5ОН	اتانول	-	
همزن مغناطیسی، آون،		خمير2TiO	تهيه لايه متخلخل	-
گرمکن		اتانول	ETL	
دستگاه چرخش پوشش،	PbI2	سرب يديد	تهیه لایههای	-
آون، همزن مغناطیسی	CH3NH3I	متيل آمونيوم يديد	پروسكايت	
	DMF	دی متیل فرمامید	-	
	الج كردن $yecv (z i : 2 m)$ $zev (z i : m)$ $F:SnO_2$ FTO $yev (z : 1 m)$ $zev (z : 1 m)$ <			
		سولفوكسايد	_	
	СЗН8О	۲-پروپانول	_	
	ТВР	ترت بوتيل پيريدين	-	
دستگاه چرخش پوشش	C ₈₁ H ₆₈ N ₄ O ₈	اسپايرو امتاد	HTL لايه	-
	C6H5Cl	كلروبنزن	-	
	C ₂ H ₃ N	استونيتريل	-	
	LiTFSI		-	
دستگاه کندوپاش	Au	طلا	کاتد	_

جدول ۴-۱۳ مراحل ساخت سلول پروسکایت

۴-۵ مشخصه یابی سلول خورشیدی

گام بعدی بدست آوردن بازده و مشخصات سلول خورشیدی می باشد. سلول ها با روش های یکسان و لایه پروسکایت با روش دو مرحله ای چرخشی-چرخشی لایه نشانی شده است. نمودار شدت جریان – ولتاژ برای سلول خورشیدی پروسکایت با لایه دی اکسید تیتانیوم ذاتی، آلایش یافته با آلومینیوم و آهن پس از یک هفته از ساخت آنها مطابق شکل (۴–۲۸) هستند. بازده سلول پروسکایت به شدت به عوامل محیطی وابسته است. همه لایه نشانی ها در شرایط محیطی و رطوبت زیر ۴۰٪ انجام شدند. به دلیل گران بودن اسپایرو امتاد بقیه سلول ها بدون لایه انتقال حفره ساخته شدند و از چسب کربن به عنوان لایه کاتد استفاده شد. بازده این سلول ها پایین بود و قابل مقایسه با سلول های دارای اسپایرو امتاد نبودند لذا از ذکر آنها در متن پایان نامه خودداری شد.



شکل ۴-۲۷ نمایی از سلول های ساخته شده با لایه و بدون لایه طلا



(b)





شکل ۴-۲۸ نمودار های جریان-ولتاژ سلول های خورشیدی (a)خالص و آلایش یافته با(b) آلومینیوم و (c)آهن

'∕. Eff	J _{sc} V _{oc}	FF	P _m =V _m I _m	V _{oc} (V)	J _{sc} (mA/cm²)	Isc (A)	نوع الايش
•/19	•/••٢٩	•/•۶٨	•/•••	۵۵/.	۵/۴	./•••۵۴	خالص
•/۴٣	•/••۴٧	•/•٩١	•/•••۴٣•	٠/٢۵	١٩	•/••١٩	آلومينيوم
٧/٢۴	•/•184	•/٣٩۴	•/•••¥٢۶	•/٩٢	۲۰	•/••٢•	آهن

جدول ۴-۱۴ مشخصات سلول های خورشیدی

در نمونه خالص مقدار V_{oc} نسبت به نمونه با آلایش آلومینیوم بیشتر است ولی مقدار J_{sc} کمتر می باشد. بهترین بازده مربوط به سلول با آلایش آهن بدست آمد شکل ۴–۲۸ (C) که در آن مقادیر I_{sc} و V_{oc} مناسب هستند ولی ضریب انباشتگی سلول کم می باشد واز روی مقایسه شیب نمودار، علت به وجود مقاومت های مزاحم نظیر آلودگی های محیطی در حین لایه نشانی نسبت داده می شود که این مقاومت ها مقدار J_mV_m را در مقایسه با مقدار J_{sc}V_{oc} کاهش می دهند و باعث کاهش بازده سلول شده است[7]. افزایش FF در اثر آلایش، نتیجه افزایش تحرک الکترون است که می تواند نتیجه خاصیت رسانایی آلومینیوم و آهن باشد[5].

۴-۶ جمع بندی

در این فصل به گزارش کارهای انجام شده در مورد سنتز و آلایش نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم و بررسی ویژگی های نانو ذرات سنتز شده جهت استفاده در لایه متخلخل سلول خورشیدی پروسکایت پرداخته شد. برای سنتز از دو روش آبی – گرمایی و آبی – گرمایی بهبود یافته استفاده شد. برای آلایش TiO_2 شد. برای سنتز از دو روش آبی – گرمایی و آبی – گرمایی بهبود یافته استفاده شد. برای آلایش TiO_2 شد. برای سنتز از دو روش آبی – گرمایی و آبی – گرمایی بهبود یافته استفاده شد. برای آلایش TiO_2 شد. برای سنتز از دو روش آبی – گرمایی و آبی – گرمایی بهبود یافته استفاده شد. برای آلایش TiO_2 از عناصر سدیم، آهن و آلومینیوم به میزان ۱٪مولی استفاده و نتایج با هم مقایسه گردیدند. در روش آبی – گرمایی استفاده و نتایج با هم مقایسه گردیدند. در روش آبی – گرمایی بهبود یافته ابتدا ماده آمورف و در ادامه فاز آناتاز دی ابی – گرمایی نیزو X و میکروسکوپ روبشی الکترونی گسیل میدانی و آنالیز عنصری استفاده شده است.

فصل يتحم

جمع بندی و پیشہادات برای پژوہش پری آتی

۵-۱ نتیجه گیری

در این پژوهش به بررسی لایه متخلخل انتقال الکترون در سلول خورشیدی پروسکایت پرداخته شد. از آنجا که دی اکسید تیتانیوم ماده رایج برای این لایه می باشد به سنتز و آلایش این ماده به دو روش آبی – گرمایی و آبی – گرمایی بهبود یافته پرداخته شد. ویژگی های این مواد از قبیل خواص ساختاری، نوری، آنالیز عنصری، ریخت شناسی سطح و طیف رامان نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت. ۳روش لایه نشانی پروسکایت انجام و مقایسه شدند. با استفاده از نانو ذرات سنتز شده ۳ نوع سلول خورشیدی پروسکایتی با دی اکسید تیتانیوم ذاتی و آلایش یافته با آهن و آلومینیوم ساخته شدند که نتایج زیر را به همراه داشت:

آنالیزها ورود و تاثیر آلایش را در پودر نانو ذرات دی اکسید بررسی کردند.

روش سنتز و نوع آلایش دی اکسید تیتانیوم نقش مهمی را در ویژگی های مورد نیاز این ماده جهت استفاده در لایه ETL سلول خورشیدی ایفا می کند .

آلایش دی اکسید تیتانیوم با آهن و آلومینیوم باعث بالا رفتن بازده سلول خورشیدی شد و بهترین عملکرد قطعه با آلایش آهن به دست آمد.

۲-۵ پیشنهادات

تخلخل لایه دی اکسید تیتانیوم عامل مهمی در نفوذ پروسکایت و انتقال الکترون ها دارد. بنابراین ساخت خمیر مناسب دی اکسید تیتانیوم جهت بهینه سازی تخلخل لایه انتقال الکترون پیشنهاد می شود.

ساخت مواد مناسب HTL به عنوان جایگزین اسپایرو امتاد و مواد رایج که گران قیمت می باشند آلایش دی اکسید تیتانیوم با سایر مواد نظیر قلع، طلا، نقره، گرافن می تواند در بالا بردن بازده سلول مفید باشد. بررسی الکتریکی لایه های خالص و آلایش یافته دی اکسید تیتانیوم به عنوان ETL استفاده از سایر روش های سنتز مانند سل-ژل جهت انجام آلایش عناصر با دی اکسید تیتانیوم تحقیق در مورد تاثیر اندازه نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر انتقال الکترون در ETL پیدا کردن جایگزین مناسب برای ترکیبات حاوی سرب مورد استفاده در سلول استفاه از سایر آنالیز های لایه مانند پیداکردن نقطه کینگ، اثر هال، EIS ، UPS ا PL و SEM مقطعی غیره جهت تشخیص بهتر نقاط ضعف و قوت کار

استفاده از دستگاه مناسب مشخصه یابی جریان-ولتاژ و انجام کار ساخت سلول به صورت گروهی

مراجع

- Ansari MIH, Qurashi A, Nazeeruddin MK. Frontiers, opportunities, and challenges in perovskite solar cells: A critical review. Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews. Υ· ۱Λ;. Υ٤- Υο: 1
- Rafieh AI, Ekanayake P, Wakamiya A, Nakajima H, Lim CM. Enhanced performance of CH^TNH^TPbI^T-based perovskite solar cells by tuning the electrical and structural properties of mesoporous TiO ^Tlayer via Al and Mg doping. Solar Energy. ^T· ۱۹;- 1VV:^TV£ .Λ1
- Xiao Y, Cheng N, Kondamareddy KK, Wang C ,Liu P, Guo S, et al. W-doped TiO Y mesoporous electron transport layer for efficient hole transport material free perovskite solar cells employing carbon counter electrodes. Journal of Power Sources. Y · ۱۷; ٣٤ Y (Supplement C): .9٤-٤٨٩
- 4. Mesquita I, Andrade L ,Mendes A. Perovskite solar cells: Materials, configurations and stability. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Υ· \Λ;ΛΥ(Part Υ):.Λ٩-Υ٤٧)
- 5. Ulkuniemi M. Influence of Processing Conditions on the Performance of Perovskite Solar Cells: Master's Thesis ,University of Oulu, Oulu, Finland; . Y · IV
- 6. Mozaffari M. Photovoltaic Properties of two Kinds of Mesoporous Perovskite Solar Cells
- Pathak SK, Abate A, Ruckdeschel P, Roose B, Gödel KC, Vaynzof Y, et al. Performance and stability enhancement of dye-sensitized and perovskite solar cells by Al doping of TiOY. Advanced Functional Materials. Y·N٤;Y٤(٣٨):.٥٥-٦٠٤٦
- Ameen S, Akhtar MS, Shin H-S, Nazeeruddin MK. Chapter Five Charge-Transporting Materials for Perovskite Solar Cells. In: van Eldik R, Macyk W, editors. Advances in Inorganic Chemistry. VY: Academic Press; Y+1A. p. .Y&J-1A0
- 9. Wu M-C, Chan S-H, Lee K-M, Chen S-H, Jao M-H, Chen Y-F, et al. Enhancing the efficiency of perovskite solar cells using mesoscopic zinc-doped TiO Yas the electron extraction layer through band alignment. Journal of Materials Chemistry A. Y+NA;7(To):.T)-179Y.
- 10. Roose B, Pathak S, Steiner U. Doping of TiO Yfor sensitized solar cells. Chemical Society Reviews. Υ·١ο; ٤٤ (ΥΥ):. ٤٩-٨٣٢٦
- 11. Zhao H, Liu L, Andino JM ,Li Y. Bicrystalline TiO Ywith controllable anatase–brookite phase content for enhanced CO Yphotoreduction to fuels. Journal of Materials Chemistry A. Υ·ΥΥ; (ΥΛ):. \٦-ΛΥ·٩
- 12. Reddy KM, Manorama SV, Reddy AR. Bandgap studies on anatase titanium dioxide nanoparticles. Materials Chemistry and Physics. Υ··<code>T;VA(1):.٤٥-Υ٣٩</code>
- Gu X, Wang Y, Zhang T, Liu D, Zhang R, Zhang P, et al. Enhanced electronic transport in Fe ^m+-doped TiO ^tfor high efficiency perovskite solar cells. Journal of Materials Chemistry C. -1-1.Vo٤:(٤١)0;۲·١٧
- 14. Li Y, Guo Y, Li Y, Zhou X. Fabrication of Cd-Doped TiO YNanorod Arrays and Photovoltaic Property in Perovskite Solar Cell. Electrochimica Acta. Y 17; Y (Supplement C):. 7-79
- 15. Cai Q, Zhang Y, Liang C, Li P, Gu H, Liu X, et al. Enhancing efficiency of planar structure perovskite solar cells using Sn-doped TiO Yas electron transport layer at low temperature. Electrochimica Acta. Υ· \Λ;. Υο-Υ٦\: ΥΥ
- 16. Koo B-R, Oh D-H, Ahn H-J. Influence of Nb-doped TiO Yblocking layers as a cascading band structure for enhanced photovoltaic properties. Applied Surface Science. Y • IA;. Υξ-ξΥΥ:YV
- 17. Liu D, Li S, Zhang P, Wang Y, Zhang R, Sarvari H, et al. Efficient planar heterojunction perovskite solar cells with Li-doped compact TiO Tlayer. Nano Energy. ۲۰۱۷: ۲۰۱۷
- 18. Abdoul-Latif MM, Xu J, Yao JX, Dai SY, editors. Au Nanoparticles Doped TiO Y Mesoporous Perovskite Solar Cells. Materials Science Forum; Y · VY: Trans Tech Publ-

- 19. Xiang Y, Ma Z, Zhuang J, Lu H, Jia C, Luo J, et al. Enhanced Performance for Planar Perovskite Solar Cells with Samarium-Doped TiO YCompact Electron Transport Layers. Journal of Physical Chemistry C. Y · NY; NY (TY): V-Y · No ·
- 20. The http://edu.nano.ir/paper/.o.g
- 21. https://nanoclub.ir/wp-content/uploads/V-Y-0/. T/Y. 19-XRD.pdf.
- 22. https://sharifsolar.ir/product./
- 23. <u>https://pvd.ir/fa/products</u>.
- 24. http://sun-lab.ir.
- 25. Burungale V, Satale V, More A, Sharma K, Kamble A, Kim J, et al. Studies on effect of temperature on synthesis of hierarchical TiO Ynanostructures by surfactant free single step hydrothermal route and its photoelectrochemical characterizations. Journal of colloid and interface science. Y · 17; 17-٤٧: 1 · Λ
- 26. Shalini S, Prabavathy N, Balasundaraprabhu R, Kumar TS, Walke P, Prasanna S, et al. Effect of Na doping on structure, morphology and properties of hydrothermally grown one dimensional TiO Tnanorod structures. Journal of Materials Science: Materials in Electronics. T · 1V; TΛ(٤):.Λ-To··
- 27. Shalini S, Prabavathy N, Balasundaraprabhu R, Kumar TS, Velauthapillai D, Balraju P, et al. Studies on DSSC encompassing flower shaped assembly of Na-doped TiO Ynanorods sensitized with extract from petals of Kigelia Africana. Optik International Journal for Light and Electron Optics. Y · \A; \oo(Supplement C):. £Y-YYE
- 28. Reyes-Coronado D, Rodríguez-Gattorno G, Espinosa-Pesqueira M, Cab C, de Coss Rd, Oskam G. Phase-pure TiO Ynanoparticles: anatase, brookite and rutile. Nanotechnology. Y · · Λ; \9(\1):\1207.0
- 29. You Y, Xu C, Xu S, Cao S, Wang J, Huang Y, et al. Structural characterization and optical property of TiO Ypowders prepared by the sol–gel method. Ceramics International. זיונגיני(ז): אראביני(ז): אראבינין אראַנין אראַגענין אראַנין אראַגין אראַגענין אראַנין אראַגענין אראַגענין אראַגענין אראַגענין אראַגענין אראַגענין אראַגענין אראַגענין אראַגעניןן אראַגענין אראַגענין אראַגענין אראַגענין אראַגענין אראַגענין אראַגענין אראַגעניןן אראַגענין אראַגענין אראַגענין אראַגענין אראַגעניןן אַגענין אַגענין אַגענין אַגענין אַגענין אַגעניןן אַגענין אַגענין אַגענע
- 30. Lee J-W, Lee T-Y, Yoo PJ, Grätzel M, Mhaisalkar S, Park N-G. Rutile TiO ^Υ-based perovskite solar cells. Journal of Materials Chemistry A. Υ·١٤;Υ(Υ٤):.٩-٩٢٥١
- 31. Yin H, Wada Y, Kitamura T, Kambe S, Murasawa S, Mori H, et al. Hydrothermal synthesis of nanosized anatase and rutile TiO Yusing amorphous phase TiOY. Journal of Materials Chemistry. ۲۰۰۱; וו(1): ۷۰۳-۱٦٩٤
- 33. Santara B, Giri P, Dhara S, Imakita K, Fujii M. Oxygen vacancy-mediated enhanced ferromagnetism in undoped and Fe-doped TiO Ynanoribbons. Journal of Physics D: Applied Physics. Υ·١٤;٤٧(ΥΥ):.ΥΥ٥٣٠٤
- 35. Senain I, Nayan N, Saim H. Structural and electrical properties of TiO Ythin film derived from sol-gel method using titanium (IV) butoxide. International Journal of Integrated Engineering. Y ·) · ;.(Υ)Y
- 36. Wang M, Feng Y, Bian J, Liu H, Shi Y. A comparative study of one-step and two-step approaches for MAPbI ^rperovskite layer and its influence on the performance of mesoscopic perovskite solar cell. Chemical Physics Letters. ۲۰۱۸;.٩-٦٩٢:٤٤
- 37. Burschka J, Pellet N, Moon S-J, Humphry-Baker R, Gao P, Nazeeruddin MK, et al. Sequential deposition as a route to high-performance perovskite-sensitized solar cells. Nature. ۲・۱۳;.٩-٣١٦:(٧٤٥٨)٤٩٩

- Zhu G, Liu P, Hojamberdiev M, Zhou J-p, Huang X, Feng B, et al. Controllable synthesis of PbI Ynanocrystals viaáaásurfactant-assisted hydrothermal route. Applied Physics A. Y·۱·;٩٨(Y):.Y٩٩
- 39. Guo N, Zhang T, Li G, Xu F, Qian X, Zhao Y . A simple fabrication of CH^πNH^πPbl ^πperovskite for solar cells using low-purity Pbl⁺. Journal of Semiconductors. ^Υ · ۱۷;^πΛ(1):·· ۱٤·· ٤
- 40. Wangyang P, Sun H, Zhu X, Yang D, Gao X. Mechanical exfoliation and Raman spectra of ultrathin PbI Tsingle crystal. Materials Letters. ۲۰۱٦; ۷۱-۱٦٨:٦٨
- 41. Park B-w, Jain SM, Zhang X, Hagfeldt A, Boschloo G, Edvinsson T. Resonance raman and excitation energy dependent charge transfer mechanism in halide-substituted hybrid perovskite solar cells. ACS nano. Υ·ιο; ٩(Υ):. ۱·ι-Υ·ΛΛ
- 42. Ko H-S, Lee J-W, Park N-G. %۱۹,V7efficiency perovskite solar cells prepared under high relative humidity: importance of PbI Ymorphology in two-step deposition of CH TNH T PbI T. Journal of Materials Chemistry A. Υ-10;T(17):.10-ΛΛ·Λ
- 43. Jeon NJ ,Noh JH, Kim YC, Yang WS, Ryu S, Seok SI. Solvent engineering for highperformance inorganic–organic hybrid perovskite solar cells. Nature materials. Υ·١٤; ١٣(٩):.٩.٣-٨٩٧
- 44. Zhao Y, Zhu K. CH^TNH^TCl-assisted one-step solution growth of CH^TNH^TPbI^T: structure, charge-carrier dynamics, and photovoltaic properties of perovskite solar cells. The Journal of Physical Chemistry C. Y · 12; 11Λ(1Λ):.Λ-9٤1Y

Abstract

In the recent years, we have witnessed the rapid development of a brandnew, type of solar cell based on organic-inorganic halide perovskite materials. The power conversion efficiency (PCE) of perovskite solar cells (PSCs) has rapidly increased from 3.8% to 22.1% since it was first reported in 2009. For PSCs, electron transport layers (ETLs) play a significant role in transporting electrons and blocking holes. In the vast majority of PSCs, TiO₂ is the preferred material for ETLs because of its superior electronic properties. In this research, undoped and doped (with 1 molar percent of Na, Al and Fe) TiO₂ were synthesized using modified hydrothermal method for the fabrication of perovskite solar cell devices. Structural, elemental composition, surface morphological and optical properties of synthesized powder were studied using XRD, EDAX, Raman, FESEM and UV-VIS analysis techniques. According to XRD results, using modified hydrothermal method caused the growth of prefertional anatase phase with little traces of brookite phase in the synthesis of nanopowders. The synthesized nanoparticles were used as electron transport layer in the fabrication of perovskite solar cells. The fabricated solar cells were of n-i-ptype made with mesoporous TiO_2 . The fabrication processes include the preparation of FTO, coating of a compact TiO₂ layer as a hole blocking layer and a mesoporous layer of undoped and Al and Fe doped TiO₂ as electron transport layer, and then coating of the perovskite layer (CH₃NH₃PbI₃). For the deposition of the last layer, two methods of single-step, two-step (by two different techniques) were utilized. In the two-step method PbI₂ was coated using spin coating technique and then CH₃NH₃I (MAI) was coated using both spin-coating and dip-coating methods, separately. The results of three applied methods were compared. Among them, the spin-spin two-step method provided the best layer quality and was chosen for the fabrication of the device. Spiro-MeOTAD without any additive was used for the coating of HTL. Finally, Au was deposited using DC sputtering to be acting as the back contact electrode. Raman and UV-Vis techniques were used for the quality control of every deposited layer during the cell fabrication. I-V measurements revealed that the device fabricated using TiO2:Fe had the best efficiency

Key words: Perovskite Solar Cell; Dioxide Titanium; Hydrothermal; Doping; I-V measurement; Efficiency.



Shahrood University of Technology Faculty of Physics Master of Science Thesis

Synthesis and Characterization of Titanium Dioxide Nanostructures for application in Perovskite Solar Cells

Seyed Mahdi Moosavi Supervisor: Dr.Mohammad Bagher Rahmani

July 2019